Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/018865

International filing date: 10 December 2004 (10.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-321803

Filing date: 05 November 2004 (05.11.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 04 February 2005 (04.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



14. 1. 2005

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2004年11月 5日

出 願 番 号
Application Number:

特願2004-321803

[ST. 10/C]:

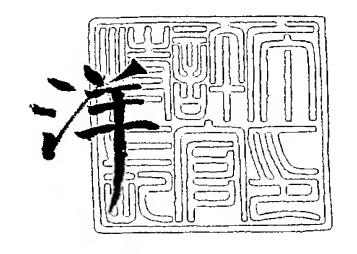
[JP2004-321803]

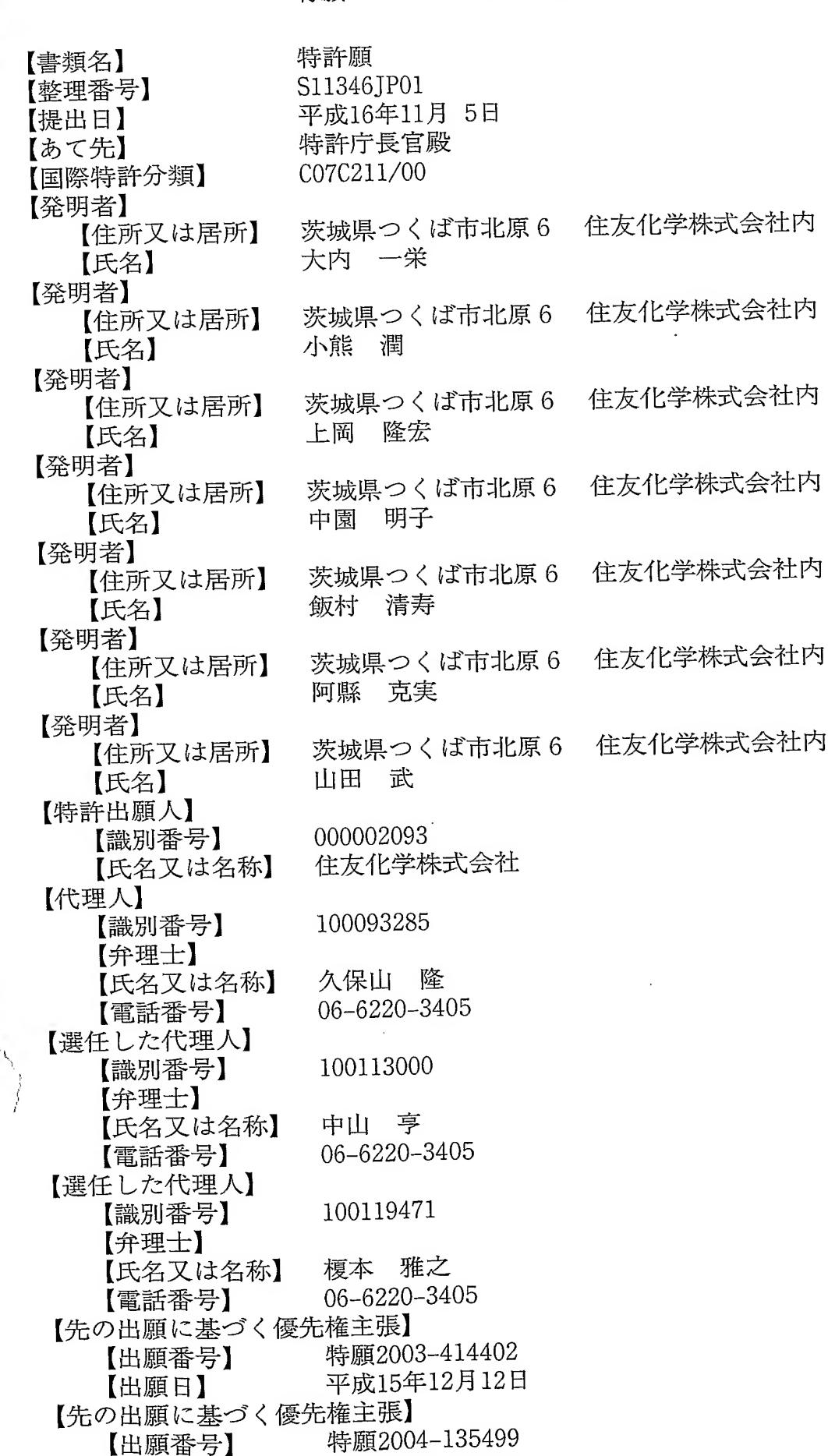
出 願 / Applicant(s):

住友化学株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 1月 6日

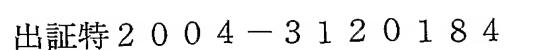






平成16年 4月30日

【出願日】



【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2004-301416

【出願日】

平成16年10月15日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

010238

【納付金額】

16,000円

【その他】

なお、平成16年10月1日付けで、氏名(名称)変更届を提出

しております。

【提出物件の目録】

【物件名】

特許請求の範囲

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

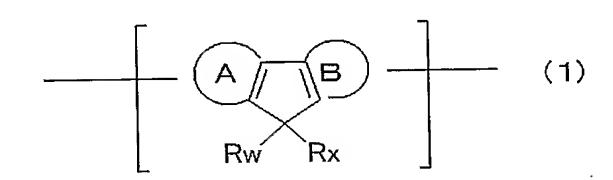
【包括委任状番号】

0212949

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

下記式(1)で示される繰り返し単位を含み、ポリスチレン換算の数平均分子量が103~ 108であることを特徴とする高分子化合物。



〔式中、A環およびB環はそれぞれ独立に、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環 を表すが、A環における芳香族炭化水素環とB環における芳香族炭化水素環とは互いに異 なる環構造の芳香族炭化水素環であり、2つの結合手はそれぞれA環および/またはB環上 に存在し、

RwおよびRxはそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基 、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアル コキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、ア ミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキ シ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カル ボキシル基またはシアノ基を表し、RwとRxはそれぞれ互いに結合して環を形成してい てもよい。〕

【請求項2】

ポリスチレン換算の重量平均分子量が 5×10⁴以上であることを特徴とする請求項1記 載の高分子化合物。

【請求項3】

ポリスチレン換算の重量平均分子量が 1 0 ⁵以上であることを特徴とする請求項 2 記載の 高分子化合物。

【請求項4】

分散度(重量平均分子量/数平均分子量)が3以上12以下であることを特徴とする請求 項1~3のいずれかに記載の高分子化合物。

【請求項5】

芳香族炭化水素環が置換基を有する場合、置換基が、アルキル基、アルコキシ基、アル キルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、ア リールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキ ニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、 アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基 、置換カルボキシル基およびシアノ基からなる群から選ばれるから選ばれることを特徴と する請求項1~4のいずれかに記載の高分子化合物。

【請求項6】

A環とB環の組合せがベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、テトラセン環、ペン タセン環、ピレン環、フェナントレン環から選ばれる組合せであることを特徴とする請求 項1~5のいずれかに記載の高分子化合物。

【請求項7】

A環とB環との組合せとして、ベンゼン環とナフタレン環、ベンゼン環とアントラセン 環、ベンゼン環とフェナントレン環、ナフタレン環とアントラセン環、ナフタレン環とフ エナントレン環、アントラセン環とフェナントレン環の組合せのいずれかから選ばれる組 合せであることを特徴とする請求項6記載の高分子化合物。

【請求項8】

A環がベンゼン環でありB環がナフタレン環であることを特徴とする請求項7記載の高分

子化合物。

【請求項9】

繰り返し単位が下記式 (1-1)、 (1-2)、 (1-3) または (1-4) で示される構造であることを特徴とする請求項 8 記載の高分子化合物。

$$(R_{q1})_b$$
 $(R_{q2})_b$
 $(R_{p2})_a$
 R_{w1}
 R_{x1}
 $(1-1)$
 $(1-2)$

$$(R_{p3})_a$$
 R_{w3}
 R_{x3}
 $(R_{q3})_b$
 R_{w4}
 R_{x4}
 $(1-3)$
 $(1-4)$

[式中、 R_{p1} 、 R_{q1} 、 R_{p2} 、 R_{q2} 、 R_{p3} 、 R_{q3} 、 R_{p4} および R_{q4} はそれぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキン基、アリールアルキカ基、アリールアルキン基、アリールアルキン基、アリールアルキュル基、アリールアルキュル基、アリールアルキュル基、アリールアルを大力を表。カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。 R_{p1} は R_{p2} に、 R_{p3} に、 R_{p3} に、 R_{p4} および R_{q4} が複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。 R_{w1} に R_{x2} に R_{x2} に R_{w3} に R_{x3} に R_{w4} および R_{x4} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリールアルキル基、アリールオキシ基、アリールオン基、アリールアルカチオ基、アリールオシ基、アリールオンチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチャンル基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチャンル基、アリールアルキルチャンル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表し、 R_{w1} と R_{x3} に R_{w4} と R_{x4} は それぞれ互いに結合して環を形成していてもよい。〕

【請求項10】

上記式 (1-1) において、a=b=0 であることを特徴とする請求項 9 記載の高分子化合物。

【請求項11】

上記式 (1-1)、 (1-2)、 (1-3) および (1-4) で示される繰り返し単位のいずれかのみからなる請求項 9 または 1 0 記載の高分子化合物。

【請求項12】

さらに、下記式(3)、式(4)、式(5)または式(6)で示される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項 $1\sim1$ 1のいずれかに記載の高分子化合物。

$$-A r_1 - (3)$$

(6)

$$-(A r 2 - X 1)_{f f} - A r 3 - (4$$

$$-A r_4 - X_2 - (5)$$

っていてもよい。〕 【請求項13】

 $-X_3-$

上記式(3)で示される繰り返し単位が、下記式(7)、(8)、(9)、(10)、(11)または(12)で示される繰り返し単位であることを特徴とする請求項12記載の高分子化合物。

$$\begin{pmatrix}
R_{14} \\
n
\end{pmatrix}$$
(7)

〔式中、 R_{14} は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。nは $0\sim4$ の整数を表す。 R_{14} が複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

$$\begin{pmatrix}
R_{17} \\
q \\
R_{18}
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
R_{19} \\
R_{20} \\
r
\end{pmatrix}$$
(9)

〔式中、 R_{17} および R_{20} は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルキン基、アリールアルキニル基、アリールアルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アリールアルチニル基、アリールアルチニル基、アリールアルチニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。 R_{18} および R_{19} は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。 R_{17} および R_{20} がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

$$\begin{array}{c|c}
 & X_4 \\
 & N \\
 & Ar_{14} \\
 & tt
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 & (10) \\
 & (R_{21})_s
\end{array}$$

〔式中、R21は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールテルキオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。sは0~2の整数を表す。Ar13およびAr14はそれぞれ独立にアリーレン基、2価の複素環基または金属錯体構造を有する2価の基を表す。ssおよび t t はそれぞれ独立に0または1を表す。X4は、O、S、SO、SO2、Se,またはTeを表す。R21が複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

$$\begin{pmatrix}
R_{22} \\
t & X_6 \\
-X_7 & R_{23} \\
-X_5 & -X_7
\end{pmatrix} u$$
(11)

〔式中、 R_{22} および R_{23} は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチル基、アリールアルキル基、アリールアルキン基、アリールアルキニル基、アリールアルキニル基、アリールアルチニル基、アリールアルキニル基、アリールアルキニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。tおよびtはそれぞれ独立にt0~4の整数を表す。t25 は、t3 に t4 に t5 に t4 に t5 に t6 に t6 に t7 に t7 に t8 に t9 に t

立に水素原子、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複素環基を表す。 R_{22} 、 R_{23} および R_{27} がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。]

$$\begin{array}{c|c}
 & R_{28} \\
\hline
 & R_{29} \\
\hline
 & R_{30}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 & R_{31} \\
\hline
 & R_{32}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 & R_{33} \\
\hline
 & R_{33} \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 & R_{33} \\
\end{array}$$

〔式中、R28およびR33は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アリールアルキュールを、アリールアルキュールを、アリールアルキュールを、アリールアルキュールを、アリールアルキュールを、アリールアルキュールを、アリールを、アリールを、アリールを、アシルオキシを、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。R29、R30、R31およびR32は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。R15はアリーレン基、2価の複素環基または金属錯体構造を有する2価の基を表す。R28およびR33がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

【請求項14】

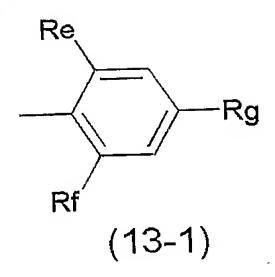
上記式(4)で示される繰り返し単位が、下記式(13)で示される繰り返し単位であることを特徴とする請求項12記載の高分子化合物。

〔式中、 Ar_6 、 Ar_7 、 Ar_8 および Ar_9 はそれぞれ独立にアリーレン基または2価の複素環基を表す。 Ar_{10} 、 Ar_{11} および Ar_{12} はそれぞれ独立にアリール基、または1価の複素環基を表す。 Ar_6 、 Ar_7 、 Ar_8 、 Ar_9 、および Ar_{10} は置換基を有していてもよい。xおよびyはそれぞれ独立に0または正の整数を表す。〕

【請求項15】

V

上記式(13)で示される繰り返し単位において、x+y=1であり、かつ Ar_{10} 、 Ar_{11} および Ar_{12} が、それぞれ独立に下記式(13-1)で示される基から選ばれることを特徴とする請求項14記載の高分子化合物。



〔式中、Re、RfおよびRgは、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチ オ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリール アルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基 、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、シリルオキシ基、置換シリルオキ シ基、1価の複素環基またはハロゲン原子を表す。]

【請求項16】

上記式(1)で示される繰り返し単位と上記式(13)で示される繰り返し単位をそれぞ れ1種以上含み、該繰り返し単位の合計が全繰り返しの50モル%以上であり、かつ式(1)で示される繰り返し単位の合計と式(13)で示される繰り返し単位の合計のモル比 が98:2~60:40の範囲であることを特徴とする請求項14または15記載の高分 子化合物。

【請求項17】

上記式(1)で示される繰り返し単位1種と上記式(13)で示される繰り返し単位を1 種または2種とを含むことを特徴とする請求項16記載の高分子化合物。

【請求項18】

上記式(1)で示される繰り返し単位と上記式(13)で示される繰り返し単位の量の合 計が全繰り返しの90モル%以上であることを特徴とする請求項16または17記載の高 分子化合物。

【請求項19】

上記式 (1) で示される繰り返し単位が上記式 (1-1)、 (1-2)、 (1-3) また は(1-4)で示されることを特徴とする請求項16~18のいずれかに記載の高分子化 合物。

【請求項20】

上記式(1)で示される繰り返し単位が上記式(1-1)または(1-2)で示されるこ とを特徴とする請求項19記載の高分子化合物。

【請求項21】

上記式(1-1)において、a=b=0であることを特徴とする請求項19または20記 載の高分子化合物。

【請求項22】

上記式(13)で示される繰り返し単位において、Ar10、Ar11およびAr12が、そ れぞれ独立に上記式(13-1)で示される基から選ばれることを特徴とする請求項16 ~21のいずれかに記載の高分子化合物。

【請求項23】

前記式(13)で示される繰り返し単位において、y=0かつx=1であることを特徴とす る請求項14~22のいずれかに記載の高分子化合物。

【請求項24】 前記式(13)で示される繰り返し単位において、y=0かつx=0であることを特徴とする 請求項14~22のいずれかに記載の高分子化合物。

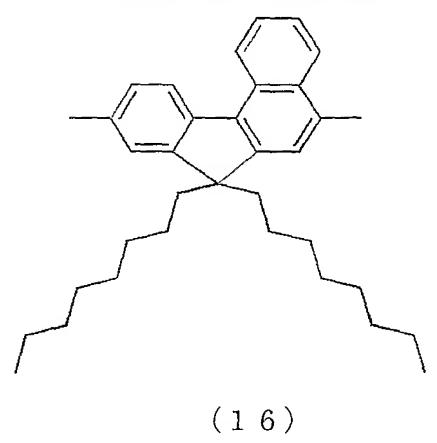
【請求項25】

前記式(13)で示される繰り返し単位において、Aェッが下記式(19-1)または (19-2)であることを特徴とする請求項14~23のいずれかに記載の高分子化合物

$$(19-1) \qquad (19-2)$$

【請求項26】

実質的に、下記式(16)で示される繰り返し単位のみからなることを特徴とする請求項 11記載の高分子化合物。

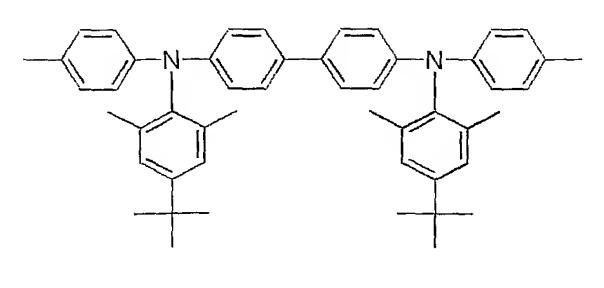


【請求項27】

GPCの溶出曲線が実質的に単峰性で、分散度が4以上7以下であることを特徴とする請求項26記載の高分子化合物。

【請求項28】

実質的に、上記式(16)で示される繰り返し単位と、下記式(17)で示される繰り返し単位のみからなることを特徴とする請求項25記載の高分子化合物。



(17)

【請求項29】

GPCの溶出曲線が2山であり、分散度が6以上8以下であることを特徴とする請求項2 8記載の高分子化合物。

【請求項30】

式(14)

〔式中、 R_y および R_z はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキール基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表し、 R_y と R_z はそれぞれ互いに結合して環を形成していてもよく、 Y_t および Y_u はそれぞれ独立に縮合重合に関与する置換基を表し、それぞれA環および/またはB環に結合している。〕で示される化合物を原料の一つとして用いて縮合重合させること特徴とする請求項 $1\sim 29$ のいずれかに記載の高分子化合物の製造方法。

【請求項31】

式(14)が式(14-1)、(14-2)、(14-3)または(14-4)

$$(R_{r1})_a$$
 Y_{t1}
 R_{y1}
 R_{z1}
 R_{z1}
 R_{y2}
 R_{z2}
 R_{z2}
 $(14-1)$
 $(14-2)$
 $(R_{r3})_a$
 R_{y3}
 R_{z3}
 $(R_{r3})_b$
 $(R_{r4})_a$
 $(R_{r4})_a$
 $(R_{r4})_a$
 $(R_{r4})_a$
 $(14-3)$
 $(14-4)$

ページ: 9/

平、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、 カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表し、Ry1とRz1、Ry2とRz2、 Rv3とRz3、Rv4とRz4はそれぞれ互いに結合して環を形成していてもよい。Yt1、Yu1 、Y_{t2}、Y_{u2}、Y_{t3}、Y_{u3}、Y_{t4}およびY_{u4}はそれぞれ独立に縮合重合に関与する置換基 を表す。〕であることを特徴とする請求項30記載の製造方法。

特願2004-321803

【請求項32】

上記式(14)で示される化合物に加えて、下記式(21)~(24)のいずれかで示 される化合物を原料として用いて縮合重合させることを特徴とする請求項30または31 に記載の製造方法。

$$Y_5 - A r_1 - Y_6$$
 (21)

$$Y_7 - \left(-Ar_2 - X_1\right) - Ar_3 - Y_8 \qquad (22)$$

$$Y_9 - A r_4 - X_2 - Y_{10}$$
 (23)
 $Y_{11} - X_3 - Y_{12}$ (24)

〔式中、Ar1、Ar2、Ar3、Ar4、ff、X1、X2およびX3は前記と同じ意味を表 す。Y₅、Y₆、Y₇、Y₈、Y₉、Y₁₀、Y₁₁およびY₁₂はそれぞれ独立に縮合重合に関与 する置換基を表す。〕

【請求項33】

縮合重合に関与する置換基がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、 アリールスルホネート基およびアリールアルキルスルホネート基から選ばれ、ニッケルゼ 口価錯体存在下で縮合重合することを特徴とする請求項30~32のいずれかに記載の製 造方法。

【請求項34】

縮合重合に関与する置換基がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、 アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、一B(OH)2、またはホ ウ酸エステル基から選ばれ、全原料化合物が有するハロゲン原子、アルキルスルホネート 基アリールスルホネート基およびアリールアルキルスルホネート基のモル数の合計と、一 B(OH)2およびホウ酸エステル基のモル数の合計の比が実質的に1であり、ニッケル またはパラジウム触媒を用いて縮合重合することを特徴とする請求項30~32のいずれ かに記載の製造方法。

【請求項35】

上記式(14-1)、(14-2)、(14-3)または(14-4)で示される化合物

【請求項36】

下記式(14-5)、(14-6)または(14-7)で示される化合物。

$$(R_{s1})_{b'}$$
 $(Y_{t1})_{c}$
 $(Y_{u1})_{d}$
 $(Y_{u1})_{d}$
 $(Y_{u2})_{d}$
 $(Y_{u2})_{d}$
 $(Y_{u3})_{d}$

$$(R_{13})_{a'}$$
 $(Y_{t3})_{c}$
 $(Y_{t3})_{c}$
 $(Y_{u3})_{d}$
 $(Y_{u3})_{d}$
 $(Y_{u3})_{d}$

$$(R_{r4})_{a'}$$
 $(Y_{t4})_{c}$
 $(Y_{t4})_{c}$
 $(Y_{t4})_{c}$
 $(Y_{t4})_{c}$
 $(Y_{t4})_{c}$
 $(Y_{t4})_{c}$
 $(Y_{t4})_{c}$
 $(Y_{t4})_{c}$
 $(Y_{t4})_{c}$
 $(Y_{t4})_{c}$

〔式中、Rr1、Rs1、Rr2、Rs2、Rr3、Rs3、Rr4、Rs4、Ry1、Rz1、Ry2、Rz2、Ry3、Rz3、Ry4、Rz4、Yt1、Yu1、Yt3、Yu3、Yt4およびYu4は前記と同じ意味を表し、a'および c はそれぞれ独立に 0~4の整数を表し、b'は 0~5の整数を表し、c は 0~3の整数を表し、d は 0~5の整数を表し、a'+c \leq 4、b'+d \leq 6、3 \leq c+d \leq 6 である。Rr1、Rs1、Rr2、Rs2、Rr3、Rs3、Rr4、Rs4、Ry1、Rz1、Yt1、Yu1、Yt3、Yu3、Yt4およびYu4がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

【請求項37】

上記式 (14) および下記式 (15-1) で示される化合物を原料として用いて縮合重合させること特徴とする請求項 $14\sim25$ 、28、29 のいずれかに記載の高分子化合物の製造方法。

$$Y_{13}$$
— Ar_{6} — N — Ar_{7} — N — X
 Ar_{8} — Y_{14}
 Ar_{9}
 Ar_{10}
 N — Ar_{11}
 Ar_{12}

(15-1)

〔式中、 Ar_6 、 Ar_7 、 Ar_8 および Ar_9 はそれぞれ独立にアリーレン基または2価の複素環基を表す。 Ar_{10} 、 Ar_{11} および Ar_{12} はそれぞれ独立にアリール基、または1価の複素環基を表す。 Ar_6 、 Ar_7 、 Ar_8 、 Ar_9 、および Ar_{10} は置換基を有していてもよい。xおよびyはそれぞれ独立に0または1を表し、xおよびyはそれぞれ独立に0または1を表し、xおよびyはそれぞれ独立に0また

【請求項38】

正孔輸送材料、電子輸送材料および発光材料から選ばれる少なくとも1種類の材料と請求項1~29のいずれかに記載の高分子化合物とを含有することを特徴とする組成物。

【請求項39】

前記式(1)で示される繰り返し単位を含む高分子化合物を2種類以上含み、該高分子化合物の合計量が全体の50重量%以上であることを特徴とする高分子組成物。

【請求項40】

前記式(1)で示される繰り返し単位のみからなる高分子化合物 1 種類以上と、前記式(1)で示される繰り返し単位を 5 0 モル%以上含む共重合体 1 種類以上とを含有することを特徴とする請求項 3 9 記載の高分子組成物。

【請求項41】

前記式(1)で示される繰り返し単位を50モル%以上含む共重合体を2種類以上含み、 該共重合体は、互いに異なる繰り返し単位も含むことを特徴とする請求項39記載の高分 子組成物。

【請求項42】

前記式(1)で示される繰り返し単位を50モル%以上含む共重合体を2種類以上含み、該共重合体は、互いに共重合比は異なっているが、同一の繰り返し単位の組み合わせからなることを特徴とする請求項39記載の高分子組成物。

【請求項43】

Y

前記式(1)で示される繰り返し単位のみからなる高分子化合物を2種類以上含むことを 特徴とする請求項39記載の高分子組成物。

【請求項44】

高分子組成物に含まれる少なくとも1種類の高分子化合物が、前記式(1)で示される繰り返し単位を50モル%以上含む共重合体であり、該共重合体は前記式(13)で示される繰り返し単位も含み、かつ前記式(1)で示される繰り返し単位と、前記式(13)の繰り返し単位のモル比が、99:1~50:50であることを特徴とする請求項39~42のいずれかに記載の高分子組成物。

【請求項45】

前記式(1)で示される繰り返し単位のみからなる高分子化合物1種類以上と、前記式(1)で示される繰り返し単位を50モル%以上含む、共重合体1種類以上とを含む高分子組成物であり、該共重合体が前記式(1)で示される繰り返し単位と前記式(13)で示される繰り返し単位からなり、かつ前記式(1)で示される繰り返し単位と前記式(13)で示される繰り返し単位とのモル比が90:10~50:50であることを特徴とする請求項39、40または44に記載の高分子組成物。

【請求項46】

前記式(1)で示される繰り返し単位と前記式(13)で示される繰り返し単位とからなり、かつ前記式(1)で示される繰り返し単位と前記式(13)で示される繰り返し単位とのモル比が99:1~90:10である共重合体と、前記式(1)で示される繰り返し単位と前記式(13)で示される繰り返し単位とからなり、かつ前記式(1)で示される繰り返し単位と前記式(13)で示される繰り返し単位とのモル比が80:20~50:50である共重合体とを含むことを特徴とする請求項39、41または42記載の高分子組成物。

【請求項47】

請求項1~29のいずれかに記載の高分子化合物を含有することを特徴とする溶液。

【請求項48】

粘度が25℃において1~20mPa·sであることを特徴とする請求項47記載の溶液。

【請求項49】

さらに粘度および/または表面張力を調整するための添加剤を含有することを特徴とする請求項47または48に記載の溶液。

【請求項50】

さらに酸化防止剤を含有することを特徴とする請求項47~48のいずれかに記載の溶液。

【請求項51】

2種類以上の有機溶媒を含有することを特徴とする請求項47~50のいずれかに記載の溶液。

【請求項52】

請求項1~29のいずれかに記載の高分子化合物を含有する発光性薄膜。

【請求項53】

請求項1~29のいずれかに記載の高分子化合物を含有する導電性薄膜。

【請求項54】

請求項1~29のいずれかに記載の高分子化合物を含有する有機半導体薄膜。

【請求項55】

陽極および陰極からなる電極間に、有機層を有し、該有機層が請求項1~29のいずれ かに記載の高分子化合物を含むことを特徴とする高分子発光素子。

【請求項56】

有機層が発光層であることを特徴とする請求項55記載の高分子発光素子。

【請求項57】

Ķ

発光層がさらに正孔輸送材料、電子輸送材料または発光材料を含むことを特徴とする請 求項56記載の高分子発光素子。

【請求項58】

陽極および陰極からなる電極間に、発光層と電荷輸送層とを有し、該電荷輸送層が請求 項1~29のいずれかに記載の高分子化合物を含むことを特徴とする高分子発光素子。

【請求項59】

陽極および陰極からなる電極間に、発光層と電荷輸送層とを有し、該電荷輸送層と電極 との間に電荷注入層を有し、該電荷注入層が請求項1~29のいずれかに記載の高分子化 合物を含むことを特徴とする請求項55記載の高分子発光素子。

【請求項60】

請求項55~59のいずれかに記載の高分子発光素子を用いたことを特徴とする面状光 源。

【請求項61】

請求項55~59のいずれかに記載の高分子発光素子を用いたことを特徴とするセグメ ント表示装置。

【請求項62】

請求項55~59のいずれかに記載の高分子発光素子を用いたことを特徴とするドット マトリックス表示装置。

【請求項63】

請求項55~59のいずれかに記載の高分子発光素子をバックライトとすることを特徴 とする液晶表示装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】高分子化合物およびそれを用いた高分子発光素子

【技術分野】

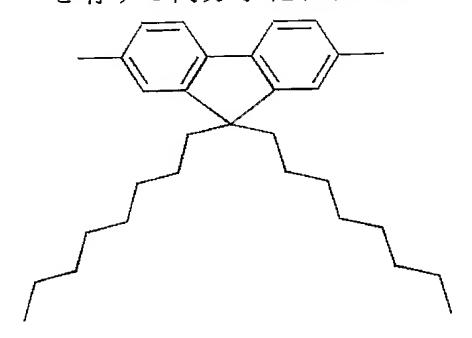
[0001]

本発明は、高分子化合物およびそれを用いた高分子発光素子に関する。

【背景技術】

[0002]

高分子量の発光材料や電荷輸送材料は低分子量のそれらとは異なり溶媒に可溶で塗布法により発光素子における有機層を形成できることから種々検討されており、その例として、繰り返し単位として、シクロペンタジエン環に、2個のベンゼン環が縮合した下の構造を有する高分子化合物が知られている(例えば、非特許文献1、特許文献1)。



[0003]

【非特許文献1】Advanced Materials 1999年9巻10号798頁

【特許文献1】国際公開第99/54385号パンフレット

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

$[0\ 0\ 0\ 4\]$

しかしながら上記の高分子化合物は、その耐熱性、蛍光強度等が必ずしも十分でないという問題があった。

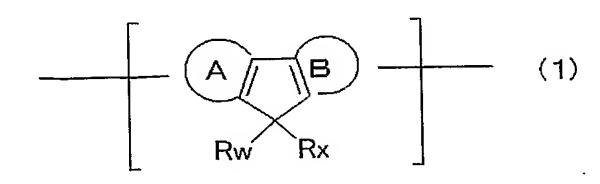
本発明の目的は、発光材料や電荷輸送材料として有用で、耐熱性、蛍光強度等に優れた 高分子化合物を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0005]

本発明者等は、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、繰り返し単位として、 シクロペンタジエン環に、互いに異なる環構造の2個の芳香族炭化水素環が縮合した構造 を有する高分子化合物が発光材料や電荷輸送材料として有用で、耐熱性、蛍光強度等に優 れることを見出し、本発明を完成した。

即ち本発明は、下記式 (1) で示される繰り返し単位を含み、ポリスチレン換算の数平均分子量が $10^3 \sim 10^8$ である高分子化合物を提供するものである。



〔式中、A環およびB環はそれぞれ独立に、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環を表すが、A環における芳香族炭化水素環とB環における芳香族炭化水素環とは互いに異なる環構造の芳香族炭化水素環であり、2つの結合手はそれぞれA環および/またはB環上に存在し、

【発明の効果】

[0006]

本発明の高分子化合物は、発光材料や電荷輸送材料として有用で、耐熱性、蛍光強度等にすぐれる。したがって、本発明の高分子化合物を含む高分子LEDは、液晶ディスプレイのバックライトまたは照明用としての曲面状や平面状の光源、セグメントタイプの表示素子、ドットマトリックスのフラットパネルディスプレイなどに使用できる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0007]

本発明の高分子化合物は上記式(1)で示される繰り返し単位を1種または2種以上含む。

[0008]

式中、A環およびB環はそれぞれ独立に置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環を表すが、A環における芳香族炭化水素環とB環における芳香族炭化水素環とは互いに異なる環構造の芳香族炭化水素環である。

[0009]

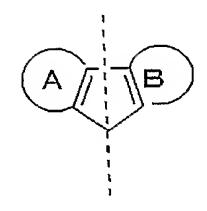
芳香族炭化水素環としては、ベンゼン環単独または複数個のベンゼン環が縮合したものが好ましく、その例としては、ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、テトラセン環、ペンタセン環、ピレン環、フェナントレン環等の芳香族炭化水素環が挙げられ、好ましくはベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、フェナントレン環が挙げられる。

A環とB環との組合せとして、好ましくはベンゼン環とナフタレン環、ベンゼン環とアントラセン環、ベンゼン環とフェナントレン環、ナフタレン環とアントラセン環、ナフタレン環とフェナントレン環、アントラセン環とフェナントレン環の組合せが挙げられ、ベンゼン環とナフタレン環の組み合わせがより好ましい。

[0010]

なお、A環における芳香族炭化水素環とB環における芳香族炭化水素環とは互いに異なる環構造であるとは、

式(1)における

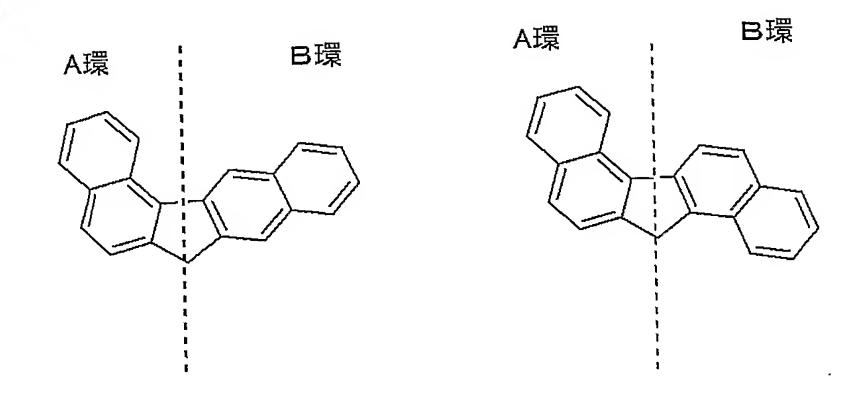


を平面構造式で表したときに、

A環における芳香族炭化水素環と、B環におけるそれとが、構造式の中央の5員環の頂点と、頂点に対向する辺の中点とを結んだ対称軸(点線)に対して非対称であることをいう

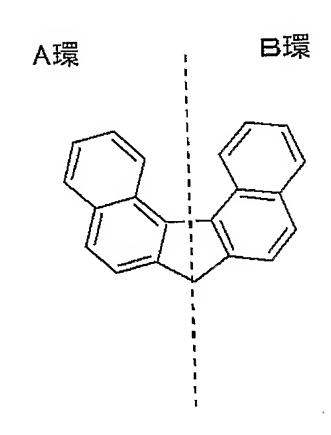
[0011]

例えば、A環およびB環がナフタレン環である場合、



の場合にはA環とB環とは環構造が異なる。

一方、A環およびB環がナフタレン環であっても、



の場合にはA環とB環とは環構造が同じである。

[0012]

芳香族炭化水素環が置換基を有する場合、置換基が、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基およびシアノ基から選ばれるものであることが好ましい。

[0013]

ここに、アルキル基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数が通常 1~20程度であり、好ましくは炭素数 3~20であり、その具体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、iープロピル基、ブチル基、iーブチル基、tーブチル基、ペンチル基、イソアミル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、2ーエチルヘキシル基、ノニル基、デシル基、3,7ージメチルオクチル基、パーフルオロヘキシル基、パーフルオロオクチル基などが挙げられ、ペンチル基、イソアミル基、ヘキシル基、オクチル基、2ーエチルヘキシル基、デシル基、3,7ージメチルオクチル基が好ましい。

$[0\ 0\ 1\ 4\]$

アルコキシ基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数が通常 $1\sim20$ 程度であり、好ましくは炭素数 $3\sim20$ であり、その具体例としては、メトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ基、i ープロピルオキシ基、ブトキシ基、i ーブトキシ基、t ーブ

トキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、3,7-ジメチルオクチルオキシ基、ラウリルオキシ基、トリフルオロメトキシ基、ペンタフルオロエトキシ基、パーフルオロブトキシ基、パーフルオロヘキシル基、パーフルオロオクチル基、メトキシメチルオキシ基、2-メトキシエチルオキシ基などが挙げられ、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、デシルオキシ基、3,7-ジメチルオクチルオキシ基が好ましい。

[0015]

アルキルチオ基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数が通常 1~20程度であり、好ましくは炭素数 3~20であり、その具体例としては、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、 iープロピルチオ基、ブチルチオ基、 iーブチルチオ基、 tーブチルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、シクロヘキシルチオ基、ヘプチルチオ基、オクチルチオ基、2ーエチルヘキシルチオ基、ノニルチオ基、デシルチオ基、3,7ージメチルオクチルチオ基、ラウリルチオ基、トリフルオロメチルチオ基などが挙げられ、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、オクチルチオ基、2ーエチルヘキシルチオ基、デシルチオ基、3,7ージメチルオクチルチオ基が好ましい。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

アリール基は、芳香族炭化水素から、水素原子1個を除いた原子団であり、縮合環をも つもの、独立したベンゼン環または縮合環2個以上が直接またはビニレン等の基を介して 結合したものも含まれる。アリール基は、炭素数が通常6~60程度であり、好ましくは 7~48であり、その具体例としては、フェニル基、C1~C12アルコキシフェニル基($C_1 \sim C_{12}$ は、炭素数 $1 \sim 1$ 2 であることを示す。以下も同様である。)、 $C_1 \sim C_{12}$ アル キルフェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントラセニル基、2ーアント ラセニル基、9-アントラセニル基、ペンタフルオロフェニル基などが例示され、C1~ C_{12} アルコキシフェニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル基が好ましい。 $C_1 \sim C_{12}$ アルコ キシとして具体的には、メトキシ、エトキシ、プロピルオキシ、iープロピルオキシ、ブ トキシ、iーブトキシ、tーブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、シクロヘキシ ルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、2-エチルヘキシルオキシ、ノニルオキシ 、デシルオキシ、3,7ージメチルオクチルオキシ、ラウリルオキシなどが例示される。 C1~C12アルキルフェニル基として具体的にはメチルフェニル基、エチルフェニル基、 ジメチルフェニル基、プロピルフェニル基、メシチル基、メチルエチルフェニル基、i-プロピルフェニル基、ブチルフェニル基、i-ブチルフェニル基、t-ブチルフェニル基 、ペンチルフェニル基、イソアミルフェニル基、ヘキシルフェニル基、ヘプチルフェニル 基、オクチルフェニル基、ノニルフェニル基、デシルフェニル基、ドデシルフェニル基な どが例示される。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

アリールオキシ基は、炭素数が通常 $6\sim 6$ 0 程度であり、好ましくは $7\sim 4$ 8 であり、その具体例としては、フェノキシ基、 $C_1\sim C_{12}$ アルコキシフェノキシ基、 $C_1\sim C_{12}$ アルキルフェノキシ基、1 ーナフチルオキシ基、2 ーナフチルオキシ基、ペンタフルオロフェニルオキシ基などが例示され、 $C_1\sim C_{12}$ アルコキシフェノキシ基、 $C_1\sim C_{12}$ アルキルフェノキシ基が好ましい。

 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシとして具体的には、メトキシ、エトキシ、プロピルオキシ、 $i-\mathcal{T}$ ロピルオキシ、ブトキシ、 $i-\mathcal{T}$ トキシ、 $t-\mathcal{T}$ トキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、シクロヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、 $2-\mathcal{I}$ エチルヘキシルオキシ、ノニルオキシ、デシルオキシ、3, $7-\mathcal{I}$ メチルオクチルオキシ、ラウリルオキシなどが例示される。

 $C_{1} \sim C_{12}$ アルキルフェノキシ基として具体的にはメチルフェノキシ基、エチルフェノキシ基、ジメチルフェノキシ基、プロピルフェノキシ基、1,3,5ートリメチルフェノキシ基基、iー基、メチルエチルフェノキシ基、iープロピルフェノキシ基、ブチルフェノキシ基、iーブチルフェノキシ基、iーブチルフェノキシ基、iーブチルフェノキシ基、iーブチルフェノキシ基、iーブチルフェノキシ

ノキシ基、ヘキシルフェノキシ基、ヘプチルフェノキシ基、オクチルフェノキシ基、ノニ ルフェノキシ基、デシルフェノキシ基、ドデシルフェノキシ基などが例示される。

[0018]

アリールチオ基は、炭素数が通常3~60程度であり、その具体例としては、フェニル チオ基、C1~C12アルコキシフェニルチオ基、C1~C12アルキルフェニルチオ基、1-ナフチルチオ基、2ーナフチルチオ基、ペンタフルオロフェニルチオ基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニルチオ基が好ましい。

[0019]

アリールアルキル基は、炭素数が通常7~60程度であり、好ましくは7~48であり 、その具体例としては、フェニルーC₁~C₁₂アルキル基、C₁~C₁₂アルコキシフェニル $-C_1 \sim C_{12}$ アルキル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニルー $C_1 \sim C_{12}$ アルキル基、1-ナフ チルー C_1 ~ C_{12} アルキル基、2ーナフチルー C_1 ~ C_{12} アルキル基などが例示され、 C_1 $\sim C_{12}$ アルコキシフェニルー $C_1 \sim C_{12}$ アルキル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニルー $C_1 \sim$ C12アルキル基が好ましい。

[0020]

アリールアルコキシ基は、炭素数が通常7~60程度であり、好ましくは炭素数7~4 8であり、その具体例としては、フェニルメトキシ基、フェニルエトキシ基、フェニルブ トキシ基、フェニルペンチロキシ基、フェニルヘキシロキシ基、フェニルヘプチロキシ基 、フェニルオクチロキシ基などのフェニルーC1~C12アルコキシ基、C1~C12アルコキ シフェニルー C_1 ~ C_{12} アルコキシ基、 C_1 ~ C_{12} アルキルフェニルー C_1 ~ C_{12} アルコキ シ基、1ーナフチルーC1~C12アルコキシ基、2ーナフチルーC1~C12アルコキシ基な どが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニルー $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アル キルフェニルーC1~C12アルコキシ基が好ましい。

[0021]

アリールアルキルチオ基は、炭素数が通常7~60程度であり、好ましくは炭素数7~ 48であり、その具体的としては、フェニルー $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アル コキシフェニルー C_1 ~ C_{12} アルキルチオ基、 C_1 ~ C_{12} アルキルフェニルー C_1 ~ C_{12} ア ルキルチオ基、1-ナフチルーC1~C12アルキルチオ基、2-ナフチルーC1~C12アル キルチオ基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニルー $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニルー $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基が好ましい。

[0022]

アリールアルケニル基は、炭素数が通常8~60程度であり、その具体的としては、フ ェニルー C_2 ~ C_{12} アルケニル基、 C_1 ~ C_{12} アルコキシフェニルー C_2 ~ C_{12} アルケニル 基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニルー $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル基、1ーナフチルー $C_2 \sim C_{12}$ ア ルケニル基、2-ナフチルー C_2 ~ C_{12} アルケニル基などが例示され、 C_1 ~ C_{12} アルコキ シフェニルーC2~C12アルケニル基、C2~C12アルキルフェニルーC1~C12アルケニ ル基が好ましい。

[0023]

アリールアルキニル基は、炭素数が通常8~60程度であり、その具体的としては、フ ェニルーC2~C12アルキニル基、C1~C12アルコキシフェニルーC2~C12アルキニル 基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニルー $C_2 \sim C_{12}$ アルキニル基、1-ナフチルー $C_2 \sim C_{12}$ ア ルキニル基、2-ナフチルーC2~C12アルキニル基などが例示され、C1~C12アルコキ シフェニルー C_2 ~ C_{12} アルキニル基、 C_1 ~ C_{12} アルキルフェニルー C_2 ~ C_{12} アルキニ ル基が好ましい。

[0024]

置換アミノ基としては、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複 素環基から選ばれる1または2個の基で置換されたアミノ基があげられ、該アルキル基、 アリール基、アリールアルキル基または1価の複素環基は置換基を有していてもよい。置 換アミノ基の炭素数は該置換基の炭素数を含めないで通常1~60程度であり、好ましく は炭素数2~48である。

具体的には、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基 、プロピルアミノ基、ジプロピルアミノ基、i-プロピルアミノ基、ジイソプロピルアミ ノ基、ブチルアミノ基、i-ブチルアミノ基、t-ブチルアミノ基、ペンチルアミノ基、 ヘキシルアミノ基、シクロヘキシルアミノ基、ヘプチルアミノ基、オクチルアミノ基、2 - エチルヘキシルアミノ基、ノニルアミノ基、デシルアミノ基、3,7ージメチルオクチ ルアミノ基、ラウリルアミノ基、シクロペンチルアミノ基、ジシクロペンチルアミノ基、 シクロヘキシルアミノ基、ジシクロヘキシルアミノ基、ピロリジル基、ピペリジル基、ジ トリフルオロメチルアミノ基フェニルアミノ基、ジフェニルアミノ基、C1~C12アルコ キシフェニルアミノ基、ジ (C1~C12アルコキシフェニル) アミノ基、ジ (C1~C12ア ルキルフェニル)アミノ基、1ーナフチルアミノ基、2ーナフチルアミノ基、ペンタフル オロフェニルアミノ基、ピリジルアミノ基、ピリダジニルアミノ基、ピリミジルアミノ基 、ピラジルアミノ基、トリアジルアミノ基フェニルーC₁~C₁₂アルキルアミノ基、C₁~ C_{12} アルコキシフェニルー C_1 ~ C_{12} アルキルアミノ基、 C_1 ~ C_{12} アルキルフェニルーC $_{1}$ ~ C_{12} アルキルアミノ基、ジ(C_{1} ~ C_{12} アルコキシフェニルー C_{1} ~ C_{12} アルキル)ア ミノ基、ジ (C1~C12アルキルフェニルーC1~C12アルキル) アミノ基、1ーナフチル -C1~C12アルキルアミノ基、2-ナフチル-C1~C12アルキルアミノ基などが例示さ れる。

[0025]

置換シリル基としては、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複 素環基から選ばれる1、2または3個の基で置換されたシリル基があげられる。置換シリ ル基の炭素数は通常1~60程度であり、好ましくは炭素数3~48である。なお該アル キル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複素環基は置換基を有していても よい。

具体的には、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリプロピルシリル基、トリ - i ープロピルシリル基、ジメチルー i ープロピリシリル基、ジエチルー i ープロピルシ リル基、tーブチルシリルジメチルシリル基、ペンチルジメチルシリル基、ヘキシルジメ チルシリル基、ヘプチルジメチルシリル基、オクチルジメチルシリル基、2-エチルヘキ シルージメチルシリル基、ノニルジメチルシリル基、デシルジメチルシリル基、3,7-ジメチルオクチルージメチルシリル基、ラウリルジメチルシリル基、フェニルーC1~C1 2アルキルシリル基、C1~C12アルコキシフェニルーC1~C12アルキルシリル基、C1~ C12アルキルフェニルーC1~C12アルキルシリル基、1ーナフチルーC1~C12アルキル シリル基、2-ナフチルーC1~C12アルキルシリル基、フェニルーC1~C12アルキルジ メチルシリル基、トリフェニルシリル基、トリーp-キシリルシリル基、トリベンジルシ リル基、ジフェニルメチルシリル基、tーブチルジフェニルシリル基、ジメチルフェニル シリル基などが例示される。

[0026]

ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が例示される。

[0027]

アシル基は、炭素数が通常2~20程度であり、好ましくは炭素数2~18であり、そ の具体例としては、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、ピバロ イル基、ベンゾイル基、トリフルオロアセチル基、ペンタフルオロベンゾイル基などが例 示される。

[0028]

アシルオキシ基は、炭素数が通常2~20程度であり、好ましくは炭素数2~18であ り、その具体例としては、アセトキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基、イ ソブチリルオキシ基、ピバロイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基、トリフルオロアセチル オキシ基、ペンタフルオロベンゾイルオキシ基などが例示される。

[0029]

イミン残基は、炭素数2~20程度であり、好ましくは炭素数2~18であり、その具 体例としては、以下の構造式で示される基などが例示される。

[0030]

アミド基は、炭素数が通常2~20程度であり、好ましくは炭素数2~18であり、そ の具体例としては、ホルムアミド基、アセトアミド基、プロピオアミド基、ブチロアミド 基、ベンズアミド基、トリフルオロアセトアミド基、ペンタフルオロベンズアミド基、ジ ホルムアミド基、ジアセトアミド基、ジプロピオアミド基、ジブチロアミド基、ジベンズ アミド基、ジトリフルオロアセトアミド基、ジペンタフルオロベンズアミド基、などが例 示される。

[0031]

酸イミド基は、酸イミドからその窒素原子に結合した水素原子を除いて得られる残基が 挙げられ、炭素数が4~20程度であり、具体的には以下に示す基などが例示される。

[0032]

1価の複素環基とは、複素環化合物から水素原子1個を除いた残りの原子団をいい、炭 素数は通常4~60程度であり、好ましくは4~20である。なお、複素環基の炭素数に は、置換基の炭素数は含まれない。ここに複素環化合物とは、環式構造をもつ有機化合物 のうち、環を構成する元素が炭素原子だけでなく、酸素、硫黄、窒素、燐、硼素などのへ テロ原子を環内に含むものをいう。具体的には、チエニル基、C1~C12アルキルチエニ ル基、ピロリル基、フリル基、ピリジル基、C1~C12アルキルピリジル基、ピペリジル

基、キノリル基、イソキノリル基などが例示され、チエニル基、C1~C12アルキルチエ ニル基、ピリジル基、C1~C12アルキルピリジル基が好ましい。

[0033]

置換カルボキシル基は、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複 素環基で置換されたカルボキシル基をいい、炭素数が通常2~60程度であり、好ましく は炭素数2~48であり、その具体例としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボ ニル基、プロポキシカルボニル基、iープロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基 、i-ブトキシカルボニル基、t-ブトキシカルボニル基、ペンチルオキシカルボニル基 、ヘキシロキシカルボニル基、シクロヘキシロキシカルボニル基、ヘプチルオキシカルボ ニル基、オクチルオキシカルボニル基、2-エチルヘキシロキシカルボニル基、ノニルオ キシカルボニル基、デシロキシカルボニル基、3,7ージメチルオクチルオキシカルボニ ル基、ドデシルオキシカルボニル基、トリフルオロメトキシカルボニル基、ペンタフルオ ロエトキシカルボニル基、パーフルオロブトキシカルボニル基、パーフルオロヘキシルオ キシカルボニル基、パーフルオロオクチルオキシカルボニル基、フェノキシカルボニル基 、ナフトキシカルボニル基、ピリジルオキシカルボニル基、などが挙げられる。なお該ア ルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複素環基は置換基を有していて もよい。置換カルボキシル基の炭素数には該置換基の炭素数は含まれない。

$[0\ 0\ 3\ 4]$

式(1)中、RwおよびRxはそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、 アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基 、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールア ルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル 基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシ ル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表し、RwとRxはそれぞれ互いに結合して 環を形成していてもよい。

RwおよびRxにおける、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、 アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリ ールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、置換アミノ基、置 換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミ ド基、1価の複素環基、置換カルボキシル基の定義、具体例は、上記芳香族炭化水素環が 置換基を有する場合の置換基におけるそれらの定義、具体例と同様である。

[0035]

RwとRxがそれぞれ結合して環を形成する場合、その環としては、置換基を有していて もよいC4~C10シクロアルキル環、C4-C10シクロアルケニル環、C4~C10複素環が 例示される。これらの環は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、ハロゲン原子 等で置換されていてもよい。

[0036]

シクロアルキル環としては、シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロ ヘプタン、シクロオクタン、シクロノナン、シクロデカンなどが例示される。

[0037]

シクロアルケニル環は、二重結合を2つ以上するものも含みその具体例としては、シク ロヘキセン環、シクロヘキサジエン環、シクロオクタトリエン環などが例示される。

[0038]

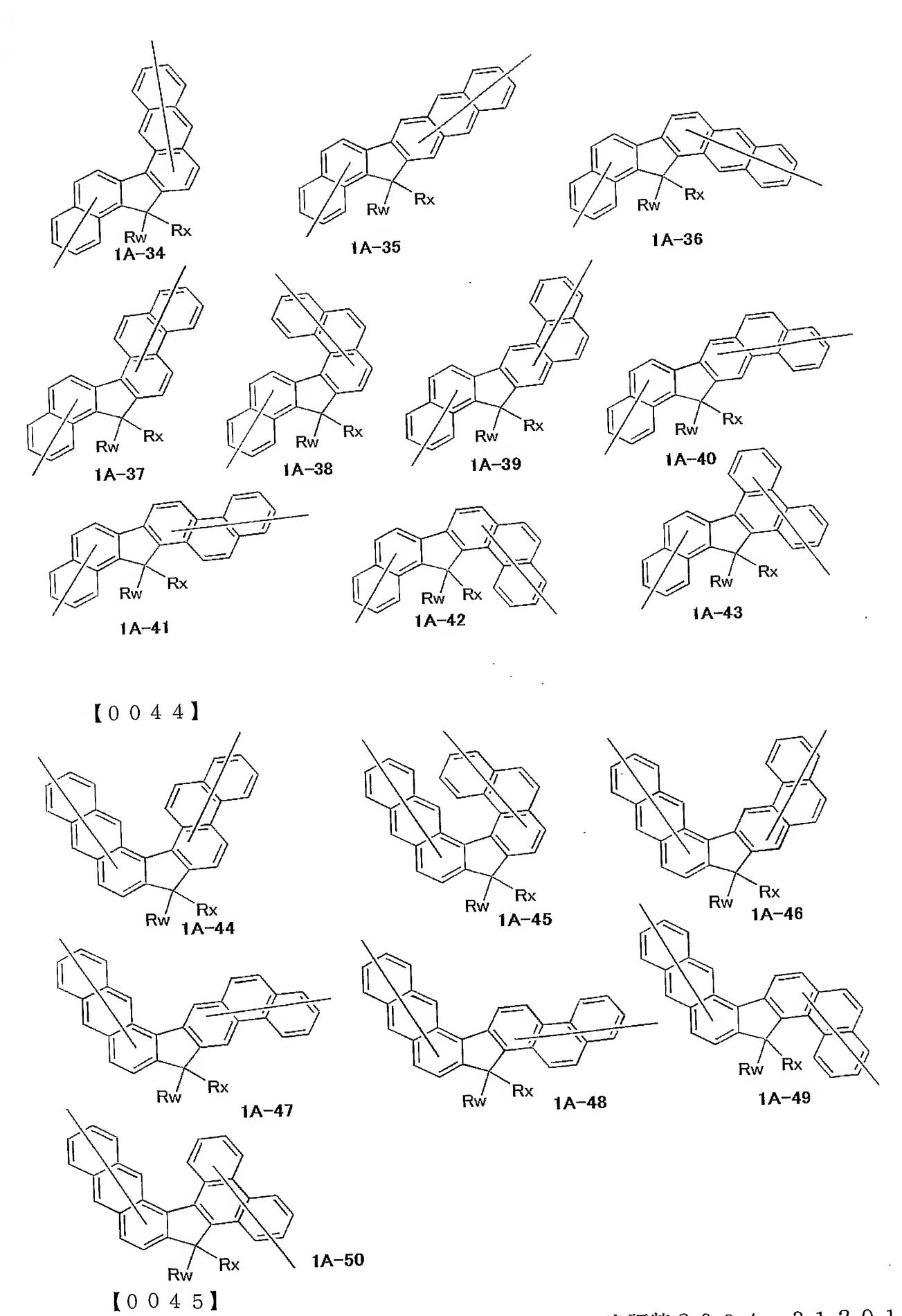
複素環としては、テトラヒドロフラン環、テトラヒドロチオフェン環、テトラヒドロイン ドール環、テトラヒドロキノリン環、ヘキサヒドロピリジン環、テトラヒドロイソキノリ ン環などが例示される。

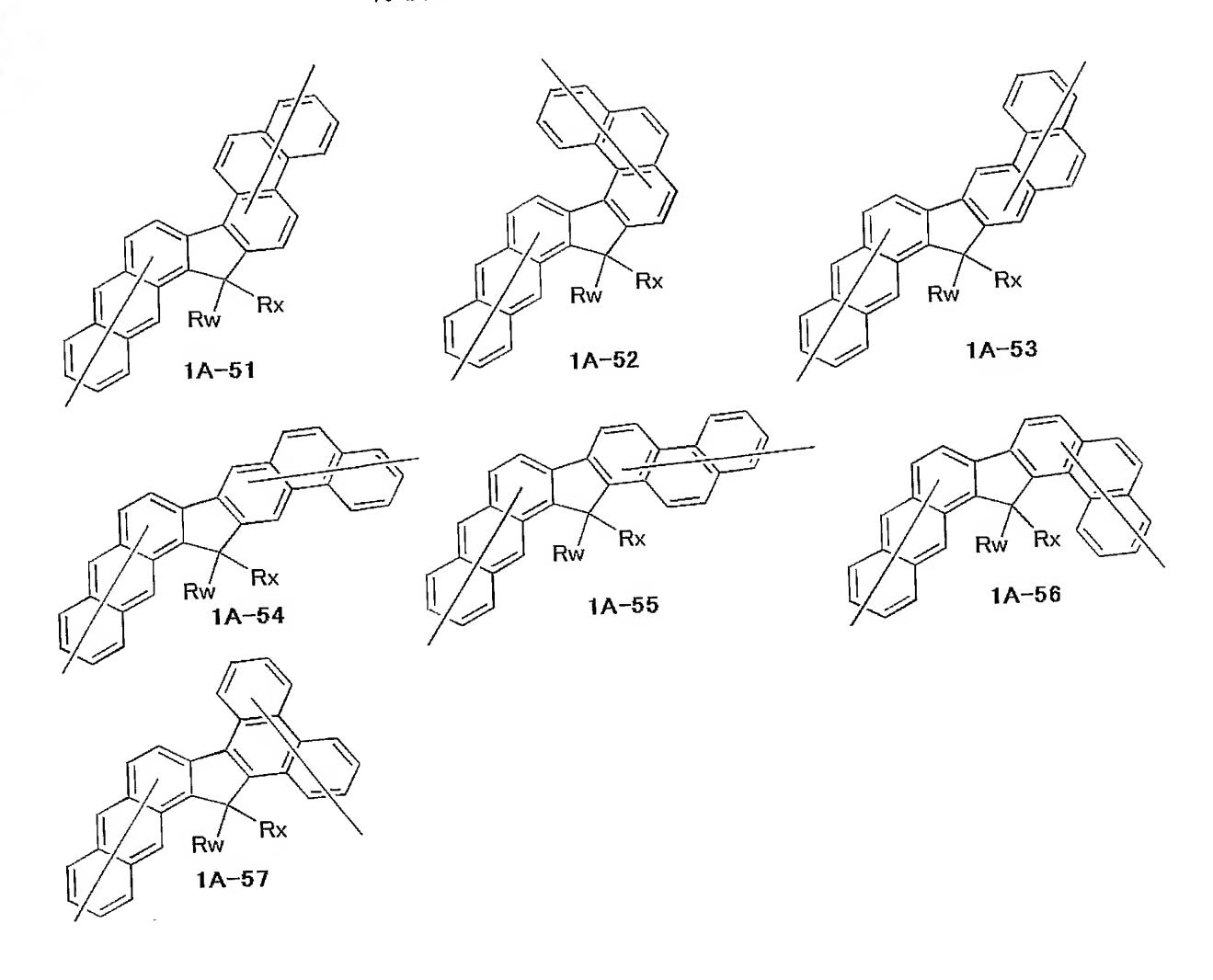
[0039]

式(1)の繰り返し単位として、具体的には、以下のもの、以下のものに、アルキル基 、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、ア リールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニ

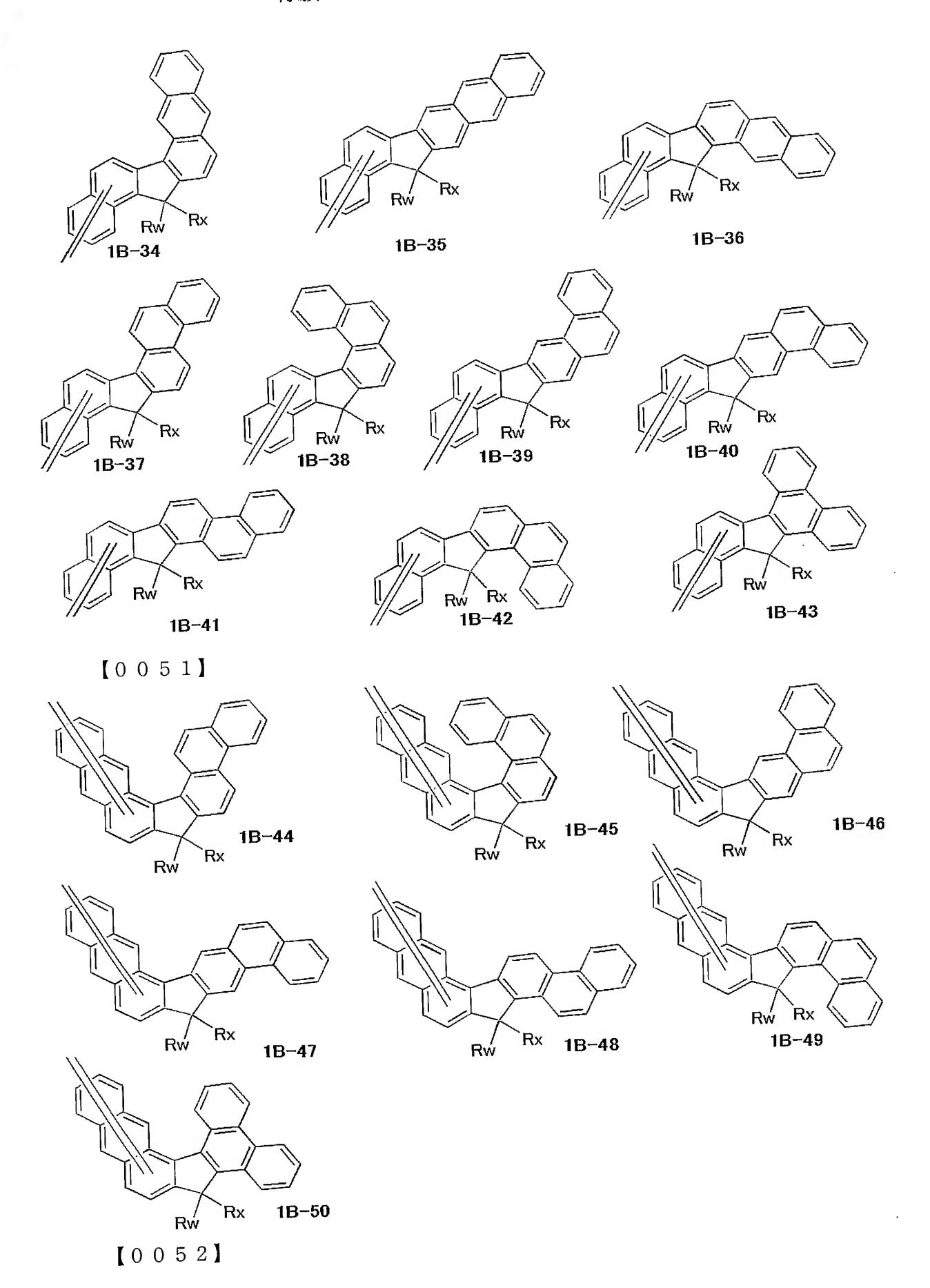
ル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロ ゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素 環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基およびシアノ基等の置換基を有するものが挙 げられる

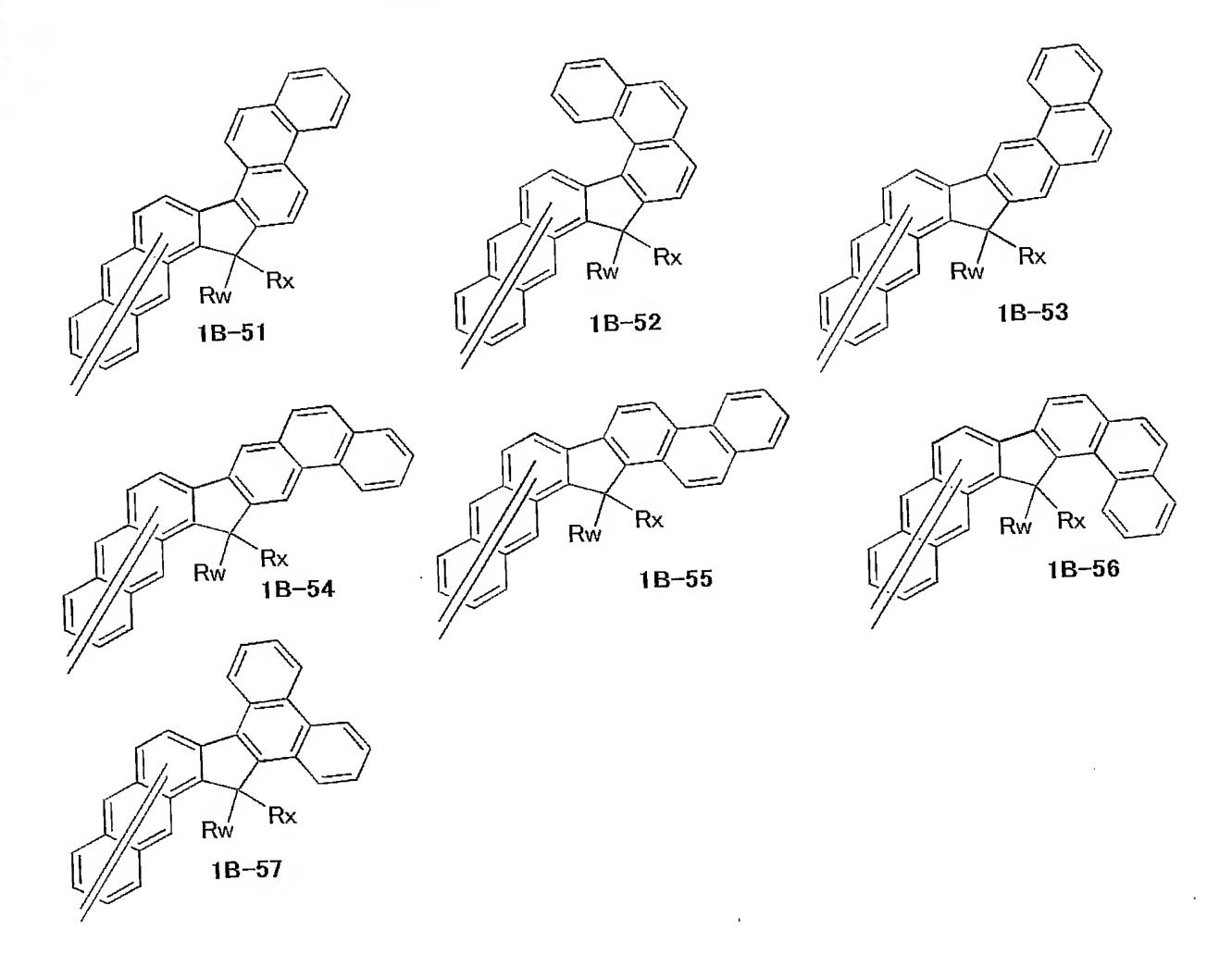
なお、以下において、芳香族炭化水素環における結合手は、任意の位置をとり得ることを 表す。



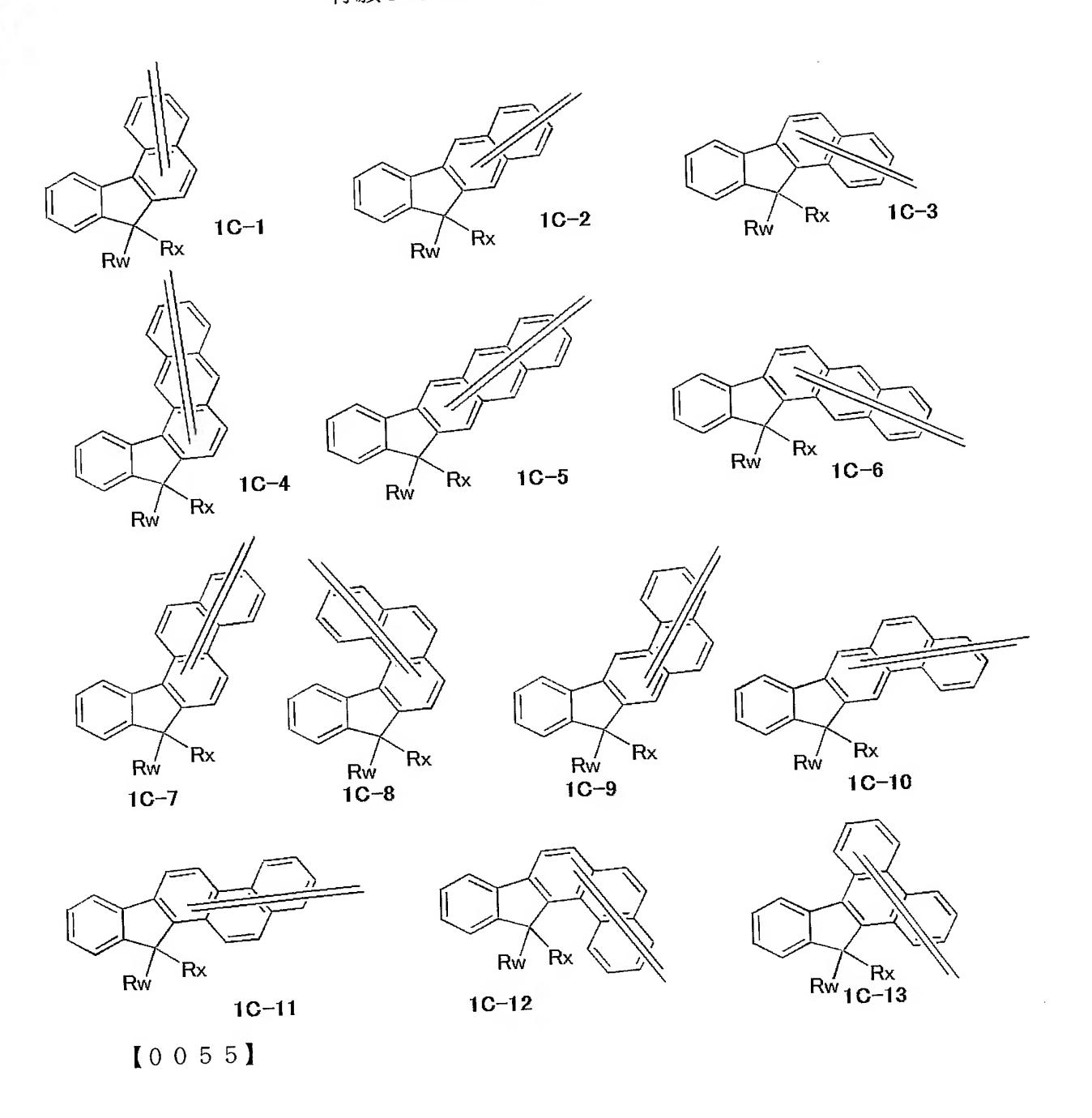


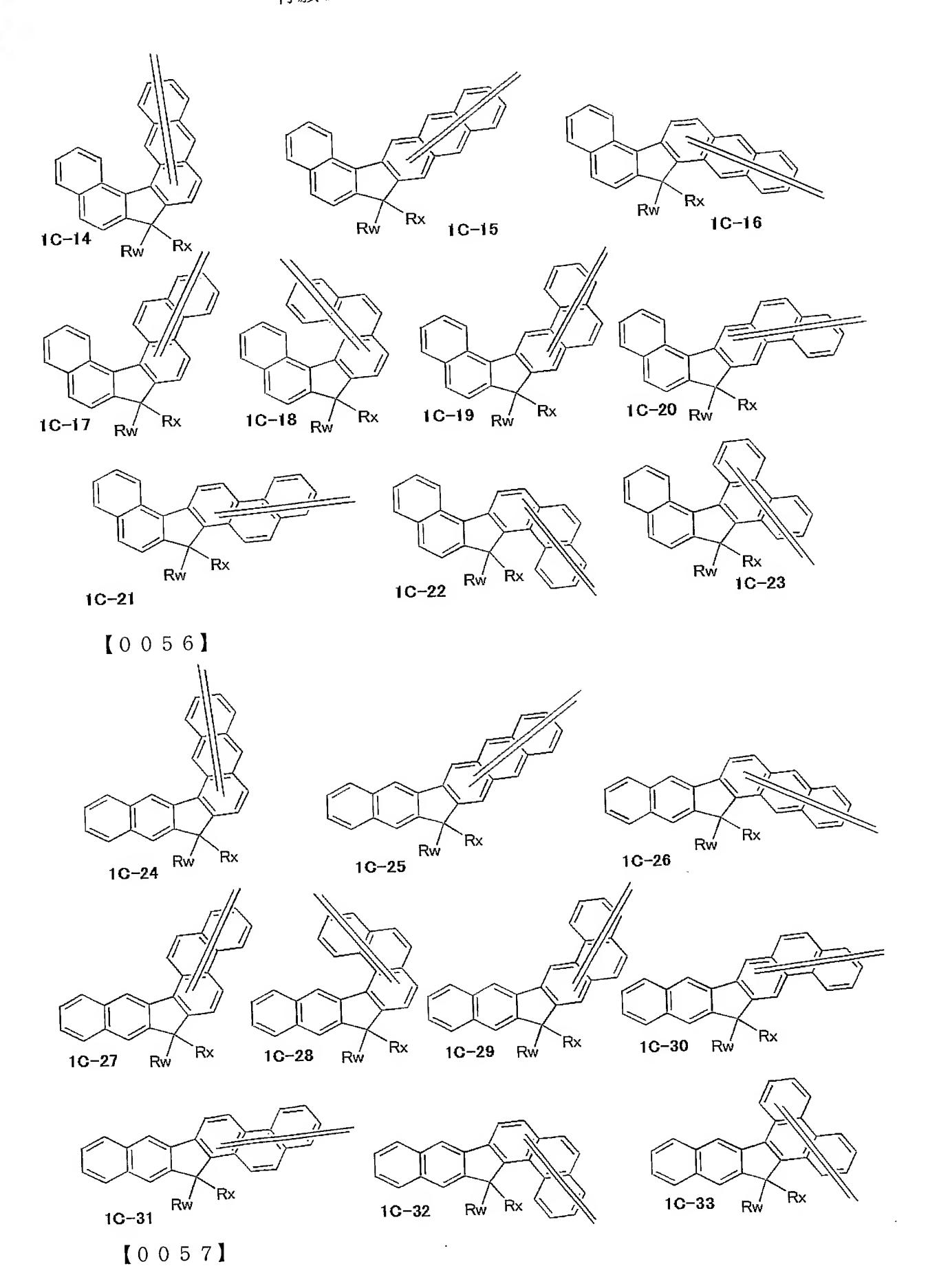
[0046]





[0053]





〔式中、RwおよびRxは前記と同じ意味を表す。〕

[0060]

上記式(1)で示される繰り返し単位において、好ましくは、2つの結合手がそれぞれ A環およびB環上に一つずつ存在するものであり、より好ましくは、A環とB環が、それ ぞれベンゼン環とナフタレン環との組合せからなるものである。

中でも、下記式 (1-1) 、 (1-2) で示される繰り返し単位、 (1-3) 、 (1-1)4) で示される繰り返し単位が好ましい。

$$(R_{q1})_b$$
 $(R_{p2})_a$
 R_{w1}
 R_{x1}
 $(R_{p2})_a$
 $(R_{p3})_a$
 $(R_{p3})_a$
 $(R_{p3})_a$
 $(R_{p3})_a$
 $(R_{p3})_a$
 $(R_{p3})_b$
 $(R_{p4})_a$
 $(R_{p4})_a$

〔式中、 R_{p1} 、 R_{q1} 、 R_{p2} 、 R_{q2} 、 R_{p3} 、 R_{q3} 、 R_{p4} および R_{q4} はそれぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルカル基、アリールアルカル基、アリールアルカル基、アリールアルカル基、アリールアルカル基、アリールアルカル基、置換アミノ基、置換アミノ基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表す。 a は 0 ~ 3 の整数を表し、b は 0 ~ 5 の整数を表す。 R_{p1} 、 R_{q1} 、 R_{p2} 、 R_{q2} 、 R_{p3} 、 R_{q3} R_{p4} および R_{q4} が複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。 R_{w1} 、 R_{x1} 、 R_{w2} 、 R_{x2} 、 R_{w3} 、 R_{x3} 、 R_{w4} および R_{x4} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリールアルキル基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルカチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルチャンル基、アミノ基、置換アミノ基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表し、 R_{w1} と R_{x4} に R_{w2} と R_{x3} 、 R_{w4} と R_{x4} はそれぞれ互いに結合して環を形成していてもよい。〕

$[0\ 0\ 6\ 1]$

上記式(1-1)、(1-2)、(1-3)または(1-4)において、 R_{p1} 、 R_{q1} 、 R_{p2} 、 R_{q2} 、 R_{p3} 、 R_{q3} 、 R_{p4} および R_{q4} としてはアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、置換アミノ基、置換シリル基、フッ素原子、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基およびシアノ基が好ましく、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルキルチオ基がさらに好ましい。

[0062]

上記式 (1-1)、 (1-2)、 (1-3) および (1-4) において、 R_{w1} 、 R_{x1} 、 R_{w2} 、 R_{x2} 、 R_{w3} 、 R_{x3} 、 R_{w4} および R_{x4} としてはアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキルチオ基、置換アミノ基、置換シリル基、フッ素原子、ルアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、置換アミノ基、置換シリル基、フッ素原子、

アシル基、アシルオキシ基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、 置換カルボキシル基およびシアノ基が好ましく、アルキル基、アルコキシ基、アリール基 、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチ オ基がより好ましく、アルキル基、アルコキシ基、アリール基がさらに好ましい。アルキ ル基、アルコキシ基、アリール基として、より具体的には、メチル基、エチル基、プロピ ル基、iープロピル基、ブチル基、iーブチル基、tーブチル基、ペンチル基、イソアミ ル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、ヘプチル基、シクロヘキシルメチル基、オクチル 基、2-エチルヘキシル基、ノニル基、デシル基、3,7-ジメチルオクチル基、ラウリ ル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、パーフルオロブチル基、パーフ ルオロヘキシル基、パーフルオロオクチル基等の炭素数が通常1~20程度の直鎖、分岐 または環状のアルキル基、

メトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ基、iープロピルオキシ基、ブトキシ基、 i ーブトキシ基、 t ーブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、シクロヘキシル オキシ基、ヘプチルオキシ基、シクロヘキシルメチルオキシ基、オクチルオキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、3,7ージメチルオクチル オキシ基、ラウリルオキシ基、トリフルオロメトキシ基、ペンタフルオロエトキシ基、パ ーフルオロブトキシ基、パーフルオロヘキシル基、パーフルオロオクチル基、メトキシメ チルオキシ基、2ーメトキシエチルオキシ基等の炭素数が通常1~20程度のアルコキシ 基、

フェニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル基($C_1 \sim C_{12}$ は、炭素数 $1 \sim 12$ であること を示す。以下も同様である。)、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル基、1ーナフチル基、2ー ナフチル基、1-アントラセニル基、2-アントラセニル基、9-アントラセニル基、ペ ンタフルオロフェニル基等の炭素数が通常6~60程度のアリール基等が例示される。 ここに、C1~C12アルコキシとして具体的には、メトキシ、エトキシ、プロピルオキシ 、iープロピルオキシ、ブトキシ、iーブトキシ、tーブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキ シルオキシ、シクロヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、2-エチルヘキ シルオキシ、ノニルオキシ、デシルオキシ、3,7ージメチルオクチルオキシ、ラウリル オキシなどが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル基として具体的にはメチルフェニル 基、エチルフェニル基、ジメチルフェニル基、プロピルフェニル基、メシチル基、メチル エチルフェニル基、i-プロピルフェニル基、ブチルフェニル基、i-ブチルフェニル基 、t-ブチルフェニル基、ペンチルフェニル基、イソアミルフェニル基、ヘキシルフェニ ル基、ヘプチルフェニル基、オクチルフェニル基、ノニルフェニル基、デシルフェニル基 、ドデシルフェニル基などが例示される。

[0063]

上記式(1-1)、(1-2)、(1-3)および(1-4)で示される繰り返し単位の 具体例として、Rw1とRx1、Rw2とRx2、Rw3とRx3、Rw4とRx4がそれぞれ互いに結合 して環を形成しているものとしては、それぞれ、下記式群(1-1-2)、(1-2-2)、(1-3-2)および(1-4-2)が例示される。

[0064]

[0068]

上記式 (1-1) および (1-2) において、a=b=0 であることが、高分子量化の観点および耐熱性向上の観点から好ましい。

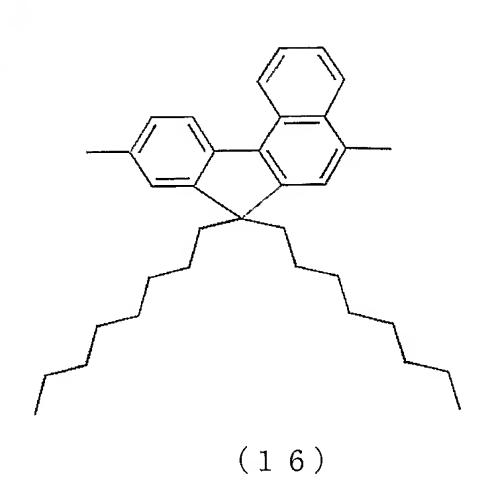
式群(1-4-2)

[0069]

本発明の高分子化合物のなかで、原料化合物の合成の容易さからは、式 (1-1)、 (1-3)、 (1-4) で示される繰り返し単位を含むものが好ましく、さらに好ましくは式 (1-1) である。

[0070]

合成した高分子化合物の溶解性を向上させる観点から、 R_{w1} 、 R_{x1} はアルキル基が好ましく、炭素数が3以上のものがさらに好ましい。最も好ましくはn-オクチル基であり、下記式(16)で示される構造である。



【0071】 本発明の高分子化合物としては、繰り返し単位として、インデン環にナフタレン環が縮合してなる構造を有し、該インデン環の5員環と該ナフタレン環とは、共通原子として2個の炭素原子を持ち、ポリスチレン換算の数平均分子量が $10^3 \sim 10^8$ であることを特徴とする高分子化合物があげられる。『該インデン環の5員環と該ナフタレン環とは、共通原子として2個の炭素原子を持ち、』とは、言い換えれば、『該インデン環の5員環と該ナフタレン環が、該5員環の隣接する2個の炭素原子を共有し、』ということである。

[0072]

本発明の高分子化合物が有する繰り返し単位(1)の量の合計は、本発明の高分子化合物が有する全繰り返し単位の合計の通常1モル%以上100モル%以下であり、20モル%以上であることが好ましく、30モル%以上100モル%以下であることがさらに好ましい。

[0073]

本発明の高分子化合物の中で、繰り返し単位として式(1)で示される繰り返し単位を2種類有するものとしては、2種の繰り返し単位であって、繰り返し単位の置換基を除いた環構造が同一で、芳香環上の置換基の有無、置換基の種類、RwおよびRxのいずれかが異なる2種の繰り返し単位(繰り返し単位(a)(b)呼ぶ)からなる共重合体であるものが挙げられる。この共重合体は、繰り返し単位(a)のみからなる単独重合体、繰り返し単位(b)のみからなる単独重合体にくらべて溶解性に優れ得る。

具体的には、上記式 (1-1) から選ばれる2種からなる共重合体、上記式 (1-2) から選ばれる2種からなる共重合体、上記式 (1-3) から選ばれる2種からなる共重合体、上記式 (1-4) から選ばれる2種からなる共重合体等があげられる。

中でも、高分子化合物の製造時における反応性の制御しやすさの観点からは、(a)(b)として、芳香環上に置換基を有しないかまたは、芳香環上の置換基は同一であるものであって、Rwおよび/またはRxで示される基が異なるものを有する共重合体が好ましい。

[0074]

本発明の高分子化合物は、発光波長を変化させる観点、発光効率を高める観点、耐熱性を向上させる観点等から、本発明の高分子化合物が有する繰り返し単位(1)に加え、それ以外の繰り返し単位を1種類以上含む共重合体が好ましい。繰り返し単位(1)以外の繰り返し単位としては、下記式(3)、式(4)、式(5)または式(6)で示される繰り返し単位が好ましい。

$$-A r_1 - (3)$$

式中、Ar1、Ar2、Ar3およびAr4はそれぞれ独立にアリーレン基、2価の複素環基 または金属錯体構造を有する2価の基を示す。X1、X2およびX3はそれぞれ独立に-C $R_9 = C R_{10} -$ 、 $-C \equiv C -$ 、 $-N (R_{11}) -$ 、または $- (S i R_{12} R_{13})_m -$ を示す。R 9およびR10は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1価の複素環基、 カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。R11、R12およびR13は、 それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1価の複素環基、アリールアルキル 基または置換アミノ基を示す。 f f は l または 2 を示す。mは l \sim 1 2 の整数を示す。 R9 、R10、R11、R12およびR13がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なって いてもよい。

[0075]

ここでアリーレン基とは、芳香族炭化水素から、水素原子2個を除いた原子団であり、 、縮合環をもつもの、独立したベンゼン環または縮合環2個以上が直接またはビニレン等 の基を介して結合したものも含まれる。アリーレン基は置換基を有していてもよい。 置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオ キシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキ ルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シ リル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド 基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基、シアノ基が挙 げられる。

アリーレン基における置換基を除いた部分の炭素数は通常6~60程度であり、好まし くは6~20である。また、アリーレン基の置換基を含めた全炭素数は、通常6~100 程度である。

アリーレン基としては、フェニレン基(例えば、下図の式1~3)、ナフタレンジイル 基(下図の式4~13)、アントラセンージイル基(下図の式14~19)、ビフェニル -ジイル基(下図の式20~25)、フルオレンージイル基(下図の式36~38)、タ ーフェニルージイル基(下図の式26~28)、縮合環化合物基(下図の式29~35) 、スチルベンージイル(下図の式A~D), ジスチルベンージイル などが例示される。中でもフェニレン基、ビフェニレン基、フルオレンージイル基、ス チルベンージイル基が好ましい。

[0076]

[0077]

[0082]

また、Ar1、Ar2、Ar3およびAr4における2価の複素環基とは、複素環化合物から 水素原子2個を除いた残りの原子団をいい、該基は置換基を有していてもよい。

ここに複素環化合物とは、環式構造をもつ有機化合物のうち、環を構成する元素が炭素原 子だけでなく、酸素、硫黄、窒素、リン、ホウ素、ヒ素などのヘテロ原子を環内に含むも のをいう。2価の複素環基の中では、芳香族複素環基が好ましい。

置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオ キシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキ ルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シ リル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド 基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基、シアノ基が挙 げられる。

2価の複素環基における置換基を除いた部分の炭素数は通常3~60程度である。また 、2価の複素環基の置換基を含めた全炭素数は、通常3~100程度である。

[0083]

2 価の複素環基としては、例えば以下のものが挙げられる。

ヘテロ原子として、窒素を含む2価の複素環基;ピリジンージイル基(下図の式39~ 44)、ジアザフェニレン基(下図の式45~48)、キノリンジイル基(下図の式49 ~63)、キノキサリンジイル基(下図の式64~68)、アクリジンジイル基(下図の 式69~72)、ビピリジルジイル基(下図の式73~75)、フェナントロリンジイル 基(下図の式76~78)、など。

ヘテロ原子としてけい素、窒素、セレンなどを含みフルオレン構造を有する基(下図の式 79~93)

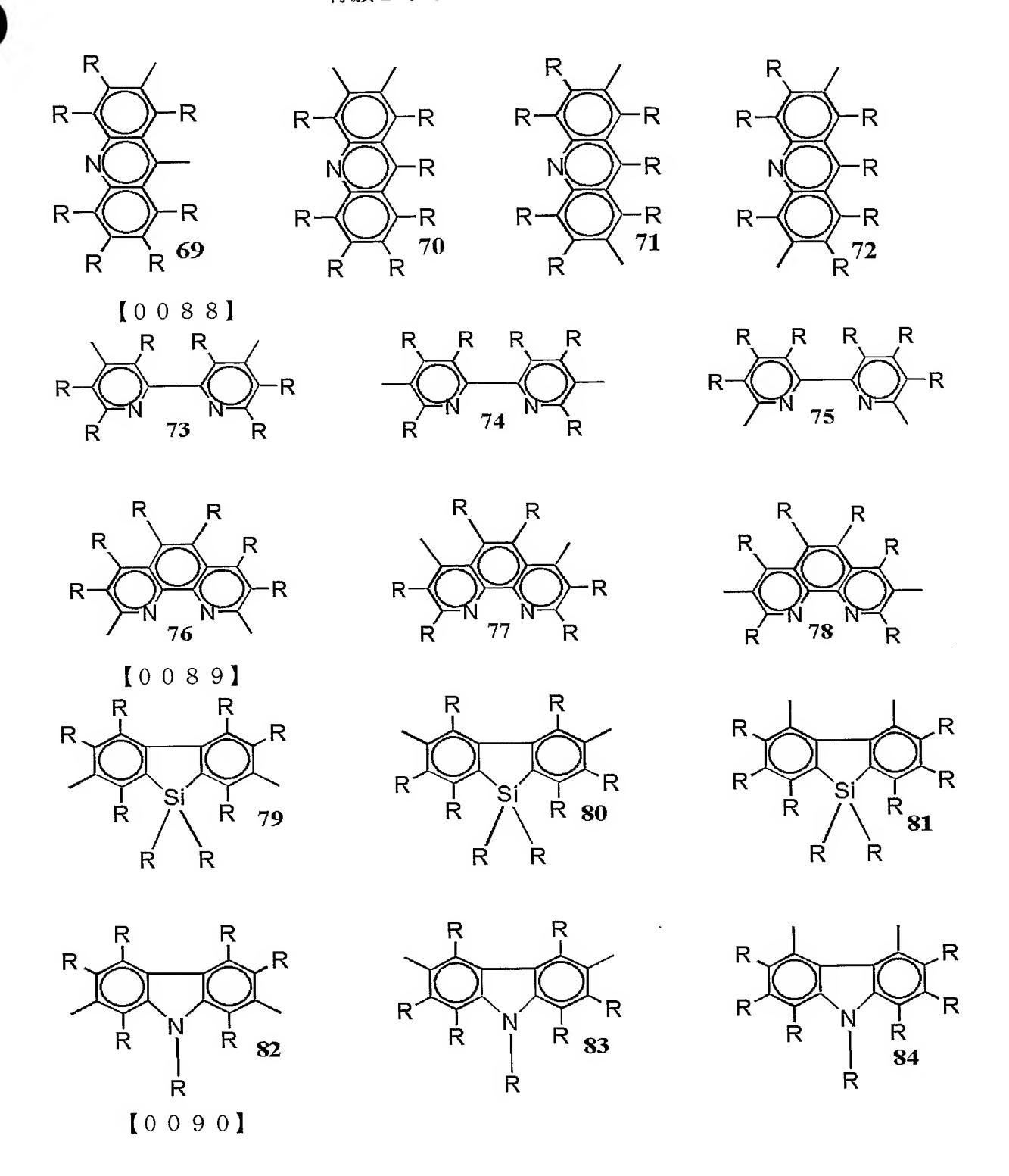
ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを含む5員環複素環基: (下図の式 94~98) が挙げられる。

ヘテロ原子としてけい素、窒素、セレンなどを含む5員環縮合複素基: (下図の式99 出証特2004-3120184 ~108)が挙げられる。

ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを含む5員環複素環基でそのヘテロ 原子のα位で結合し2量体やオリゴマーになっている基: (下図の式109~113) が 挙げられる。

ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを含む 5 員環複素環基でそのヘテロ 原子の α 位でフェニル基に結合している基: (下図の式113~119) が挙げられる。 ヘテロ原子として酸素、窒素、硫黄、などを含む5員環縮合複素環基にフェニル基やフリ ル基、チエニル基が置換した基: (下図の式120~125)が挙げられる。

[0084]



[0094]

また、Ar1、Ar2、Ar3およびAr4における金属錯体構造を有する2価の基とは、有機配位子を有する金属錯体の有機配位子から水素原子を2個除いた残りの2価の基である。

該有機配位子の炭素数は、通常4~60程度であり、その例としては、8ーキノリノールおよびその誘導体、ベンゾキノリノールおよびその誘導体、2ーフェニルーピリジンおよびその誘導体、2ーフェニルーベンゾチアゾールおよびその誘導体、2ーフェニルーベンゾキサゾールおよびその誘導体、ポルフィリンおよびその誘導体などが挙げられる。

また、該錯体の中心金属としては、例えば、アルミニウム、亜鉛、ベリリウム、イリジウム、白金、金、ユーロピウム、テルビウムなどが挙げられる。

有機配位子を有する金属錯体としては、低分子の蛍光材料、燐光材料として公知の金属錯

体、三重項発光錯体などが挙げられる。

[0095]

金属錯体構造を有する2価の基としては、具体的には、以下の(126~132)が例 示される。

上記の式 $1 \sim 132$ において、R はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールテルキ 水基、アリールアルカチオ基、アリールアルキル基、アリールアルカチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルカール基、アリールアルカール基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。また、式 $1 \sim 132$ の基が有する炭素原子は、窒素原子、酸素原子または硫黄原子と置き換えられていてもよく、水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。

[0097]

上記式 (3) で示される繰り返し単位の中では、下記式 (7)、式 (8)、式 (9)、式 (10)、式 (11)、または式 (12)で示される繰り返し単位が好ましい。

$$\begin{pmatrix}
R_{14} \\
 - \\
 -
\end{pmatrix}$$
(7)

〔式中、R₁₄は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオ 出証特2004-3120184 キシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。nは $0\sim4$ の整数を示す。 R_{14} が複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。]

〔式中、 R_{15} および R_{16} は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールオール基、アリールアルキル基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルをこり、アシル基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。0および0はそれぞれ独立に0~00整数を示す。015 および016がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

$$\begin{array}{c|c}
 & R_{17} \\
 & R_{18} \\
\hline
 & R_{19} \\
\hline
 & R_{20} \\
 & R$$

〔式中、R17およびR20は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルキル基、アリールアルキール基、アリールアルキン基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリールアルキール基、アリール基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。Qおよびrはそれぞれ独立に $0\sim4$ の整数を示す。R18およびR19は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。R17およびR20が複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

$$\begin{array}{c}
X_4 \\
N \\
N \\
N \\
N \\
N \\
Ar_{14} \\
Mt
\end{array}$$
(10)

〔式中、R₂₁は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオ 出証特2004-3120184 キシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。sは $0\sim2$ の整数を示す。Ar₁₃およびAr₁₄はそれぞれ独立にアリーレン基、2価の複素環基または金属錯体構造を有する2価の基を示す。ssおよび t t はそれぞれ独立に0または1を示す。

 X_4 は、O、S、SO、SO₂、Se,またはTeを示す。 R_{21} が複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

$$\begin{pmatrix}
R_{22} \\
t
\end{pmatrix}$$

$$X_{6} - X_{7} \begin{pmatrix}
R_{23} \\
t
\end{pmatrix}$$

$$X_{5} - X_{7} \begin{pmatrix}
R_{23} \\
t
\end{pmatrix}$$

$$(11)$$

、式(11)で示される繰り返し単位の中央の5員環の例としては、チアジアゾール、オキサジアゾール、トリアゾール、チオフェン、フラン、シロールなどが挙げられる。

[0098]

$$\begin{array}{c}
\left(\begin{array}{c}
R_{28}\right) \\
R_{30}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{31} \\
R_{32}
\end{array}$$

$$\left(\begin{array}{c}
R_{33}\right)_{W}
\end{array}$$

$$(12)$$

〔式中、R28およびR33は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキン基、アリールアルキール基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アリールアルチュ基、世換アミノ基、宣換アミノ基、宣換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。vおよびwはそれぞれ独立に $0 \sim 4$ の整数を示す。R29、R30、R31およびR36は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。Ar5はアリーレン基、2価の複素環基または金属錯体構造を有する2価の基を示す。R28およびR33が

複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。〕

[0099]

また上記式(4)で示される繰り返し単位の中で、下記式(13)で示される繰り返し単位が、発光波長を変化させる観点、発光効率を高める観点、耐熱性を向上させる観点からも好ましい。

〔式中、 Ar_6 、 Ar_7 、 Ar_8 および Ar_9 はそれぞれ独立にアリーレン基または 2 価の複素環基を示す。 Ar_{10} 、 Ar_{11} および Ar_{12} はそれぞれ独立にアリール基、または 1 価の複素環基を示す。 Ar_6 、 Ar_7 、 Ar_8 、 Ar_9 、 Ar_{10} 、 Ar_{11} および Ar_{12} は置換基を有していてもよい。xおよびyはそれぞれ独立に 0または正の整数を示す。〕

[0100]

式(1)で示される繰り返し単位と下記式(13)で示される繰り返し単位の合計が全繰り返しの50モル%以上であり、さらに好ましくは70モル%以上、さらに90%である場合が最も好ましい。

[0101]

本発明において前記式(1)で示される繰り返し単位と前記式(13)で示される繰り返し単位を含む場合、そのモル比は98:2~60:40であることが好ましい。

蛍光強度の観点からは、前記式(13)で示される繰り返し単位が前記式(1)で示される繰り返し単位と前記式(13)で示される繰り返し単位の合計に対して30モル%以下であることがさらに好ましい。

素子特性等の観点から、好ましくは95:5~70:30であり、好ましくは90:10~80:20である。

[0102]

上記式(13)で示される繰り返し単位の具体例としては、以下の(式133~140)で示されるものが挙げられる。

[0104]

æ,

[0105]

上記式においてRは、前記式1~132のそれと同じである。

上記式においてRはそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ 基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールア ルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、 アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオ キシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カ ルボキシル基またはシアノ基を示す。溶媒への溶解性を高めるためには、水素原子以外を 1つ以上有していることが好ましく、また置換基を含めた繰り返し単位の形状の対称性が 少ないことが好ましい。

[0106]

上記式においてRがアルキルを含む置換基においては、高分子化合物の溶媒への溶解性を 高めるために、1つ以上に環状または分岐のあるアルキルが含まれることが好ましい。 さらに、上記式においてRがアリール基や複素環基をその一部に含む場合は、それらがさ らに1つ以上の置換基を有していてもよい。

上記式133~140で示される構造のうち、発光波長を調節する観点から、式(133)、(134)および(137)で示される構造が好ましい。

[0107]

上記式(13)で示される繰り返し単位において、発光波長を調節する観点、素子特性 等の観点から、Ar6、Ar7、Ar8およびAr9がそれぞれ独立にアリーレン基であり、 Ar10、Ar11およびAr12がそれぞれ独立にアリール基を示すものが好ましい。

[0108]

Ar6、Ar7、Ar8としては、それぞれ独立に、無置換のフェニレン基、無置換のビフ ェニル基、無置換のナフチレン基、無置換のアントラセンジイル基である場合が好ましい

[0109]

Ar10、Ar11およびAr12としては、溶解性、素子特性等の観点から、それぞれ独立に 、3つ以上の置換基を有するアリール基であるものが好ましく、Ar10、Ar11およびA r 12が置換基を3つ以上有するフェニル基、3つ以上の置換基を有するナフチル基または 3つ以上の置換基を有するアントラニル基であるものがより好ましく、A r 10、A r 11お よびA r 12が置換基を3つ以上有するフェニル基であるものがさらに好ましい。

[0110]

中でも、Ar10、Ar11およびAr12が、それぞれ独立に下記式(13-1)であり、か つx+y≤3であるものが好ましく、x+y=1であるものがより好ましく、さらに好ま しくはx=1、y=0の場合である。

〔式中、Re、RfおよびRgは、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチ オ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリール アルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基 、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、シリルオキシ基、置換シリルオキ シ基、1価の複素環基またはハロゲン原子を表す。]

[0111]

より好ましくは上記式(13-1)において、ReおよびRfがそれぞれ独立に、炭素数3 以下のアルキル基、炭素数3以下のアルコキシ基、炭素数3以下のアルキルチオ基であり 、かつRgが炭素数3~20のアルキル基、炭素数3~20のアルコキシ基、炭素数3~ 20のアルキルチオ基であるものが挙げられる。

[0112]

前記式(13)で示される繰り返し単位において、Ar7が下記式(19-1)または (19-2) であることが好ましい。

$$(19-1) \qquad (19-2)$$

[0113]

上記式(13)で示される繰り返し単位として、特に好ましい具体例としては、以下の(式141~142)で示されるものが挙げられる。

式(13)の好ましい具体例としては、発光波長を調節する観点から、下記式(17)、 (19)、(20)で示される繰り返し単位が好ましい。さらに好ましくは蛍光強度の観 点から、下記式(17)で示される繰り返し単位である。この場合、耐熱性がより高くな りうる。

[0114]

本発明の高分子化合物の中で、繰り返し単位として式(13)で示される繰り返し単位を 2種類有する場合、発光波長を調節する観点、素子特性等の観点から、x=y=0で示さ れる繰り返し単位と x = 1 かつ y = 0で示される繰り返し単位の組み合わせ、あるいは x = 1かつy=0で示される繰り返し単位2種の組み合わせから選ばれる場合が好ましい。

[0115]

なお、本発明の高分子化合物は、発光特性や電荷輸送特性を損なわない範囲で、上記式 (1)、式(3)~式(13)で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位を含んでいて もよい。また、これらの繰り返し単位や他の繰り返し単位が、非共役の単位で連結されて いてもよいし、繰り返し単位にそれらの非共役部分が含まれていてもよい。結合構造とし ては、以下に示すもの、および以下に示すもののうち2つ以上を組み合わせたものなどが 例示される。ここで、Rは前記のものと同じ置換基から選ばれる基であり、Arは炭素数 6~60個の炭化水素基を示す。

[0116]

本発明の高分子化合物の中では、上記式(1)で示される繰り返し単位のいずれかのみからなるもの、上記式(1)で示される繰り返し単位から選ばれる2種以上の繰り返し単位からなるもの、実質的に上記式(1)で示される繰り返し単位から選ばれる1種以上の繰り返し単位と上記式(3)~(13)で示される繰り返し単位の1種以上とからなるものが好ましい。

これらのうち、上記式(1-1)、(1-2)、(1-3)および(1-4)で示される繰り返し単位のいずれかのみからなるもの、上記式(1-1)、(1-2)、(1-3)および(1-4)で示される繰り返し単位から選ばれる 2 種以上の繰り返し単位からなるもの、実質的に上記式(1-1)、(1-2)、(1-3)および(1-4)で示される繰り返し単位から選ばれる 1 種以上の繰り返し単位と上記式(3)~(1 3)で示される繰り返し単位の 1 種以上とからなるものが、蛍光特性の観点からは好ましい。

さらに、式 (1-1) で示される繰り返し単位のみからなるもの、式 (133)、 (134) および (137) で示される繰り返し単位のいずれか1種類と式 (1-1) で示される繰り返し単位とからなるものが好ましく、さらに好ましくは、式 (134) および式 (137) で示される繰り返し単位のいずれか1種類と式 (1-1) で示される繰り返し単位とからなるものである。特に好ましくは、式 (1-1) で示される繰り返し単位と式 (134) で示される繰り返し単位とからなるものである。

特に好ましくは、実質的に式(16)で示される繰り返し単位のみからなるもの、式(16)で示される繰り返し単位と式(17)で示される繰り返し単位のみからなるもの、および式(16)で示される繰り返し単位と式(20)で示される繰り返し単位のみからなるものである。

[0117]

また、本発明の高分子化合物は、ランダム、ブロックまたはグラフト共重合体であってもよいし、それらの中間的な構造を有する高分子、例えばブロック性を帯びたランダム共重合体であってもよい。蛍光またはりん光の量子収率の高い高分子発光体を得る観点からは完全なランダム共重合体よりブロック性を帯びたランダム共重合体やブロックまたはグラフト共重合体が好ましい。主鎖に枝分かれがあり、末端部が3つ以上ある場合やデンドリマーも含まれる。

[0118]

また、本発明の高分子化合物の末端基は、重合活性基がそのまま残っていると、素子にしたときの発光特性や寿命が低下する可能性があるので、安定な基で保護されていてよい。主鎖の共役構造と連続した共役結合を有しているものが好ましく、例えば、炭素一炭素結合を介してアリール基または複素環基と結合している構造が例示される。具体的には、結合を介してアリール基または複素環基と結合している構造が例示される。具体的には、

特開平9-45478号公報の化10に記載の置換基等が例示される。

[0119]

発光素子等を作成するための様々なプロセスに耐えうる為には、高分子化合物のガラス転 移温度は100℃程度以上であることが好ましい。

[0120]

本発明の高分子化合物のポリスチレン換算の数平均分子量は通常 10³~10⁸程度であ り、好ましくは $10^4 \sim 10^6$ である。また、ポリスチレン換算の重量平均分子量は通常 1 $0^3 \sim 10^8$ 程度であり、好ましくは $5 \times 10^4 \sim 5 \times 10^6$ である。さらに、成膜性を向上 させる観点から、105以上が好ましい。同じく高分子化合物の成膜性を向上させる観点 から、分子量分布(重量平均分子量/数平均分子量)が3以上12以下であることが好ま しい。さらに好ましくは4以上10以下である。

[0121]

繰り返し単位が前記式(16)のみの構造からなる場合、GPCの溶出曲線が実質的に単 峰性で、分散度が2以上7以下であることが好ましく、4以上7以下であることがより好 ましい。

[0122]

実質的に上記式(16)と、前記式(17)で示される構造のみである場合、GPCの 溶出曲線が2つのピークを持ち、分散度が6以上8以下であることが好ましい。

[0123]

GPCの溶出曲線は、一般的にはGPC(ゲルパーミッションクロマトグラフィー)によ り測定される。本発明におけるGPCの溶出曲線の測定は、GPCの移動相としてテトラ ヒドロフランを用い、0.6mL/minの流速で流した。また、カラムは、TSKge 1 SuperHM-H (東ソー製) 2本とTSKgel SuperH2000 (東ソ ー製) 1本を直列に繋げ、検出器には示差屈折率検出器を用いて行った。

[0124]

実質的に上記式(16)で示される繰り返し単位のみからなる高分子化合物のGPCの溶 出曲線は、左右対称に近い単峰形であることが好ましい。素子特性の再現性を観点から、 GPCの溶出曲線においてピークトップを境とした左側の溶出曲線の面積と右側の溶出曲 線の面積の差が、左右のうち小さい方の面積の値に対して、0.5以下であることが好ま しく、0.3以下であることがより好ましい。また、ピークトップを境にして右側(低分 子量側)の面積が左側(高分子側)の面積よりも小さいことが好ましい。

[0125]

高分子化合物の分散度は、重量平均分子量を数平均で割った値である。分散度7以下であ ることが好ましく、2以上7以下であることが好ましく、4以上7以下であることがさら に好ましい。

[0126]

繰り返し単位が上記式(16)と上記式(17)で示される構造のみの高分子化合物の場 合、素子特性の観点から、GPCの溶出曲線が2山になっていることが好ましい。また、 分散度は6以上8以下であることが好ましい。

[0127]

本発明の高分子化合物に対する良溶媒としては、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロ ロエタン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、メシチレン、テトラリン、デカリ ン、n-ブチルベンゼンなどが例示される。高分子化合物の構造や分子量にもよるが、通 常はこれらの溶媒に 0. 1 重量%以上溶解させることができる。

[0128]

次に本発明の高分子化合物の製造方法について説明する。

式(1)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物は、例えば、式(14)

$$Y_{t} = A B Y_{u} \qquad (14)$$

$$R_{y} R_{z}$$

で示される化合物を原料の一つとして用いて縮合重合させることにより製造することができる。

[0129]

Fish.

、式 (1-1)、 (1-2)、 (1-3)、 (1-4) で示される繰り返し単位を有する 高分子化合物は、

(14) として、式 (14-1) 、 (14-2) 、 (14-3) または (14-4)

$$(R_{r1})_a$$
 Y_{t1}
 R_{y1}
 R_{z1}
 R_{z1}
 R_{y2}
 R_{z2}
 R_{z2}
 $(14-1)$
 $(R_{r3})_a$
 $(R_{r4})_a$
 $(R_{r4})_a$
 $(R_{r4})_a$
 $(R_{r4})_a$

(14-3) $(R_{r4})_a$ $(R_{r4})_a$

〔式中、Rr1、Rs1、Rr2、Rs2、Rr3、Rs3、Rr4およびRs4はそれぞれ独立にアルキ ル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基 、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアル ケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、 ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の 複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表し、aは0~3の整 数を表し、bは0~5の整数を表し、R_{r1}、R_{s1}、R_{r2}、R_{s2}、R_{r3}、R_{s3}、R_{r4}および Rs4がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。Ry1、Rz1、 Ry2、Rz2、Ry3、Rz3、Ry4およびRz4はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アル コキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリール アルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、 アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原 子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、 カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を表し、Ry1とRz1、Ry2とRz2、 R_{y3} と R_{z3} 、 R_{y4} と R_{z4} はそれぞれ互いに結合して環を形成していてもよい。 Y_{t1} 、 Y_{u1} 、 Y_{t2} 、 Y_{u2} 、 Y_{t3} 、 Y_{u3} 、 Y_{t4} および Y_{u4} はそれぞれ独立に縮合重合に関与する置換基 を表す。〕で示される化合物を原料の一つとして用いて縮合重合させることにより製造す ることができる。

[0130]

また、主鎖に枝分かれがあり、末端部が3つ以上ある高分子化合物やデンドリマーを製造 する場合においては、下記式(14B)で示される化合物を原料の一つとして用いて縮合 重合させることにより製造することができる。

$$(Y_t)c \xrightarrow{A//(B)} (Y_u)d$$

$$R_y R_z$$

$$(14B)$$

〔式中、 R_y 、 R_z 、 Y_t 、 Y_u はそれぞれ前記と同様の意味を表す。cは0~3の整数を表 し、dは0~5の整数を表し、かつ3 \leq c+d \leq 6を満たす整数を表し、好ましくは3 \leq $c+d \leq 4$ を満たす整数を表す。 Y_t 、 Y_u が複数存在する場合、それらは同一でも異なっ ていてもよい。〕で示される化合物を原料の一つとして用いて縮合重合させることにより 製造することができる。

[0131]

式(14B)で示される原料としては、好ましくは、下記式(14-5)、(14-6) 、(14-7)で示される化合物が挙げられる。

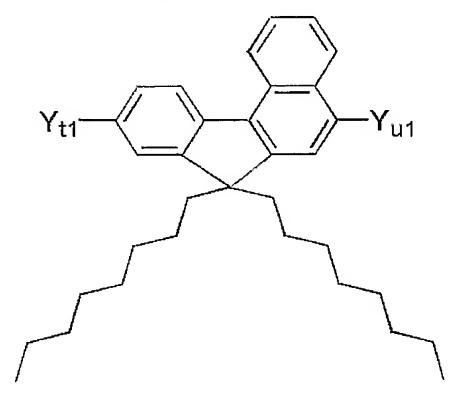
$$(R_{r1})_{a'}$$
 $(Y_{t1})_{c}$
 $(Y_{t1})_{c}$
 $(Y_{u1})_{d}$
 $(Y_{u4})_{d}$
 $(R_{r3})_{a'}$
 $(Y_{t3})_{c}$
 $(Y_{u3})_{d}$
 $(Y_{u3})_{d}$
 $(Y_{u4})_{d}$
 $(Y_{t4})_{c}$
 $(Y_{t4})_{c}$

〔式中、Rr1、Rs1、Rr2、Rs2、Rr3、Rs3、Rr4、Rs4、Ry1、Rz1、Ry2、Rz2、 Ry3、Rz3、Ry4、Rz4、Yt1、Yu1、Yt3、Yu3、Yt4およびYu4は前記と同じ意味を 表し、a'および c はそれぞれ独立に 0~4の整数を表し、b'は 0~5の整数を表し、 c は 0 ~ 3 の整数を表し、d は 0 ~ 5 の整数を表し、a'+c ≤ 4 、b'+d ≤ 6 、3 ≤ $c+d \leq 6 \, \text{である。} \, R_{r1}, \, R_{s1}, \, R_{r2}, \, R_{s2}, \, R_{r3}, \, R_{s3}, \, R_{r4}, \, R_{s4}, \, R_{y1}, \, R_{z1}, \, Y$ t_1 、 Y_{u1} 、 Y_{t3} 、 Y_{u3} 、 Y_{t4} および Y_{u4} がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも 異なっていてもよい。〕

[0132]

上記式(14-1) \sim (14-7)において、耐熱性を向上させる観点から、a=b=a'=b'=0であることが好ましい。

中でも、化合物の合成の容易さの観点から、式(14-1)で示される化合物が好ましい。さらに好ましくは、式(26)で示される化合物である。



(26)

〔式中、Yt1およびYu1は前記と同じ意味を表す〕

[0133]

また、本発明の高分子化合物が、式(1)以外の繰り返し単位を有する場合には、式(1)以外の繰り返し単位となる、2個の縮合重合に関与する置換基を有する化合物を共存させて縮合重合させればよい。

[0134]

上記式(1)で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位となる、2個の縮合重合可能な置換基を有する化合物としては、下記式(21)~(24)の化合物が例示される。

上記式 (14) で示される化合物に加えて、下記式 (21) ~ (24) のいずれかで示される化合物を縮合重合させることにより

式(21)

 $Y_5 - A r_1 - Y_6$

式(22)

$$Y_7 - \left(-Ar_2 - X_1\right)_{ff} Ar_3 - Y_8$$

式(23)

 $Y_9 - A r_4 - X_2 - Y_{10}$

式(24)

 $Y_{11} - X_3 - Y_{12}$

〔式中、 Ar_1 、 Ar_2 、 Ar_3 、 Ar_4 、ff、 X_1 、 X_2 および X_3 は前記と同じである。 Y_5 、 Y_6 、 Y_7 、 Y_8 、 Y_9 、 Y_{10} 、 Y_{11} 、および Y_{12} はそれぞれ独立に縮合重合可能な置換基を示す。〕

上記式 (1) で示される単位に加えて、順に (3)、 (4)、 (5) または (6) の単位 を 1 つ以上有する高分子化合物を製造することができる。

[0135]

また、上記式(1)で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位となる、上記式(13)に対応する2個の縮合に関与する置換基を有する化合物としては、下記式(15-1)で示される化合物があげられる。

$$Y_{13}$$
— Ar_{6} — N — Ar_{7} — N — Ar_{8} — Y_{14}
 Ar_{9}
 N — Ar_{11}
 Y
 Ar_{12}

(15 - 1)

〔式中、 Ar_6 、 Ar_7 、 Ar_8 、 Ar_9 、 Ar_{10} 、 Ar_{11} 、 Ar_{12} 、xおよびyの定義および好ましい例については前記と同じ。 Y_{13} および Y_{14} はそれぞれ独立に縮合重合に関与する置換基を示す。〕

[0136]

本発明の製造方法において、縮合重合に関与する置換基としては、ハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基、スルホニウムメチル基、ホスホニウムメチル基、ホスホネートメチル基、モノハロゲン化メチル基、-B(OH)2、ホルミル基、シアノ基、ビニル基等があげられる。

[0137]

ここに、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子があげられる。

[0138]

アルキルスルホネート基としては、メタンスルホネート基、エタンスルホネート基、トリフルオロメタンスルホネート基などが例示され、アリールスルホネート基としては、ベンゼンスルホネート基、pートルエンスルホネート基などが例示され、アリールスルホネート基としては、ベンジルスルホネート基などが例示される。

[0139]

ホウ酸エステル基としては、下記式で示される基が例示される。

式中、Meはメチル基を、Etはエチル基を示す。

[0140]

スルホニウムメチル基としては、下記式で示される基が例示される。

 $-CH_2S^+Me_2X^-$, $-CH_2S^+Ph_2X^-$

(Xはハロゲン原子を示し、Phはフェニル基を示す。)

[0141]

ホスホニウムメチル基としては、下記式で示される基が例示される。

- C H₂ P⁺ P h₃ X⁻ (Xはハロゲン原子を示す。)

[0142]

ホスホネートメチル基としては、下記式で示される基が例示される。

- C H₂ P O (O R')₂ (Xはハロゲン原子を示し、R'はアルキル基、アリール基、アリールアルキル基を示す。)

[0143]

モノハロゲン化メチル基としては、フッ化メチル基、塩化メチル基、臭化メチル基、ヨウ化メチル基が例示される。

$[0 \ 1 \ 4 \ 4]$

縮合重合に関与する置換基として好ましい置換基は重合反応の種類によって異なるが、

例えばYamamotoカップリング反応など0価ニッケル錯体を用いる場合には、ハロ ゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基またはアリールアルキルス ルホネート基が挙げられる。またSuzukiカップリング反応などニッケル触媒あるい はパラジウム触媒を用いる場合には、アルキルスルホネート基、ハロゲン原子、ホウ酸エ ステル基、-B (ОН) 2などが挙げられる。

[0145]

本発明の製造方法は、具体的には、モノマーとなる、縮合重合に関与する置換基を複数 有する化合物を、必要に応じ、有機溶媒に溶解し、例えばアルカリや適当な触媒を用い、 有機溶媒の融点以上沸点以下で行うことができる。例えば、"オルガニック リアクショ ンズ (Organic Reactions)",第14巻,270-490頁,ジョン ワイリー アンド サンズ (John Wiley&Sons, Inc.), 1965年 "オルガニック シンセシス (Organic Syntheses)", コレクテ ィブ第6巻(Collective Volume VI), 407-411頁, ジョン ワイリー アンド サンズ (John Wiley&Sons, Inc.), 1988年 、ケミカル レビュー (Chem. Rev.), 第95巻, 2457頁 (1995年)、 ジャーナル オブ オルガノメタリック ケミストリー (J. Organomet. Ch em.), 第576巻, 147頁(1999年)、マクロモレキュラー ケミストリー マクロモレキュラー シンポジウム (Makromol. Chem., Macromol . Symp.), 第12巻, 229頁(1987年)などに記載の公知の方法を用いるこ とができる。

[0146]

本発明の高分子化合物の製造方法において、縮合重合させる方法としては、上記式(1 4), (14-1), (14-2), (14-3), (14-4), (14B), (14 -5), (14-6), (14-7), (21), (22), (23), (24) (15)-1)で表される化合物の縮合重合に関与する置換基に応じて、既知の縮合反応を用いる ことにより製造できる。

本発明の高分子化合物が縮合重合において、二重結合を生成する場合は、例えば特開平 5-202355号公報に記載の方法が挙げられる。すなわち、ホルミル基を有する化合 物とホスホニウムメチル基を有する化合物との、もしくはホルミル基とホスホニウムメチ ル基とを有する化合物のWittig反応による重合、ビニル基を有する化合物とハロゲ ン原子を有する化合物とのHeck反応による重合、モノハロゲン化メチル基を2つある いは2つ以上有する化合物の脱ハロゲン化水素法による重縮合、スルホニウムメチル基を 2つあるいは2つ以上有する化合物のスルホニウム塩分解法による重縮合、ホルミル基を 有する化合物とシアノ基を有する化合物とのKnoevenagel反応による重合など の方法、ホルミル基を2つあるいは2つ以上有する化合物のMcMurry反応による重 合などの方法が例示される。

本発明の高分子化合物が縮合重合によって主鎖に三重結合を生成する場合には、例えば 、Heck反応、Sonogashira反応が利用できる。

[0 1 4 7]

また、二重結合や三重結合を生成しない場合には、例えば該当するモノマーからSuz ukiカップリング反応により重合する方法、Grignard反応により重合する方法 、Ni(0)錯体により重合する方法、FeCl3等の酸化剤により重合する方法、電気 化学的に酸化重合する方法、あるいは適当な脱離基を有する中間体高分子の分解による方 法などが例示される。

[0148]

これらのうち、Wittig反応による重合、Heck反応による重合、Knoeve nagel反応による重合、およびSuzukiカップリング反応により重合する方法、 Grignard反応により重合する方法、ニッケルゼロ価錯体により重合する方法が、 構造制御がしやすいので好ましい。

[0149]

本発明の高分子化合物はその繰り返し単位において、式(1)に示されるように、非対 称な骨格を有しているため、高分子化合物に繰り返し単位の向きが存在する。これらの繰 り返し単位の向きを制御する場合には、例えば、該当するモノマーの縮合重合に関与する 置換基および用いる重合反応の組合せを選択して、繰り返し単位の向きを制御して重合す る方法などが例示される。

[0150]

本発明の高分子化合物において、2種類以上の繰り返し単位のシーケンスを制御する場合には、目的とするシーケンスの中での繰り返し単位の一部または全部を有するオリゴマーを合成してから重合する方法、用いるそれぞれのモノマーの、縮合重合に関与する置換基および用いる重合反応を選択して、繰り返し単位のシーケンスを制御して重合する方法などが例示される。

[0151]

本発明の製造方法の中で、縮合重合に関与する置換基(Y_t 、 Y_u 、 Y_{t1} 、 Y_{u1} 、 Y_{t2} 、 Y_{u2} 、 Y_{t3} 、 Y_{u3} 、 Y_{t4} および Y_{u4} Y_5 、 Y_6 、 Y_7 、 Y_8 、 Y_9 、 Y_{10} 、 Y_{11} および Y_{12})がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基またはアリールアルキルスルホネート基から選ばれ、ニッケルゼロ価錯体存在下で縮合重合する製造方法が好ましい。

原料化合物としては、ジハロゲン化化合物、ビス(アルキルスルホネート)化合物、ビス(アリールスルホネート)化合物、ビス(アリールアルキルスルホネート)化合物あるいはハロゲンーアルキルスルホネート化合物、ハロゲンーアリールスルホネート化合物、ハロゲンーアリールアルキルスルホネート化合物、アルキルスルホネートーアリールスルホネート化合物、アルキルスルホネート化合物、アリールスルホネートーアリールアルキルスルホネート化合物が挙げられる。

[0152]

この場合、例えば原料化合物としてハロゲンーアルキルスルホネート化合物、ハロゲンーアリールスルホネート化合物、ハロゲンーアリールアルキルスルホネート化合物、アルキルスルホネートーアリールスルホネート化合物、アルキルスルホネートーアリールアルキルスルホネート化合物、アリールスルホネートーアリールアルキルスルホネート化合物を用いることにより、繰り返し単位の向きやシーケンスを制御した高分子化合物を製造する方法が挙げられる。

[0153]

具体的な原料化合物の組み合わせとしては、ジハロゲン化化合物、ビス(アルキルスルホネート)化合物、ビス(アリールスルホネート)化合物またはビス(アリールアルキルスルホネート)化合物とジホウ酸化合物またはジホウ酸エステル化合物との組み合わせが挙げられる。

また、ハロゲンーホウ酸化合物、ハロゲンーホウ酸エステル化合物、アルキルスルホネートーホウ酸化合物、アルキルスルホネートーホウ酸エステル化合物、アリールスルホネートーホウ酸化合物、アリールアルキルスルホネートーホウ酸化合物、アリールアルキルスルホネートーホウ酸化合物、アリールアルキルスルホネートーホウ酸化合物、アリールアルキルスルホネートーホウ酸エステル化合物挙げられる。

[0154]

この場合、例えば原料化合物としてハロゲンーホウ酸化合物、ハロゲンーホウ酸エステル 化合物、アルキルスルホネートーホウ酸化合物、アルキルスルホネートーホウ酸エステル 化合物、アリールスルホネートーホウ酸化合物、アリールスルホネートーホウ酸エステル 化合物、アリールアルキルスルホネートーホウ酸化合物、アリールアルキルスルホネート ーホウ酸化合物、アリールアルキルスルホネートーホウ酸エステル化合物を用いることに より、繰り返し単位の向きやシーケンスを制御した高分子化合物を製造する方法が挙げら れる。

[0155]

有機溶媒としては、用いる化合物や反応によっても異なるが、一般に副反応を抑制する ために、用いる溶媒は十分に脱酸素処理を施し、不活性雰囲気化で反応を進行させること が好ましい。また、同様に脱水処理を行うことが好ましい。但し、Suzukiカップリ ング反応のような水との2相系での反応の場合にはその限りではない。

[0156]

溶媒としては、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサンなどの飽和 炭化水素、ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレンなどの不飽和炭化水素、四塩 化炭素、クロロホルム、ジクロロメタン、クロロブタン、ブロモブタン、クロロペンタン 、ブロモペンタン、クロロヘキサン、ブロモヘキサン、クロロシクロヘキサン、ブロモシ クロヘキサンなどのハロゲン化飽和炭化水素、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、トリ クロロベンゼンなどのハロゲン化不飽和炭化水素、メタノール、エタノール、プロパノー ル、イソプロパノール、ブタノール、tーブチルアルコールなどのアルコール類、蟻酸、 酢酸、プロピオン酸などのカルボン酸類、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、メチル - t - ブチルエーテル、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、ジオキサンなどのエ ーテル類、トリメチルアミン、トリエチルアミン、N, N, N', ーテトラメチル エチレンジアミン、ピリジンなどのアミン類、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nー ジメチルアセトアミド、N, Nージエチルアセトアミド、Nーメチルモルホリンオキシド などのアミド類などが例示され、単一溶媒、またはこれらの混合溶媒を用いてもよい。こ れらの中で、エーテル類が好ましく、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルがさらに好 ましい。

[0157]

反応させるために適宜アルカリや適当な触媒を添加する。これらは用いる反応に応じて 選択すればよい。該アルカリまたは触媒は、反応に用いる溶媒に十分に溶解するものが好 ましい。アルカリまたは触媒を混合する方法としては、反応液をアルゴンや窒素などの不 活性雰囲気下で攪拌しながらゆっくりとアルカリまたは触媒の溶液を添加するか、逆にア ルカリまたは触媒の溶液に反応液をゆっくりと添加する方法が例示される。

[0158]

本発明の高分子化合物を高分子LED等に用いる場合、その純度が発光特性等の素子の 性能に影響を与えるため、重合前のモノマーを蒸留、昇華精製、再結晶等の方法で精製し たのちに重合することが好ましい。また重合後、再沈精製、クロマトグラフィーによる分 別等の純化処理をすることが好ましい。

[0159]

本発明の高分子化合物の原料として有用な(14)、(14-1)、(14-2)、(14-3)、(14-4)、(14B)、(14-5)、(14-6)、および(14-7) の中で Y_t 、 Y_u 、 Y_{t1} 、 Y_{u1} 、 Y_{t2} 、 Y_{u2} 、 Y_{t3} 、 Y_{u3} 、 Y_{t4} および Y_{u4} がハロゲン を示すのものは、例えばカップリング反応、閉環反応等を用いて(14-1)、(14-2)、(14-3)、(14-4)、(14-5)、(14-6)、および(14-7) の Y_t 、 Y_u 、 Y_{t1} 、 Y_{u1} 、 Y_{t2} 、 Y_{u2} 、 Y_{t3} 、 Y_{u3} 、 Y_{t4} および Y_{u4} を水素原子に置き換 えた構造の化合物を合成した後に、例えば、塩素、臭素、ヨウ素、Nークロロスクシンイ ミド、N-ブロモスクシンイミド、ベンジルトリメチルアンモニウムトリブロミド等の種 々のハロゲン化試剤によりハロゲン化することによって得られる。

[0 1 6 0]

また、本発明の高分子化合物の原料として有用な(14)、(14-1)、(14-2) 、(14-3)、(14-4)、(14B)、(14-5)、(14-6)、および(1 4-7) の中で、 Y_t 、 Y_u 、 Y_{t1} 、 Y_{u1} 、 Y_{t2} 、 Y_{u2} 、 Y_{t3} 、 Y_{u3} 、 Y_{t4} および Y_{u4} がア ルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、またはアリールアルキルスルホネート 基を示すものは、例えば、それぞれ、アルコキシ基等の水酸基へ誘導可能な官能基をもつ 化合物をカップリング反応、閉環反応等に供して、(14)、(14-1)、(14-2)、(14-3)、(14-4)、(14B)、(14-5)、(14-6)、および($14-7) \hspace{0.1cm} \text{OY}_{t}, \hspace{0.1cm} Y_{u}, \hspace{0.1cm} Y_{t1}, \hspace{0.1cm} Y_{u1}, \hspace{0.1cm} Y_{t2}, \hspace{0.1cm} Y_{u2}, \hspace{0.1cm} Y_{t3}, \hspace{0.1cm} Y_{u3}, \hspace{0.1cm} Y_{t4} \\ \text{\sharpL$$$\'{\sc T}$$$$Y$}_{u4} \\ \text{$\~{\sc E}$} \\ \text{$\r{\sc T}$} \hspace{0.1cm} \mathcal{Y}_{u2}, \hspace{0.1cm} Y_{t3}, \hspace{0.1cm} Y_{u3}, \hspace{0.1cm} Y_{t4} \\ \text{\sharpL$$\'{\sc E}$} \hspace{0.1cm} Y_{u4} \\ \text{$\~{\sc E}$} \hspace{0.1cm} \mathcal{P} \hspace{0$ キシ基等の水酸基へ誘導可能な官能基に置き換えた化合物を合成した後に、例えば三臭化 ホウ素等により脱アルキル化試剤用いるなどの種々の反応により、Yt、Yu、Yt1、Yu1 、Yt2、Yu2、Yt3、Yu3、Yt4およびYu4を水酸基に置き換えた化合物を合成し、つい で、例えば、種々のスルホニルクロライド、スルホン酸無水物等により水酸基をスルホニ ル化することにより得られる。

[0 1 6 1]

また、本発明の高分子化合物の原料として有用な(14)、(14-1)、(14-2) 、(14-3)、(14-4)、(14B)、(14-5)、(14-6)、および(1 4-7) の中で、 Y_t 、 Y_u 、 Y_{t1} 、 Y_{u1} 、 Y_{t2} 、 Y_{u2} 、 Y_{t3} 、 Y_{u3} 、 Y_{t4} および Y_{u4} がホ ウ酸基、またはホウ酸エステル基を示すものは、前記の方法等により、(14)、(14 -1), (14-2), (14-3), (14-4), (14B), (14-5), (1およびYu4をハロゲン原子に置き換えた化合物を合成した後に、アルキルリチウム、金属 マグネシウム等を作用させ、さらにホウ酸トリメチルによりホウ酸化することにより、ハ ロゲン原子をホウ酸基に変換すること、および、ホウ酸化した後に、アルコールを作用さ せてホウ酸エステル化することにより得られる。また、前記の方法等により、(14)、 (14-1), (14-2), (14-3), (14-4), (14B), (14-5)、 (14-6)、および (14-7) の Y_t 、 Y_u 、 Y_{t1} 、 Y_{u1} , Y_{t2} 、 Y_{u2} 、 Y_{t3} 、 Y_{u3} 、Yt4およびYu4をハロゲン、トリフルオロメタンスルホネート基等に置き換えた化合物 を合成し、ついで、非特許文献[Journal of Organic Chemistry, 1995, 60, 7508-7510、 Tetrahedoron Letters, 1997,28(19),3447-3450]等に記載の方法により、ホウ酸エステル 化することにより得られる。

本発明の高分子化合物の中では、ニッケルゼロ価錯体により重合する方法により製造され たものが、寿命特性の観点から好ましい。

[0162]

次に本発明の高分子化合物の用途について説明する。

本発明の高分子化合物は、通常は、固体状態で蛍光または燐光を発し、高分子発光体(高 分子量の発光材料)として用いることができる。

また、該高分子化合物は優れた電荷輸送能を有しており、高分子LED用材料や電荷輸送 材料として好適に用いることができる。該高分子発光体を用いた高分子LEDは低電圧、 高効率で駆動できる高性能の高分子LEDである。従って、該高分子LEDは液晶ディス プレイのバックライト、または照明用としての曲面状や平面状の光源、セグメントタイプ の表示素子、ドットマトリックスのフラットパネルディスプレイ等の装置に好ましく使用 できる。

また、本発明の高分子化合物はレーザー用色素、有機太陽電池用材料、有機トランジス タ用の有機半導体、導電性薄膜、有機半導体薄膜などの伝導性薄膜用材料としても用いる ことができる。

さらに、蛍光や燐光を発する発光性薄膜材料としても用いることができる。

[0163]

次に、本発明の高分子LEDについて説明する。

本発明の高分子LEDは、陽極および陰極からなる電極間に、有機層を有し、該有機層 が本発明の高分子化合物を含むことを特徴とする。

有機層(有機物を含む層)は、発光層、正孔輸送層、電子輸送層等のいずれであっても よいが、有機層が発光層であることが好ましい。

[0164]

ここに、発光層とは、発光する機能を有する層をいい、正孔輸送層とは、正孔を輸送す る機能を有する層をいい、電子輸送層とは、電子を輸送する機能を有する層をいう。なお 、電子輸送層と正孔輸送層を総称して電荷輸送層と呼ぶ。発光層、正孔輸送層、電子輸送 層は、それぞれ独立に2層以上用いてもよい。

[0165]

有機層が発光層である場合、有機層である発光層がさらに正孔輸送性材料、電子輸送性 材料または発光性材料を含んでいてもよい。ここで、発光性材料とは、蛍光および/また は燐光を示す材料のことをさす。

本発明の高分子化合物と正孔輸送性材料と混合する場合には、その混合物全体 に対して、正孔輸送性材料の混合割合は1wt%~80wt%であり、好ましくは5wt %~60wt%である。本発明の高分子材料と電子輸送性材料を混合する場合には、その 混合物全体に対して電子輸送性材料の混合割合は1wt%~80wt%であり、好ましく は5wt%~60wt%である。さらに、本発明の高分子化合物と発光性材料を混合する 場合にはその混合物全体に対して発光性材料の混合割合は1wt%~80wt%であり、 好ましくは5wt%~60wt%である。本発明の高分子化合物と発光性材料、正孔輸送 性材料および/または電子輸送性材料を混合する場合にはその混合物全体に対して発光性 材料の混合割合は1wt%~50wt%であり、好ましくは5wt%~40wt%であり 、正孔輸送性材料と電子輸送性材料はそれらの合計で1wt%~50wt%であり、好ま しくは5wt%~40wt%であり、本発明の高分子化合物の含有量は99wt%~20 wt%である。

[0166]

混合する正孔輸送性材料、電子輸送性材料、発光性材料は公知の低分子化合物、三重項発 光錯体、または高分子化合物が使用できるが、高分子化合物を用いることが好ましい。 高分子化合物の正孔輸送性材料、電子輸送性材料および発光性材料としては、WO99/ 13692, WO99/48160, GB2340304A, WO00/53656, W O 0 1 / 1 9 8 3 4 、 WO 0 0 / 5 5 9 2 7 、 G B 2 3 4 8 3 1 6 、 WO 0 0 / 4 6 3 2 1, WOO0/06665, WO99/54943, WO99/54385, US577 7070, WO98/06773, WO97/05184, WO00/35987, WO 00/53655、WO01/34722、WO99/24526、WO00/2202 7、WOO0/22026、WO98/27136、US573636、WO98/21 262, US5741921, WO97/09394, WO96/29356, WO96 /10617、EP0707020、WO95/07955、特開平2001-1816 18、特開平2001-123156、特開平2001-3045、特開平2000-3 51967、特開平2000-303066、特開平2000-299189、特開平2 000-252065、特開平2000-136379、特開平2000-104057 、特開平2000-80167、特開平10-324870、特開平10-114891 、特開平9-111233、特開平9-45478等に開示されているポリフルオレン、 その誘導体および共重合体、ポリアリーレン、その誘導体および共重合体、ポリアリーレ ンビニレン、その誘導体および共重合体、芳香族アミンおよびその誘導体の(共)重合体 が例示される。

低分子化合物の蛍光性材料としでは、例えば、ナフタレン誘導体、アントラセンもしく はその誘導体、ペリレンもしくはその誘導体、ポリメチン系、キサンテン系、クマリン系 、シアニン系などの色素類、8-ヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、芳 香族アミン、テトラフェニルシクロペンタジエンもしくはその誘導体、またはテトラフェ ニルブタジエンもしくはその誘導体などを用いることができる。

具体的には、例えば特開昭57-51781号、同59-194393号公報に記載さ れているもの等、公知のものが使用可能である。

[0167]

三重項発光錯体としては、例えば、イリジウムを中心金属とするIr(ppy)3、Btp2Ir(aca c)、白金を中心金属とするPtOEP、ユーロピウムを中心金属とするEu(TTA)3phen等が挙げ られる。

[0168]

[0169]

$$CH_3$$
 CH_3
 CH_3

C2H5 C2H5 C_2H_5 C_2H_5

PtOEP

[0171]

Eu(TTA)₃phen

三重項発光錯体として具体的には、例えばNature, (1998), 395, 151、Appl. Phys. Le tt. (1999), 75(1), 4, Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng. (2001), 4105(Organic Light-Emitting Materials and Devices I V), 119, J. Am. Chem. Soc., (2001), 123, 4304, Appl. Phys. Lett., (1997), 71(18), 2596, Syn. Met., (1998), 94(1), 103, Syn. Met ., (1999), 99(2), 1361, Adv. Mater., (1999), 11(10), 852, Jpn.J.Appl.Phys.,34, 1883 (1995)などに記載されている。

[0172]

本発明の組成物は、正孔輸送材料、電子輸送材料、発光材料から選ばれる少なくとも1 種類の材料と本発明の高分子化合物を含有し、発光材料や電荷輸送材料として用いること ができる。

その正孔輸送材料、電子輸送材料、発光材料から選ばれる少なくとも1種類の材料と本 発明の高分子化合物の含有比率は、用途に応じて決めればよいが、発光材料の用途の場合 は、上記の発光層におけると同じ含有比率が好ましい。

[0173]

本発明の別の実施態様としては、本発明の高分子化合物を2種類以上含む高分子組成物 が例示される。

具体的には、前記式(1)で示される繰り返し単位を含む高分子化合物を2種類以上含み 、該高分子化合物の合計量が全体の50重量%以上である高分子組成物が、高分子LED の発光材料として用いた場合に、発光効率、寿命特性などの点で優れており、好ましい。 より好ましくは、該高分子化合物の合計量は全体の70重量%以上である。

該高分子組成物において、好ましい例としては、前記式(1)で示される繰り返し単位の みからなる高分子化合物 1 種類以上と、前記式 (1) で示される繰り返し単位を 5 0 モル %以上含む共重合体1種類以上とを含む高分子組成物である。該共重合体が、前記式(1)で示される繰り返し単位を70モル%以上含むことが、発光効率、寿命特性などの点で 、より好ましい。

また、別の好ましい例としては、前記式(1)で示される繰り返し単位を50モル%以上 含む共重合体を2種類以上含み、該共重合体は、互いに異なる繰り返し単位も含む、高分 子組成物が好ましい。少なくとも1種類の該共重合体が、前記式(1)で示される繰り返 し単位を70モル%以上含むことが、発光効率、寿命特性などの点でより好ましい。

さらに、別の好ましい例としては、前記式(1)で示される繰り返し単位を50モル%以 上含む共重合体を2種類以上含み、該共重合体は、互いに共重合比は異なっているが、同 一の繰り返し単位の組み合わせからなる、高分子組成物が好ましい。少なくとも1種類の 該共重合体が、前記式(1)で示される繰り返し単位を70モル%以上含むことが、発光 効率、寿命特性などの点で、より好ましい。

あるいは、別の好ましい例としては、前記式(1)で示される繰り返し単位のみからなる 高分子化合物を2種類以上含む高分子組成物が好ましい。

より好ましい高分子組成物の例としては、上記例で示された高分子組成物に含まれる少な くとも1種類の高分子化合物が、前記式(1)で示される繰り返し単位を50モル%以上 含む共重合体であり、前記式(13)で示される繰り返し単位も含み、かつ前記式(1) で示される繰り返し単位と、前記式(13)で示される繰り返し単位とのモル比が、99 :1~50:50となる高分子組成物である。該モル比が、98:2~70:30である ことが、発光効率、寿命特性などの点で、より好ましい。

また、別のより好ましい高分子組成物の例としては、前記式(1)で示される繰り返し単 位のみからなる高分子化合物 1 種類以上と、前記式(1)で示される繰り返し単位を 5 0 モル%以上含む共重合体1種類以上とを含む高分子組成物であり、該共重合体は、前記式 (1) で示される繰り返し単位と、前記式(13)で示される繰り返し単位とからなり、 かつ前記式(1)で示される繰り返し単位と前記式(13)で示される繰り返し単位との モル比が90:10~50:50である、高分子組成物である。該モル比が、85:15 ~60:40であることが、発光効率、寿命特性などの点で、より好ましい。

[0174]

本発明の高分子化合物を高分子組成物として用いる場合、溶解性の観点や発光効率や寿命 特性等の素子特性の観点から、前記式(1)で示される繰り返し単位は、前記式(1-1) で示される繰り返し単位または式 (1-2) で示される繰り返し単位から選ばれること が好ましく、式(1-1)で示される繰り返し単位である場合がより好ましく、式(1-1) においてaおよびbが0の場合がさらに好ましく、Rv1とRx1がアルキル基の場合が より好ましく、該アルキル基の炭素数が3以上である場合がさらに好ましく、前記式(1 6) で示される繰り返し単位である場合がより好ましい。また、前記式(13)で示され る繰り返し単位は、前記式(134)で示される繰り返し単位もしくは式(137)で示 される繰り返し単位であることが好ましく、前記式 (17)で示される繰り返し単位もし くは式(20)で示される繰り返し単位であることがより好ましい。

[0175]

本発明の高分子組成物としては、溶解性の観点や発光効率や寿命特性等の素子特性の観点

から、前記式(1)で示される繰り返し単位のみからなる高分子化合物を1種類と、前記式(1)で示される繰り返し単位を50モル%以上含む共重合体を1種類含む高分子組成物、前記式(1)で示される繰り返し単位を50モル%以上含む共重合体であって、互いに共重合比は異なっているが、同一の繰り返し単位の組み合わせからなる共重合体を2種類含む高分子組成物が好ましい。

[0176]

前記式(1)で示される繰り返し単位のみからなる高分子化合物を1種類と、前記式(1)で示される繰り返し単位を50モル%以上含む共重合体を1種類含む高分子組成物とし ては、溶解性の観点や発光効率や寿命特性等の素子特性の観点から、前記式(1)で示さ れる繰り返し単位のみからなる高分子化合物と前記式(1)で示される繰り返し単位と前 記式(13)で示される繰り返し単位からなる高分子化合物を含む高分子組成物が好まし く、前記式(1-1)で示される繰り返し単位のみからなる高分子化合物と前記式(1-1)で示される繰り返し単位と前記式(134)で示される繰り返し単位からなる高分子 化合物を含む高分子組成物、前記式(1-1)で示される繰り返し単位のみからなる高分 子化合物と前記式(1-1)で示される繰り返し単位と前記式(137)で示される繰り 返し単位からなる高分子化合物を含む高分子組成物がより好ましく、前記式(16)で示 される繰り返し単位のみからなる高分子化合物と前記式(16)で示される繰り返し単位 と前記式(17)で示される繰り返し単位からなる高分子化合物を含む高分子組成物、前 記式(16)で示される繰り返し単位のみからなる高分子化合物と前記式(16)で示さ れる繰り返し単位と前記式(20)で示される繰り返し単位からなる高分子化合物を含む 高分子組成物がさらに好ましく、前記式(16)で示される繰り返し単位のみからなる高 分子化合物と前記式(16)で示される繰り返し単位と前記式(17)で示される繰り返 し単位からなる高分子化合物であって前記式(16)で示される繰り返し単位が全繰り返 し単位の70モル%以上である高分子化合物を含む高分子組成物、前記式(16)で示さ れる繰り返し単位のみからなる高分子化合物と前記式(16)で示される繰り返し単位と 前記式(20)で示される繰り返し単位からなる高分子化合物であって前記式(16)で 示される繰り返し単位が全繰り返し単位の70モル%以上である高分子化合物を含む高分 子組成物がより好ましい。

[0177]

前記式(1)で示される繰り返し単位を50モル%以上含む共重合体であって、互いに共 重合比は異なっているが、同一の繰り返し単位の組み合わせからなる共重合体を2種類含 む高分子組成物としては、溶解性の観点や発光効率や寿命特性等の素子特性の観点から、 前記式(1)で示される繰り返し単位と前記式(13)で示される繰り返し単位からなる 共重合体を2種類含む高分子組成物であって、該共重合体の共重合比は互いに異なるが繰 り返し単位の組み合わせは同一である高分子組成物が好ましく、前記式(1-1)で示さ れる繰り返し単位と前記式(134)で示される繰り返し単位からなる共重合体を2種類 含む高分子組成物であって、該共重合体の共重合比は互いに異なるが繰り返し単位の組み 合わせは同一である高分子組成物、前記式(1-1)で示される繰り返し単位と前記式(137)で示される繰り返し単位からなる共重合体を2種類含む高分子組成物であって、 該共重合体の共重合比は互いに異なるが繰り返し単位の組み合わせは同一である高分子組 成物がより好ましく、前記式(16)で示される繰り返し単位と前記式(17)で示され る繰り返し単位からなる共重合体を2種類含む高分子組成物であって、該共重合体の共重 合比は互いに異なるが繰り返し単位の組み合わせは同一である高分子組成物、前記式(1 6)で示される繰り返し単位と前記式(20)で示される繰り返し単位からなる共重合体 を2種類含む高分子組成物であって、該共重合体の共重合比は互いに異なるが繰り返し単 位の組み合わせは同一である高分子組成物がさらに好ましい。共重合体の組成比に関して は、溶解性の観点や発光効率や寿命特性等の素子特性の観点から、前記式(1)で示され る繰り返し単位と前記式(1)で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位のモル比が9 9:1~90:10である共重合体と前記式(1)で示される繰り返し単位と前記式(1)で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位のモル比が80:20~50:50である

共重合体を含有する高分子組成物が好ましく、前記式(1)で示される繰り返し単位と前記式(1)で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位のモル比が98:2~95:5である共重合体と前記式(1)で示される繰り返し単位と前記式(1)で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位のモル比が70:30~60:40である共重合体を含有する高分子組成物がより好ましい。

[0178]

高分子化合物の混合比は、発光効率や寿命特性等の素子特性の観点から、高分子組成物において、前記式(1)で示される繰り返し単位と前記式(1)で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位のモル比が99:1~70:30であることが好ましい。

[0179]

前記式(16)で示される繰り返し単位のみからなる高分子化合物と前記式(16)で示される繰り返し単位と前記式(17)で示される繰り返し単位と前記式(17)で示される繰り返し単位と前記式(17)で示される繰り返し単位からなる共重合体を2種類含む高分子組成物であって、該共重合体の共重合比は互いに異なるが繰り返し単位の組み合わせは同一である高分子組成物においては、発光効率や寿命特性等の素子特性の観点から、高分子組成物において、前記式(16)で示される繰り返し単位と前記式(17)で示される繰り返し単位のモル比が99:1~70:30であるように高分子化合物もしくは共重合体を混合することが好ましく、95:5~80:20であることが好ましく、92:8~85:15であることがさらに好ましい。

[0180]

前記式(16)で示される繰り返し単位のみからなる高分子化合物と前記式(16)で示される繰り返し単位と前記式(20)で示される繰り返し単位からなる高分子化合物を含む高分子組成物、前記式(16)で示される繰り返し単位と前記式(20)で示される繰り返し単位からなる共重合体を2種類含む高分子組成物であって、該共重合体の共重合比は互いに異なるが繰り返し単位の組み合わせは同一である高分子組成物においては、発光効率や寿命特性等の素子特性の観点から、高分子組成物において、前記式(16)で示される繰り返し単位と前記式(20)で示される繰り返し単位のモル比が99:1~70:30であるように高分子化合物もしくは共重合体を混合することが好ましく、95:5~80:20であることが好ましく、92:8~85:15であることがさらに好ましい。

[0181]

[0182]

発光層の形成方法としては、例えば、溶液からの成膜による方法が例示される。溶液からの成膜方法としては、スピンコート法、キャスティング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。パターン形成や多色の塗分けが容易であるという点で、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の印刷法が好ましい。

[0183]

印刷法等で用いる溶液(インク組成物)としては、少なくとも1種類の本発明の高分子 化合物が含有されていればよく、また本発明の高分子化合物以外に正孔輸送材料、電子輸 送材料、発光材料、溶媒、安定剤などの添加剤を含んでいてもよい。

該インク組成物中における本発明の高分子化合物の割合は、溶媒を除いた組成物の全重量に対して通常は $20wt\%\sim100wt\%$ であり、好ましくは $40wt\%\sim100wt$ %である。

またインク組成物中に溶媒が含まれる場合の溶媒の割合は、組成物の全重量に対して1

wt%~99.9wt%であり、好ましくは60wt%~99.5wt%であり、さらに好ましく80wt%~99.0wt%である。

インク組成物の粘度は印刷法によって異なるが、インクジェットプリント法などインク組成物中が吐出装置を経由するもの場合には、吐出時の目づまりや飛行曲がりを防止するために粘度が25℃において1~20mPa·sの範囲であることが好ましい。

[0184]

本発明の溶液は、発明の高分子化合物の他に、粘度および/または表面張力を調節するための添加剤を含有していても良い。該添加剤としては、粘度を高めるための高分子量の高分子化合物(増粘剤)や貧溶媒、粘度を下げるための低分子量の化合物、表面張力を下げるための界面活性剤などを適宜組み合わせて使用すれば良い。

[0185]

前記の高分子量の高分子化合物としては、本発明の高分子化合物と同じ溶媒に可溶性で、 発光や電荷輸送を阻害しないものであれば良い。例えば、高分子量のポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、あるいは本発明の高分子化合物のうち分子量が大きいものなどを 用いることができる。重量平均分子量が50万以上が好ましく、100万以上がより好ま しい。

賃溶媒を増粘剤として用いることもできる。すなわち、溶液中の固形分に対する賃溶媒を少量添加することで、粘度を高めることができる。この目的で賃溶媒を添加する場合、溶液中の固形分が析出しない範囲で、溶媒の種類と添加量を選択すれば良い。保存時の安定性も考慮すると、賃溶媒の量は、溶液全体に対して50wt%以下であることが好ましく、30wt%以下であることが更に好ましい。

[0186]

また、本発明の溶液は、保存安定性を改善するために、本発明の高分子化合物の他に、酸化防止剤を含有していても良い。酸化防止剤としては、本発明の高分子化合物と同じ溶媒に可溶性で、発光や電荷輸送を阻害しないものであれば良く、フェノール系酸化防止剤、リン系酸化防止剤などが例示される。

[0187]

溶液に用いる溶媒としては特に制限はないが、該インク組成物を構成する溶媒以外の材 料を溶解または均一に分散できるものが好ましい。該溶媒としてクロロホルム、塩化メチ レン、1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、クロロベンゼン、o-ジクロロベンゼン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶媒 、トルエン、キシレン、シクロヘキシルベンゼン、テトラリン等の芳香族炭化水素系溶媒 、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、ジシクロヘキシル、デカリン、nーペンタン 、n-ヘキサン、n-ヘプタン、n-オクタン、n-ノナン、n-デカン等の脂肪族炭化 水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン系溶媒、酢酸 エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒、エチレングリコ ール、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル 、エチレングリコールモノメチルエーテル、ジメトキシエタン、プロピレングリコール、 ジエトキシメタン、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、グリセリン、1,2-ヘキサンジオール等の多価アルコールおよびその誘導体、メタノール、エタノール、プロ パノール、イソプロパノール、シクロヘキサノール等のアルコール系溶媒、ジメチルスル ホキシド等のスルホキシド系溶媒、Nーメチルー2ーピロリドン、N,Nージメチルホル ムアミド等のアミド系溶媒が例示される。また、これらの有機溶媒は、単独で、または複 数組み合わせて用いることができる。

本発明の溶液に含まれる溶媒は、塗布法に応じて適宜選択すれば良いが、2種類以上の有機溶媒を組み合わせることで、乾燥・成膜条件を容易に制御できるため、より好ましい。例えば、低沸点溶媒と高沸点溶媒とを組み合わせることで、乾燥速度を制御しやすくなり、適宜制御することで、膜の表面平坦性を向上させることができる。

[0188]

また、本発明の高分子LEDとしては、陰極と発光層との間に、電子輸送層を設けた高 出証特2004-3120184 分子LED、陽極と発光層との間に、正孔輸送層を設けた高分子LED、陰極と発光層と の間に、電子輸送層を設け、かつ陽極と発光層との間に、正孔輸送層を設けた高分子LE D等が挙げられる。

[0189]

例えば、具体的には、以下の a) ~d) の構造が例示される。

- a) 陽極/発光層/陰極
- b) 陽極/正孔輸送層/発光層/陰極
- c) 陽極/発光層/電子輸送層/陰極
- d) 陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極

(ここで、/は各層が隣接して積層されていることを示す。以下同じ。)

[0190]

本発明の高分子LEDとしては、本発明の高分子化合物が正孔輸送層および/または電 子輸送層に含まれているものも含む。

本発明の高分子化合物が正孔輸送層に用いられる場合には、本発明の高分子化合物が正孔 輸送性基を含む高分子化合物であることが好ましく、その具体例としては、芳香族アミン との共重合体、スチルベンとの共重合体などが例示される。

また、本発明の高分子化合物が電子輸送層に用いられる場合には、本発明の高分子化合物 が電子輸送性基を含む高分子化合物であることが好ましく、その具体例としては、オキサ ジアゾールとの共重合体、トリアゾールとの共重合体、キノリンとの共重合体、キノキサ リンとの共重合体、ベンゾチアジアゾールとの共重合体などが例示される。

[0191]

本発明の高分子LEDが正孔輸送層を有する場合、使用される正孔輸送性材料としては 、ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖も しくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体、ピラゾリン誘導体、アリール アミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体、ポリアニリンもしくは その誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリピロールもしくはその誘導体、ポ リ (p-フェニレンビニレン) もしくはその誘導体、またはポリ (2,5-チエニレンビ ニレン) もしくはその誘導体などが例示される。

[0192]

具体的には、該正孔輸送性材料として、特開昭63-70257号公報、同63-17 5860号公報、特開平2-135359号公報、同2-135361号公報、同2-2 09988号公報、同3-37992号公報、同3-152184号公報に記載されてい るもの等が例示される。

[0193]

rel.

これらの中で、正孔輸送層に用いる正孔輸送性材料として、ポリビニルカルバゾールも しくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミン化 合物基を有するポリシロキサン誘導体、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェ ンもしくはその誘導体、ポリ(p-フェニレンビニレン)もしくはその誘導体、またはポ リ(2,5-チエニレンビニレン)もしくはその誘導体等の高分子正孔輸送性材料が好ま しく、さらに好ましくはポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしく はその誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体である。

[0194]

また、低分子化合物の正孔輸送性材料としてはピラブリン誘導体、アリールアミン誘導体 、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体が例示される。低分子の正孔輸送性材 料の場合には、高分子バインダーに分散させて用いることが好ましい。

[0195]

混合する高分子バインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、ま た可視光に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。該高分子バインダーとして、 ポリ(N-ビニルカルバゾール)、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンも しくはその誘導体、ポリ (p-フェニレンビニレン) もしくはその誘導体、ポリ (2,5 ーチエニレンビニレン)もしくはその誘導体、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポ リメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポ リシロキサン等が例示される。

[0196]

ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体は、例えばビニルモノマーからカチオン重 合またはラジカル重合によって得られる。

[0197]

ポリシランもしくはその誘導体としては、ケミカル・レビュー (Chem. Rev.) 第89巻、1359頁(1989年)、英国特許GB2300196号公開明細書に記載 の化合物等が例示される。合成方法もこれらに記載の方法を用いることができるが、特に キッピング法が好適に用いられる。

[0198]

ポリシロキサンもしくはその誘導体は、シロキサン骨格構造には正孔輸送性がほとんど ないので、側鎖または主鎖に上記低分子正孔輸送性材料の構造を有するものが好適に用い られる。特に正孔輸送性の芳香族アミンを側鎖または主鎖に有するものが例示される。

[0199]

正孔輸送層の成膜の方法に制限はないが、低分子正孔輸送性材料では、高分子バインダ ーとの混合溶液からの成膜による方法が例示される。また、高分子正孔輸送性材料では、 溶液からの成膜による方法が例示される。

[0200]

溶液からの成膜に用いる溶媒としては、正孔輸送性材料を溶解または均一に分散できる ものが好ましい。該溶媒としてクロロホルム、塩化メチレン、1,2ージクロロエタン、 1,1,2-トリクロロエタン、クロロベンゼン、o-ジクロロベンゼン等の塩素系溶媒 、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族 炭化水素系溶媒、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、nーペンタン、nーヘキサン 、n-ヘプタン、n-オクタン、n-ノナン、n-デカン等の脂肪族炭化水素系溶媒、ア セトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブ チル、エチルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒、エチレングリコール、エチレン グリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリ コールモノメチルエーテル、ジメトキシエタン、プロピレングリコール、ジエトキシメタ ン、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、グリセリン、1,2-ヘキサンジオー ル等の多価アルコールおよびその誘導体、メタノール、エタノール、プロパノール、イソ プロパノール、シクロヘキサノール等のアルコール系溶媒、ジメチルスルホキシド等のス ルホキシド系溶媒、Nーメチルー2ーピロリドン、N, Nージメチルホルムアミド等のア ミド系溶媒が例示される。また、これらの有機溶媒は、単独で、または複数組み合わせて 用いることができる。

[0201]

溶液からの成膜方法としては、溶液からのスピンコート法、キャスティング法、マイク ログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバー コート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、 オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

[0202]

正孔輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率 が適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚 さが必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該正 孔輸送層の膜厚としては、例えば1 nmから1 μmであり、好ましくは2 nm~500 n mであり、さらに好ましくは5nm~200nmである。

[0203]

本発明の高分子LEDが電子輸送層を有する場合、使用される電子輸送性材料としては 公知のものが使用でき、オキサジアゾール誘導体、アントラキノジメタンもしくはその誘 導体、ベンゾキノンもしくはその誘導体、ナフトキノンもしくはその誘導体、アントラキ ノンもしくはその誘導体、テトラシアノアンスラキノジメタンもしくはその誘導体、フル オレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチレンもしくはその誘導体、ジフェノキノン誘導 体、または8-ヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、ポリキノリンもしく はその誘導体、ポリキノキサリンもしくはその誘導体、ポリフルオレンもしくはその誘導 体等が例示される。

[0204]

具体的には、特開昭63-70257号公報、同63-175860号公報、特開平2 -135359号公報、同2-135361号公報、同2-209988号公報、同3-37992号公報、同3-152184号公報に記載されているもの等が例示される。

[0205]

これらのうち、オキサジアゾール誘導体、ベンゾキノンもしくはその誘導体、アントラ キノンもしくはその誘導体、または8ーヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯 体、ポリキノリンもしくはその誘導体、ポリキノキサリンもしくはその誘導体、ポリフル オレンもしくはその誘導体が好ましく、2- (4-ビフェニリル) -5- (4-t-ブチ ルフェニル) -1,3,4-オキサジアゾール、ベンゾキノン、アントラキノン、トリス (8-キノリノール) アルミニウム、ポリキノリンがさらに好ましい。

[0206]

電子輸送層の成膜法としては特に制限はないが、低分子電子輸送性材料では、粉末から の真空蒸着法、または溶液もしくは溶融状態からの成膜による方法が、高分子電子輸送材 料では溶液または溶融状態からの成膜による方法がそれぞれ例示される。溶液または溶融 状態からの成膜時には、上記の高分子バインダーを併用してもよい。

[0207]

溶液からの成膜に用いる溶媒としては、電子輸送材料および/または高分子バインダー を溶解または均一に分散できるものが好ましい。該溶媒としてクロロホルム、塩化メチレ ン、1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、クロロベンゼン、oージ クロロベンゼン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶媒、 トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン 、nーペンタン、nーヘキサン、nーヘプタン、nーオクタン、nーノナン、nーデカン 等の脂肪族炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケト ン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒、 エチレングリコール、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノ エチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、ジメトキシエタン、プロピレ ングリコール、ジエトキシメタン、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、グリセ リン、1,2-ヘキサンジオール等の多価アルコールおよびその誘導体、メタノール、エ タノール、プロパノール、イソプロパノール、シクロヘキサノール等のアルコール系溶媒 、ジメチルスルホキシド等のスルホキシド系溶媒、Nーメチルー2ーピロリドン、N, N ージメチルホルムアミド等のアミド系溶媒が例示される。また、これらの有機溶媒は、単 独で、または複数組み合わせて用いることができる。

[0208]

溶液または溶融状態からの成膜方法としては、スピンコート法、キャスティング法、マ イクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアー バーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷 法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

[0209]

電子輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率 が適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚 さが必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該電 子輸送層の膜厚としては、例えば1nmから1μmであり、好ましくは2nm~500n mであり、さらに好ましくは5 nm~200 nmである。

[0210]

また、電極に隣接して設けた電荷輸送層のうち、電極からの電荷注入効率を改善する機 能を有し、素子の駆動電圧を下げる効果を有するものは、特に電荷注入層(正孔注入層、 電子注入層)と一般に呼ばれることがある。

[0211]

さらに電極との密着性向上や電極からの電荷注入の改善のために、電極に隣接して前記 の電荷注入層又は膜厚2nm以下の絶縁層を設けてもよく、また、界面の密着性向上や混 合の防止等のために電荷輸送層や発光層の界面に薄いバッファー層を挿入してもよい。

積層する層の順番や数、および各層の厚さについては、発光効率や素子寿命を勘案して 適宜用いることができる。

[0212]

本発明において、電荷注入層(電子注入層、正孔注入層)を設けた高分子LEDとして は、陰極に隣接して電荷注入層を設けた高分子LED、陽極に隣接して電荷注入層を設け た高分子LEDが挙げられる。

例えば、具体的には、以下の e)~p)の構造が挙げられる。

- e) 陽極/正孔注入層/発光層/陰極
- f) 陽極/発光層/電子注入層/陰極
- g) 陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極
- h) 陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/陰極
- i) 陽極/正孔輸送層/発光層/電子注入層/陰極
- j) 陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子注入層/陰極
- k) 陽極/正孔注入層/発光層/電子輸送層/陰極
- 陽極/発光層/電子輸送層/電子注入層/陰極
- m) 陽極/正孔注入層/発光層/電子輸送層/電子注入層/陰極
- n) 陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極
- o) 陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層/陰極
- p) 陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層/陰極

[0213]

本発明の高分子LEDとしては、前述のとおり、本発明の高分子化合物が正孔輸送層およ び/または電子輸送層に含まれているものも含む。

また、本発明の高分子LEDとしては、本発明の高分子化合物が正孔注入層および/また は電子注入層に含まれているものも含む。本発明の高分子化合物が正孔注入層に用いられ る場合には、電子受容性化合物と同時に用いられることが好ましい。また、本発明の高分 子化合物が電子輸送層に用いられる場合には、電子供与性化合物と同時に用いられること が好ましい。ここで、同時に用いるためには、混合、共重合、側鎖としての導入などの方 法がある。

[0214]

電荷注入層の具体的な例としては、導電性高分子を含む層、陽極と正孔輸送層との間に 設けられ、陽極材料と正孔輸送層に含まれる正孔輸送性材料との中間の値のイオン化ポテ ンシャルを有する材料を含む層、陰極と電子輸送層との間に設けられ、陰極材料と電子輸 送層に含まれる電子輸送性材料との中間の値の電子親和力を有する材料を含む層などが例 示される。

[0215]

上記電荷注入層が導電性高分子を含む層の場合、該導電性高分子の電気伝導度は、10 -5 S/cm以上10³以下であることが好ましく、発光画素間のリーク電流を小さくする ためには、 10^{-5} S/c m以上 10^2 以下がより好ましく、 10^{-5} S/c m以上 10^1 以下 がさらに好ましい。

[0216]

上記電荷注入層が導電性高分子を含む層の場合、該導電性高分子の電気伝導度は、10

-5 S/c m以上 1 0 3 S/c m以下であることが好ましく、発光画素間のリーク電流を小 さくするためには、 10^{-5} S/c m以上 10^2 S/c m以下がより好ましく、 10^{-5} S/ $cm以上<math>10^1 S/cm$ 以下がさらに好ましい。

通常は該導電性高分子の電気伝導度を10⁻⁵S/cm以上10³以下とするために、該 導電性高分子に適量のイオンをドープする。

[0217]

ドープするイオンの種類は、正孔注入層であればアニオン、電子注入層であればカチオ ンである。アニオンの例としては、ポリスチレンスルホン酸イオン、アルキルベンゼンス ルホン酸イオン、樟脳スルホン酸イオンなどが例示され、カチオンの例としては、リチウ ムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、テトラブチルアンモニウムイオンなどが 例示される。

電荷注入層の膜厚としては、例えば1 n m ~ 1 0 0 n m であり、2 n m ~ 5 0 n m が好 ましい。

[0218]

電荷注入層に用いる材料は、電極や隣接する層の材料との関係で適宜選択すればよく、 ポリアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリピロールおよび その誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよび その誘導体、ポリキノリンおよびその誘導体、ポリキノキサリンおよびその誘導体、芳香 族アミン構造を主鎖または側鎖に含む重合体などの導電性高分子、金属フタロシアニン(銅フタロシアニンなど)、カーボンなどが例示される。

[0219]

膜厚2 nm以下の絶縁層は電荷注入を容易にする機能を有するものである。上記絶縁層 の材料としては、金属フッ化物、金属酸化物、有機絶縁材料等が挙げられる。膜厚2nm 以下の絶縁層を設けた高分子LEDとしては、陰極に隣接して膜厚2ヵm以下の絶縁層を 設けた高分子LED、陽極に隣接して膜厚2 nm以下の絶縁層を設けた高分子LEDが挙 げられる。

[0220]

1

具体的には、例えば、以下のq)~ab)の構造が挙げられる。

- q) 陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/発光層/陰極
- r) 陽極/発光層/膜厚2nm以下の絶縁層/陰極
- s)陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/発光層/膜厚2 n m以下の絶縁層/陰極
- t) 陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/正孔輸送層/発光層/陰極
- u) 陽極/正孔輸送層/発光層/膜厚2 n m以下の絶縁層/陰極
- 陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/正孔輸送層/発光層/膜厚2nm以下の絶縁層/陰 極
- w) 陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/発光層/電子輸送層/陰極
- x) 陽極/発光層/電子輸送層/膜厚2 n m以下の絶縁層/陰極
- y) 陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/発光層/電子輸送層/膜厚2 n m以下の絶縁層/陰 極
- z) 陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極
- a a) 陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/膜厚2 n m以下の絶縁層/陰極
- a b)陽極/膜厚 2 n m以下の絶縁層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/膜厚 2 n m以 下の絶縁層/陰極

本発明の高分子LEDは、上記a)~ab)に例示した素子構造において、正孔注入層 、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層のうちのいずれかに、本発明の高分子 化合物を含むものがあげられる。

[0221]

本発明の高分子LEDを形成する基板は、電極を形成し、有機物の層を形成する際に変 化しないものであればよく、例えばガラス、プラスチック、高分子フィルム、シリコン基 板などが例示される。不透明な基板の場合には、反対の電極が透明または半透明であるこ とが好ましい。

[0222]

通常本発明の高分子LEDが有する陽極および陰極の少なくとも一方が透明または半透 明である。陽極側が透明または半透明であることが好ましい。

該陽極の材料としては、導電性の金属酸化物膜、半透明の金属薄膜等が用いられる。具体 的には、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化スズ、およびそれらの複合体であるインジウム ・スズ・オキサイド(ITO)、インジウム・亜鉛・オキサイド等からなる導電性ガラス を用いて作成された膜(NESAなど)や、金、白金、銀、銅等が用いられ、ITO、イ ンジウム・亜鉛・オキサイド、酸化スズが好ましい。作製方法としては、真空蒸着法、ス パッタリング法、イオンプレーティング法、メッキ法等が挙げられる。また、該陽極とし て、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体などの有機の 透明導電膜を用いてもよい。

陽極の膜厚は、光の透過性と電気伝導度とを考慮して、適宜選択することができるが、 例えば10nmから10 μ mであり、好ましくは20nm~1 μ mであり、さらに好まし くは50nm~500nmである。

また、陽極上に、電荷注入を容易にするために、フタロシアニン誘導体、導電性高分子 、カーボンなどからなる層、あるいは金属酸化物や金属フッ化物、有機絶縁材料等からな る平均膜厚2 nm以下の層を設けてもよい。

[0223]

本発明の高分子LEDで用いる陰極の材料としては、仕事関数の小さい材料が好ましい 。例えば、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、ベリリウム、マグ ネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、アルミニウム、スカンジウム、バナ ジウム、亜鉛、イットリウム、インジウム、セリウム、サマリウム、ユーロピウム、テル ビウム、イッテルビウムなどの金属、およびそれらのうち2つ以上の合金、あるいはそれ らのうち1つ以上と、金、銀、白金、銅、マンガン、チタン、コバルト、ニッケル、タン グステン、錫のうち1つ以上との合金、グラファイトまたはグラファイト層間化合物等が 用いられる。合金の例としては、マグネシウムー銀合金、マグネシウムーインジウム合金 、マグネシウムーアルミニウム合金、インジウムー銀合金、リチウムーアルミニウム合金 、リチウムーマグネシウム合金、リチウムーインジウム合金、カルシウムーアルミニウム 合金などが挙げられる。陰極を2層以上の積層構造としてもよい。

陰極の膜厚は、電気伝導度や耐久性を考慮して、適宜選択することができるが、例えば $10\,n\,m$ から $10\,\mu\,m$ であり、好ましくは $20\,n\,m$ \sim $1\,\mu\,m$ であり、さらに好ましくは 50 n m~5 0 0 n m である。

[0224]

陰極の作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、また金属薄膜を熱圧着する ラミネート法等が用いられる。また、陰極と有機物層との間に、導電性高分子からなる層 、あるいは金属酸化物や金属フッ化物、有機絶縁材料等からなる平均膜厚2nm以下の層 を設けてもよく、陰極作製後、該高分子LEDを保護する保護層を装着していてもよい。 該高分子LEDを長期安定的に用いるためには、素子を外部から保護するために、保護層 および/または保護カバーを装着することが好ましい。

[0225]

該保護層としては、高分子化合物、金属酸化物、金属フッ化物、金属ホウ化物などを用 いることができる。また、保護カバーとしては、ガラス板、表面に低透水率処理を施した プラスチック板などを用いることができ、該カバーを熱効果樹脂や光硬化樹脂で素子基板 と貼り合わせて密閉する方法が好適に用いられる。スペーサーを用いて空間を維持すれば 、素子がキズつくのを防ぐことが容易である。該空間に窒素やアルゴンのような不活性な ガスを封入すれば、陰極の酸化を防止することができ、さらに酸化バリウム等の乾燥剤を 該空間内に設置することにより製造工程で吸着した水分が素子にタメージを与えるのを抑 制することが容易となる。これらのうち、いずれか1つ以上の方策をとることが好ましい

[0226]

本発明の高分子LEDは面状光源、セグメント表示装置、ドットマトリックス表示装置 、液晶表示装置のバックライトとして用いることができる。

本発明の高分子LEDを用いて面状の発光を得るためには、面状の陽極と陰極が重なり 合うように配置すればよい。また、パターン状の発光を得るためには、前記面状の発光素 子の表面にパターン状の窓を設けたマスクを設置する方法、非発光部の有機物層を極端に 厚く形成し実質的に非発光とする方法、陽極または陰極のいずれか一方、または両方の電 極をパターン状に形成する方法がある。これらのいずれかの方法でパターンを形成し、い くつかの電極を独立にOn/OFFできるように配置することにより、数字や文字、簡単 な記号などを表示できるセグメントタイプの表示素子が得られる。更に、ドットマトリッ クス素子とするためには、陽極と陰極をともにストライプ状に形成して直交するように配 置すればよい。複数の種類の発光色の異なる高分子蛍光体を塗り分ける方法や、カラーフ ィルターまたは蛍光変換フィルターを用いる方法により、部分カラー表示、マルチカラー 表示が可能となる。ドットマトリックス素子は、パッシブ駆動も可能であるし、TFTな どと組み合わせてアクティブ駆動してもよい。これらの表示素子は、コンピュータ、テレ ビ、携帯端末、携帯電話、カーナビゲーション、ビデオカメラのビューファインダーなど の表示装置として用いることができる。

[0227]

さらに、前記面状の発光素子は、自発光薄型であり、液晶表示装置のバックライト用の 面状光源、あるいは面状の照明用光源として好適に用いることができる。また、フレキシ ブルな基板を用いれば、曲面状の光源や表示装置としても使用できる。

【実施例】

[0228]

以下、本発明をさらに詳細に説明するために実施例を示すが、本発明はこれらに限定さ れるものではない。

(数平均分子量および重量平均分子量)

ここで、数平均分子量および重量平均分子量については、GPC(島津製作所製:LC-10Avp)によりポリスチレン換算の数平均分子量および重量平均分子量を求めた。測 定する重合体は、約0.5wt%の濃度になるようテトラヒドロフランに溶解させ、GP $C に 50 \mu$ L注入した。GPCの移動相はテトラヒドロフランを用い、0.6 m L/m i nの流速で流した。カラムは、TSKgel SuperHM-H(東ソー製)2本とT SKgel SuperH2000 (東ソー製) 1本を直列に繋げた。検出器には示差屈 折率検出器(島津製作所製:RID-10A)を用いた。

[0229]

(蛍光スペクトル)

蛍光スペクトルの測定は以下の方法で行った。重合体の 0.8 w t %クロロホルム溶液 を石英上にスピンコートして重合体の薄膜を作製した。この薄膜を375 nmの波長で励 起し、蛍光分光光度計(日立製作所850もしくは堀場製作所製F1uorolog)を 用いて蛍光スペクトルを測定した。

[0230]

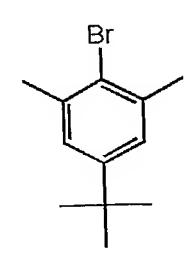
(ガラス転移温度)

ガラス転移温度はDSC(DSC2920、TA Instruments製)により求 めた。

[0231]

合成例1

(1-ブロモー4-t-ブチルー2,6-ジメチルベンゼンの合成)



不活性雰囲気下で、500m1の3つ口フラスコに酢酸225gを入れ、5-t-ブチル -m-キシレン24.3gを加えた。続いて臭素31.2gを加えた後、15~20℃で 3時間反応させた。

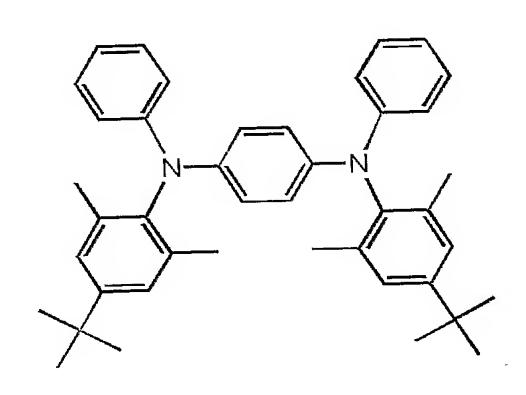
反応液を水500m1に加え析出した沈殿をろ過した。水250m1で2回洗浄し、白 色の固体34.2gを得た。

 $^{1}H-NMR$ (3 0 0 MHz/CDC 1 3):

 δ (ppm) = 1.3 (s, 9H), 2.4 (s, 6H), 7.1 (s, 2H) MS (FD+) M+ 241

[0232]

<N, N' ージフェニルーN, N' ービス(4-tーブチルー2, 6ージメチルフェニル) -1, 4-フェニレンジアミンの合成>



不活性雰囲気下で、100m1の3つ口フラスコに脱気した脱水トルエン36m1を入れ 、トリ(t-ブチル)ホスフィン0. 63gを加えた。続いてトリス(ジベンジリデンア セトン) ジパラジウム 0.41g、1-ブロモー4-t-ブチルー2,6-ジメチルベ ンゼン9. 6 g、 t ープトキシナトリウム5. 2 g、N, N, ージフェニルー1, 4 ーフ ェニレンジアミン4.7gを加えた後、100℃で3時間反応させた。

反応液を飽和食塩水300m1に加え、約50℃に温めたクロロホルム300m1で抽出 した。溶媒を留去した後、トルエン100m1を加えて、固体が溶解するまで加熱、放冷 した後、沈殿をろ過し、白色の固体9.9gを得た。

[0233]

<N, N' - -ビス (4-プロモフェニル) -N, N' -ビス (4-t -プチルー 2, 6-ジメチルフェニル)-1,4-フェニレンジアミンの合成>

不活性雰囲気下で、1000mlの3つ口フラスコに脱水N, N-ジメチルホルムアミド 350m1を入れ、, N' ージフェニルーN, N' ービス(4-tーブチルー2, 6 ージ メチルフェニル) -1, 4-フェニレンジアミン5.2gを溶解した後、氷浴下でNーブ ロモスクシンイミド3.5g/N, Nージメチルホルムアミド溶液を滴下し、一昼夜反応 させた。

反応液に水150m1を加え、析出した沈殿をろ過し、メタノール50m1で2回洗浄し 白色の固体4.4gを得た。

 $^{1}H-NMR$ (300MHz/THF-d8):

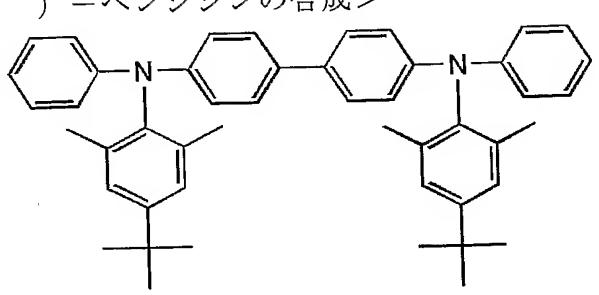
 $\delta (ppm) = 1.3 (s, 18H), 2.0 (s, 12H), 6.6 \sim 6.7 (d,$ 4H], 6.8~6.9 [br, 4H], 7.1 [s, 4H], 7.2~7.3 [d, 4 H

 $MS (FD^{+}) M^{+} 738$

[0234]

合成例 2

<N, N' -ジフェニルーN, N' -ビス(4-t - ブチルー2, 6-ジメチルフェニル -ベンジジンの合成>



不活性雰囲気下で、300mlの3つ口フラスコに脱気した脱水トルエン1660ml を入れ、N, N' -ジフェニルベンジジン275.0g、4-t-ブチルー2,6-ジメ チルブロモベンゼン449.0gを加えた。続いてトリス(ジベンジリデンアセトン)ジ パラジウム 7.48g、tーブトキシナトリウム196.4g、を加えた後、トリ(t ーブチル) ホスフィン5.0gを加えた。その後、105℃で7時間反応させた。

反応液にトルエン2000m1を加え、セライト濾過し、濾液を水1000m1で3回 洗浄した後、700m1まで濃縮した。これにトルエン/メタノール(1:1)溶液16 00m1を加え、析出した結晶を濾過し、メタノールで洗浄した。白色の固体479.4 gを得た。

MS (APCI (+)) : (M+H) + 657.4

6-ジメチルフェニル)ーベンジジンの合成>

不活性雰囲気下で、クロロホルム4730gに、上記N, N'ージフェニルーN, N'ー ビス (4-t-ブチルー2,6-ジメチルフェニル) -ベンジジン472.8gを溶解し た後、遮光および氷浴下でN-ブロモスクシンイミド281.8gを12分割で1時間か けて仕込み、3時間反応させた。

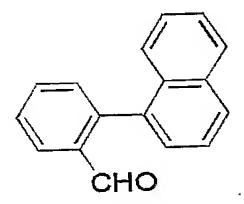
クロロホルム1439m1を反応液に加え、濾過し、濾液のクロロホルム溶液を5%チオ 硫酸ナトリウム2159m1で洗浄し、トルエンを溶媒留去して白色結晶を得た。得られ た白色結晶をトルエン/エタノールで再結晶し、白色結晶678.7gを得た。

MS (APCI (+)) : (M+H) + 815.2

[0235]

合成例3 <化合物Gの合成>

(化合物Dの合成)



化合物D

不活性雰囲気下、300m1三つ口フラスコに1-ナフタレンボロン酸5.00g(2 9 m m o 1)、2 - ブロモベンズアルデヒド6.46 g (35 m m o 1)、炭酸カリウム 10.0g(73mmol)、トルエン36ml、イオン交換水36mlを入れ、室温で 撹拌しつつ20分間アルゴンバブリングした。続いてテトラキス(トリフェニルホスフィ ン) パラジウム 1 6. 8 mg (0.15 mm o 1) を入れ、さらに室温で撹拌しつつ 1 0 分間アルゴンバブリングした。100℃に昇温し、25時間反応させた。室温まで冷却後 、トルエンで有機層を抽出、硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を留去した。トルエン:シク ロヘキサン=1:2混合溶媒を展開溶媒としたシリカゲルカラムで生成することにより、 化合物 D 5.18g(収率 86%)を白色結晶として得た。

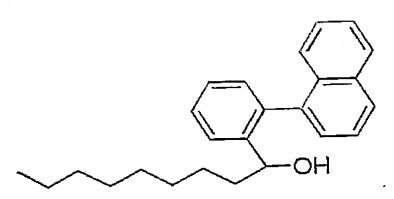
 $^{1}H-NMR$ (3 0 0 MHz/CDC 1 3):

 δ 7. 39 \sim 7. 62 (m, 5H), 7. 70 (m, 2H), 7. 94 (d, 2H), 8. 12 (dd, 2H), 9. 63 (s, 1H)

 $MS (APCI (+)) : (M+H)^{+} 233$

[0236]

(化合物 E の合成)

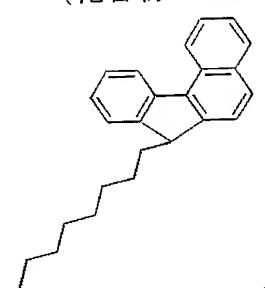


化合物E

不活性雰囲気下で300mlの三つ口フラスコに化合物D 8.00g(34.4mmo 1)と脱水THF46m1を入れ、一78℃まで冷却した。続いてnーオクチルマグネシ ウムブロミド (1.0 m o 1 / 1 T H F 溶液) 5 2 m 1 を 3 0 分かけて滴下した。滴下終 了後0℃まで昇温し、1時間撹拌後、室温まで昇温して45分間撹拌した。氷浴して1N 塩酸20m1を加えて反応を終了させ、酢酸エチルで有機層を抽出、硫酸ナトリウムで乾 燥した。溶媒を留去した後トルエン:ヘキサン=10:1混合溶媒を展開溶媒とするシリ カゲルカラムで精製することにより、化合物E7.64g(収率64%)を淡黄色のオイ ルとして得た。HPLC測定では2本のピークが見られたが、LC-MS測定では同一の 質量数であることから、異性体の混合物であると判断した。

[0237]

(化合物 F の合成)



化合物F

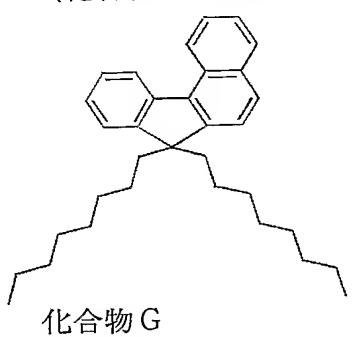
不活性雰囲気下、500m1三つ口フラスコに化合物E(異性体の混合物)5.00g(14.4mmo1)と脱水ジクロロメタン74m1を入れ、室温で撹拌、溶解させた。続 いて、三フッ化ホウ素のエーテラート錯体を室温で1時間かけて滴下し、滴下終了後室温 で4時間撹拌した。撹拌しながらエタノール125mlをゆっくりと加え、発熱がおさま ったらクロロホルムで有機層を抽出、2回水洗し、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を 留去後、ヘキサンを展開溶媒とするシリカゲルカラムで精製することにより、化合物 F3 . 22g(収率68%)を無色のオイルとして得た。

 $^{1}H-NMR$ (300MHz/CDC1₃):

 δ 0. 90 (t, 3H), 1. 03 \sim 1. 26 (m, 14H), 2. 13 (m, 2H) , 4. 05 (t, 1H), 7. 35 (dd, 1H), 7. 46~7. 50 (m, 2H), 7. 59~7. 65 (m, 3H), 7. 82 (d, 1H), 7. 94 (d, 1H), 8. 35 (d, 1H), 8.75 (d, 1H) 3 2 9 $MS (APCI (+)) : (M+H)^{+}$

[0238]

(化合物 G の合成)



不活性雰囲気下200m1三つ口フラスコにイオン交換水20m1をいれ、撹拌しなが ら水酸化ナトリウム18.9g(0.47mo1)を少量ずつ加え、溶解させた。水溶液 が室温まで冷却した後、トルエン20ml、化合物F5.17g(15.7mmol)、臭 化トリブチルアンモニウム1.52g(4.72mmol)を加え、50℃に昇温した。 臭化n-オクチルを滴下し、滴下終了後50℃で9時間反応させた。反応終了後トルエン で有機層を抽出し、2回水洗し、硫酸ナトリウムで乾燥した。ヘキサンを展開溶媒とする シリカゲルカラムで精製することにより、化合物 G 5. 13g(収率 74%)を黄色のオ イルとして得た。

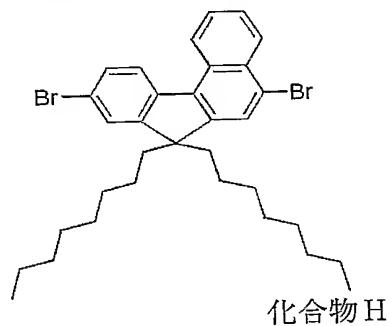
 $^{1}H-NMR$ (300MHz/CDC1₃):

80.52 (m, 2H), 0.79 (t, 6H), 1.00~1.20 (m, 22H) 、2.05(t,4H)、7.34(d,1H)、7.40~7.53(m,2H)、7 . 63 (m, 3H), 7. 83 (d, 1H), 7. 94 (d, 1H), 8. 31 (d, 1 H) 、8.75 (d、1H)

 $4\ 4\ 1$ $MS (APCI (+)) : (M+H)^{+}$

[0239]

実施例1 (化合物Hの合成)



空気雰囲気下、50mlの三つ口フラスコに化合物G4.00g(9.08mmol) と酢酸:ジクロロメタン=1:1混合溶媒57mlを入れ、室温で撹拌、溶解させた。続 いて三臭化ベンジルトリメチルアンモニウム 7.79g(20.0mmo1)を加えて撹 拌しつつ、塩化亜鉛を三臭化ベンジルトリメチルアンモニウムが完溶するまで加えた。室 温で20時間撹拌後、5%亜硫酸水素ナトリウム水溶液10m1を加えて反応を停止し、 クロロホルムで有機層を抽出、炭酸カリウム水溶液で2回洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥 した。ヘキサンを展開溶媒とするフラッシュカラムで2回精製した後、エタノール:ヘキ サン=1:1、続いて10:1混合溶媒で再結晶することにより、化合物 H4.13g(収率76%)を白色結晶として得た。

 $^{1}H-NMR$ (300MHz/CDC1₃):

δ0.60 (m, 2H), 0.91 (t, 6H), 1.01~1.38 (m, 22H) , 2. 09 (t, 4H), 7. 62 \sim 7. 75 (m, 3H), 7. 89 (s, 1H), 8 . 20 (d, 1H), 8. 47 (d, 1H), 8. 72 (d, 1H) 5 9 8

 $MS (APPI (+)) : (M+H)^{+}$ [0240]

実施例 2

化合物 H (10.6g、17.6mmol)、N、N'ービス(4-ブロモフェニル) -N、N' -ビス (4-t-ブチルー2, 6-ジメチルフェニル)-1, 4-フェニレン ジアミン (0. 27g、0. 36mmol) および2, 2'ービピリジル (7. 6g、4 8. 6 mm o 1) を脱水したテトラヒドロフラン1200mLに溶解した後、窒素でバブ リングして系内を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液を60℃まで昇温し、 60℃でビス (1、5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) {Ni (COD) 2} (1 3. 4g、48.6mmol)加え、攪拌しながら3時間反応させた。反応後、この反応 液を室温(約25℃)まで冷却し、25%アンモニア水65mL/メタノール1200m L/イオン交換水1200mL混合溶液中に滴下して攪拌した後、析出した沈殿をろ過し て2時間減圧乾燥し、その後、トルエン540mLに溶解させてからろ過を行い、ろ液を アルミナカラムを通して精製し、トルエン層を、5.2%塩酸水約1000mLで3時間 、4%アンモニア水約1000mLで2時間、さらにイオン交換水約1000mLで洗浄 した。有機層をメタノール約1000mLに滴下して30分攪拌し、析出した沈殿をろ過 して 2 時間減圧乾燥させた。得られた重合体の収量は 8. 4 2 gであった。この重合体を 高分子化合物1と呼ぶ。得られた高分子化合物1のポリスチレン換算重量平均分子量は、 3. 9×10^5 であり、数平均分子量は、5. 4×10^4 であった。

[0241]

実施例3

化合物H (7. 1g、11. 9mmol)、N、N', ービス (4-ブロモフェニル) ーN、 N' ービス (4-t-ブチルー2, 6-ジメチルフェニル) ー1, 4ーフェニレンジアミン (0. 46g、0. 63mmol) および2, 2'ービピリジル (5. 3g、33. 9 mmol)を脱水したテトラヒドロフラン720mLに溶解した後、窒素でバブリングし て系内を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液を60℃まで昇温し、60℃で ビス (1, 5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) $\{Ni(COD)_2\}$ (9.3g,33.9mmol)加え、攪拌しながら3時間反応させた。反応後、この反応液を室温(約25℃) まで冷却し、25%アンモニア水45mL/メタノール700mL/イオン交 換水700mL混合溶液中に滴下して攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾 燥し、その後、トルエン540mLに溶解させてからろ過を行い、ろ液をアルミナカラム を通して精製し、トルエン層を、5.2%塩酸水約500mLで3時間、4%アンモニア 水約500mLで2時間、さらにイオン交換水約500mLで洗浄した。有機層にメタノ ール約100mLを滴下して1時間攪拌し、上澄み液をデカンテーションで除去した。得 られた沈殿物をトルエン300mLに溶解して、メタノール約600mLに滴下して1時 間攪拌し、ろ過して2時間減圧乾燥した。収量は3.6gであった。この重合体を高分子 化合物 2 と呼ぶ。ポリスチレン換算の数平均分子量および重量平均分子量は、それぞれM n = 2. 1×10^4 , Mw = 4. 5×10^5 σ σ

[0242]

実施例 4

化合物H (17.8g、29.7mmol)、N、N'ービス (4-ブロモフェニル) -N、N' -ビス (4-t-ブチルー2, 6-ジメチルフェニル)-1, 4-フェニレン ジアミン (2.4g、3.3mmol) および2,2'ービピリジル (13.9g、89 . 1 mm o 1) を脱水したテトラヒドロフラン1200mLに溶解した後、窒素でバブリ ングして系内を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液を60℃まで昇温し、6 0℃でビス (1、5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) {Ni (COD) 2} (24 . 5g、89.1mmol)加え、攪拌しながら3時間反応させた。反応後、この反応液 を室温(約25℃)まで冷却し、25%アンモニア水120mL/メタノール1200m L/イオン交換水1200mL混合溶液中に滴下して攪拌した後、析出した沈殿をろ過し て2時間減圧乾燥し、その後、トルエン1000mLに溶解させてからろ過を行い、ろ液 をアルミナカラムを通して精製し、トルエン層を、5.2%塩酸水約1000mLで3時 間、4%アンモニア水約1000mLで2時間、さらにイオン交換水約1000mLで洗 浄した。有機層にメタノール約400mLを滴下して1時間攪拌し、上澄み液をデカンテ ーションで除去した。得られた沈殿物をトルエン300mLに溶解して、メタノール約6 00mLに滴下して1時間攪拌し、ろ過して2時間減圧乾燥した。収量は10.5gであ った。この重合体を高分子化合物3と呼ぶ。ポリスチレン換算の数平均分子量および重量 平均分子量は、それぞれMn=1. 3×10^5 、Mw=5. 8×10^5 であった。

[0243]

実施例 5

化合物H(6.0g、10.0mmol)、N、N'ービス(4-ブロモフェニル)-N 、N' ービス (4-t-ブチルー2, 6-ジメチルフェニル) ー1, 4ーフェニレンジアミン (1.8g、2.5mmol) および2,2'ービピリジル (5.3g、33.9m 出証特2004-3120184 mol)を脱水したテトラヒドロフラン230mLに溶解した後、窒素でバブリングして 系内を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液を60℃まで昇温し、60℃でビ ス (1、5 - シクロオクタジエン) ニッケル (0) {Ni (COD) 2} (9.3g、3 3. 9 mm o 1) 加え、攪拌しながら3時間反応させた。反応後、この反応液を室温(約 25℃)まで冷却し、25%アンモニア水45mL/メタノール230mL/イオン交換 水230mL混合溶液中に滴下して攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥 し、その後、トルエン400mLに溶解させてからろ過を行い、ろ液をアルミナカラムを 通して精製し、トルエン層を、4%アンモニア水約400mLで2時間、さらにイオン交 換水約400mLで洗浄した。有機層にメタノール約100mLを滴下して1時間攪拌し 、上澄み液をデカンテーションで除去した。得られた沈殿物をトルエン200mLに溶解 して、メタノール約400mLに滴下して1時間攪拌し、ろ過して2時間減圧乾燥した。 収量は4.7gであった。この重合体を高分子化合物4と呼ぶ。ポリスチレン換算の数平 均分子量および重量平均分子量は、それぞれMn=1. 6×10^5 、Mw=3. 9×10^5 であった。

[0244]

実施例6

化合物H(5.2g、8.8mmol)、N、N', ービス(4-ブロモフェニル)ーN、N , ービス (4-tーブチルー2, 6-ジメチルフェニル) -1, 4-フェニレンジアミン (2.8g、3.8mmol) および2,2' ービピリジル (5.3g、33.9mmo 1)を脱水したテトラヒドロフラン230mLに溶解した後、窒素でバブリングして系内 を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液を60℃まで昇温し、60℃でビス(1、5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) {Ni (COD) 2} (9.3g、33. 9 mm o 1) 加え、攪拌しながら3時間反応させた。反応後、この反応液を室温(約25 °C) まで冷却し、25%アンモニア水45mL/メタノール230mL/イオン交換水2 30mL混合溶液中に滴下して攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、 その後、トルエン200mLに溶解させてからろ過を行い、ろ液をアルミナカラムを通し て精製し、トルエン層を、4%アンモニア水約200mLで2時間、さらにイオン交換水 約200mLで洗浄した。有機層にメタノール約200mLを滴下して1時間攪拌し、上 澄み液をデカンテーションで除去した。得られた沈殿物をトルエン200mLに溶解して 、メタノール約400mLに滴下して1時間攪拌し、ろ過して2時間減圧乾燥した。収量 は4.7gであった。この重合体を高分子化合物5と呼ぶ。ポリスチレン換算の数平均分 子量および重量平均分子量は、それぞれMn=7. 6×10^4 、Mw=3. 1×10^5 であ った。

[0245]

実施例 3 9

化合物HとN、N'ービス(4ープロモフェニル)ーN、N'ービス(4ーtーブチルー 2,6-ジメチルフェニル)-1,4-フェニレンジアミンをモル比で3:7で混合し、 実施例6と同様の手法で重合を行う。2,2'ービピリジルとビス(1、5ーシクロオク タジエン) ニッケル (0) {Ni (COD) 2} は、化合物HとN、N' ービス (4-ブロ モフェニル) -N、N' -ビス (4-t-ブチルー2, 6-ジメチルフェニル) <math>-1, 4 ーフェニレンジアミンの合計に対して約2.5倍のモル量を加える。この方法で重合を行 えば、上記式(16)で示される繰り返し単位と上記式(20)で示される繰り返し単位 を含み、そのモル比が3:7となる高分子化合物が得られる。

[0246]

実施例7

化合物H(10.6g、17.6mmol)、 N, N'-ビス(4-ブロモフェニル) -N, N, -ビス (4-t-ブチルー2, 6-ジメチルフェニル) <math>-ベンジジン (0. 29g、0.36mmol) および2,2'ービピリジル (7.6g、48.6mmol)を脱水したテトラヒドロフラン1100mLに溶解した後、窒素でバブリングして系内 を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液を60℃まで昇温し、60℃でビス(

1、5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) {Ni (COD) 2} (13.4g、48 . 6 mm o 1) 加え、攪拌しながら3時間反応させた。反応後、この反応液を室温(約2 5℃) まで冷却し、25%アンモニア水65mL/メタノール1100mL/イオン交換 水1100mL混合溶液中に滴下して攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾 燥し、その後、トルエン550mLに溶解させてからろ過を行い、ろ液をアルミナカラム を通して精製し、トルエン層を、5.2%塩酸水約550mLで3時間、4%アンモニア 水約550mLで2時間、さらにイオン交換水約550mLで洗浄した。有機層をメタノ ール約550mLに滴下して30分攪拌し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させ た。得られた重合体の収量は6.3gであった。この重合体を高分子化合物6と呼ぶ。ポ リスチレン換算重量平均分子量は、4.2 x 105であり、数平均分子量は、6.6 x 1 0^4 であった。

[0247]

実施例8

化合物H(4.85g、8.1mmol)、N、N'ービス(4-ブロモフェニル)ーN、 N' ービス (4-t-ブチルー2, 6-ジメチルフェニル) ー1, 4ーフェニレンジアミン (0. 73g、0. 9mmol) および2, 2' ービピリジル (3. 80g、24. 3 mmol)を脱水したテトラヒドロフラン420mLに溶解した後、窒素でバブリングし て系内を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液を60℃まで昇温し、60℃で ビス (1、5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) {Ni(COD)2} (6.68g 、24.3mmol)加え、攪拌しながら3時間反応させた。反応後、この反応液を室温 (約25℃) まで冷却し、25%アンモニア水30mL/メタノール420mL/イオン 交換水420mL混合溶液中に滴下して攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧 乾燥し、その後、トルエン500mLに溶解させてからろ過を行い、ろ液をアルミナカラ ムを通して精製し、トルエン層を、5.2%塩酸水約500mLで3時間、4%アンモニ ア水約500mLで2時間、さらにイオン交換水約500mLで洗浄した。有機層をメタ ノール約1000mLに滴下して30分攪拌し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥 させた。収量は3.5gであった。この重合体を高分子化合物7と呼ぶ。ポリスチレン換 算の数平均分子量および重量平均分子量は、それぞれMn=3. 9×10^4 、Mw=3. 7×10^5 であった。

[0248]

実施例 9

化合物 H (1.0 g、1.7 mmol)、N、N, -ビス(4 -プロモフェニル) - N、N' ービス (4-t-ブチルー2,6-ジメチルフェニル) ーベンジジン (0.34g、0.42mmol) および2,2'ービピリジル(0.78g、5.0mmol)を 脱水したテトラヒドロフラン55mLに溶解した後、窒素でバブリングして系内を窒素置 換した。この溶液にビス(1、5ーシクロオクタジエン)ニッケル(0) $\{Ni(COD)\}$) 2} (1.4g、5.0mmol)加え、60℃まで昇温し、窒素雰囲気下において、 攪拌しながら3時間反応させた。反応後、この反応液を室温(約25℃)まで冷却し、2 5%アンモニア水5mL/メタノール50mL/イオン交換水50mL混合溶液中に滴下 して攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、その後、トルエン50mL に溶解させてからろ過を行い、ろ液をアルミナカラムを通して精製し、トルエン層を、5 . 2%塩酸水約50mLで3時間、4%アンモニア水約50mLで2時間、さらにイオン 交換水約50mLで洗浄した。有機層をメタノール約150mLに滴下して1時間攪拌し 、ろ過して2時間減圧乾燥した。収量は0.87gであった。この重合体を高分子化合物 8と呼ぶ。ポリスチレン換算の数平均分子量および重量平均分子量は、それぞれMn=3 . 8×10^4 , Mw = 1. 2×10^5 σ σ σ .

[0249]

実施例10

化合物 H (5.2g、8.8mmol)、N、N'ービス(4ーブロモフェニル)ーN、 . 8 mmo1) および2, 2' ービピリジル (5.3g、33.9 mmo1) を脱水した テトラヒドロフラン230mLに溶解した後、窒素でバブリングして系内を窒素置換した 。窒素雰囲気下において、この溶液を60℃まで昇温し、60℃でビス(1、5ーシクロ オクタジエン) ニッケル (0) {Ni (COD) 2} (9.3g、33.9mmol)加 え、攪拌しながら3時間反応させた。反応後、この反応液を室温(約25℃)まで冷却し 、25%アンモニア水45mL/メタノール230mL/イオン交換水230mL混合溶 液中に滴下して攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、その後、トルエ ン200mLに溶解させてからろ過を行い、ろ液をアルミナカラムを通して精製し、トル エン層を、5.2%塩酸水約200mLで3時間、4%アンモニア水約200mLで2時 間、さらにイオン交換水約200mLで洗浄した。有機層にメタノール約200mLを滴 下して1時間攪拌し、上澄み液をデカンテーションで除去した。得られた沈殿物をトルエ ン200mLに溶解して、メタノール約400mLに滴下して1時間攪拌し、ろ過して2 時間減圧乾燥した。収量は4.7gであった。この重合体を高分子化合物9と呼ぶ。ポリ スチレン換算の数平均分子量および重量平均分子量は、それぞれMn=8. 9×10^4 、 $Mw = 5.2 \times 10^{5}$ であった。

[0250]

実施例40

化合物HとN、N'ービス(4-ブロモフェニル)ーN、N'ービス(4ーtーブチルー2 , 6 ージメチルフェニル)ーベンジジンをモル比で5:5で混合し、実施例6と同様の手 法で重合を行う。2,2'ービピリジルとビス(1、5-シクロオクタジエン)ニッケル (0) {Ni(COD)2} は、化合物HとN、N'ービス(4-ブロモフェニル)-N、 N' -ビス (4-t-ブチルー2, 6-ジメチルフェニル) -ベンジジンの合計に対して 約2.5倍のモル量を加える。この方法で重合を行えば、上記式(16)で示される繰り 返し単位と上記式(17)で示される繰り返し単位を含み、そのモル比が5:5となる高 分子化合物が得られる。

[0251]

実施例 4 1

化合物HとN、N'ービス(4-ブロモフェニル)ーN、N'ービス(4ーtーブチルー 2, 6-ジメチルフェニル)ーベンジジンをモル比で3:7で混合し、実施例6と同様の手 法で重合を行う。2,2'ービピリジルとビス(1、5-シクロオクタジエン)ニッケル (0) {Ni(COD)2} は、化合物HとN、N'-ビス(4-ブロモフェニル)-N、 N' ービス (4-t-ブチルー2, 6-ジメチルフェニル) ーベンジジンの合計に対して約2.5倍のモル量を加える。この方法で重合を行えば、上記式(16)で示される繰り 返し単位と上記式(17)で示される繰り返し単位を含み、そのモル比が3:7となる高 分子化合物が得られる。

[0252]

実施例11

化合物 H 0.58 g と N、N'ービス (4- ブロモフェニル)ー N、N'ービス (4ーtーブチルー2,6-ジメチルフェニル)-1,4-フェニレンジアミン0.089g とTPA 0.053gと2,2'ービピリジル0.45gとを反応容器に仕込んだ後、 反応系内を窒素ガスで置換した。

TPA

これに、あらかじめアルゴンガスでバブリングして、脱気したテトラヒドロフラン(脱水 溶媒)40gを加えた。次に、この混合溶液に、ビス(1,5ーシクロオクタジエン)ニ ッケル (0) を 0. 8 g を 加え、室温で 1 0 分間攪拌した後、 6 0 ℃で 3 時間反応した。 なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。

反応後、この溶液を冷却した後、メタノール50m1/イオン交換水50m1混合溶液を そそぎ込み、約1時間攪拌した。次に、生成した沈殿を濾過し、回収した。この沈殿を乾 燥した後、トルエンに溶解した。この溶液を濾過し、不溶物を除去した後、この溶液をア ルミナを充填したカラムを通し、精製した。次に、このトルエン溶液を1規定塩酸で洗浄 した後、静置、分液、トルエン溶液を回収、このトルエン溶液を、約3%アンモニア水で 洗浄した後、静置、分液、トルエン溶液を回収、次に、このトルエン溶液をイオン交換水 で洗浄し、静置、分液、トルエン溶液を回収した。このトルエン溶液に、攪拌下、メタノ ールを加えることにより、再沈精製した。

次に、生成した沈殿を回収し、この沈殿を減圧乾燥して、重合体0.16gを得た。この 重合体を高分子化合物10と呼ぶ。得られた高分子化合物10のポリスチレン換算重量平 均分子量は、1.5 x 1 0^5 であり、数平均分子量は、2.9 x 10^4 であった。

[0253]

実施例12

化合物 H 0.50 g と N、N'ービス(4-ブロモフェニル)-N、N'ービス(4 - t - ブチル-2, 6 - ジメチルフェニル) - 1, 4 - フェニレンジアミン 0. 0 8 4 g とTPA 0.11gと2,2'ービピリジル0.45gとを反応容器に仕込んだ後、反 応系内を窒素ガスで置換した。

これに、あらかじめアルゴンガスでバブリングして、脱気したテトラヒドロフラン(脱水 溶媒) 40gを加えた。次に、この混合溶液に、ビス(1,5-シクロオクタジエン)ニ ッケル (0) を 0.8 g を 加え、室温で 10分間攪拌した後、60℃で3時間反応した。 なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。

反応後、この溶液を冷却した後、メタノール50m1/イオン交換水50m1混合溶液を そそぎ込み、約1時間攪拌した。次に、生成した沈殿を濾過し、回収した。この沈殿を乾 燥した後、トルエンに溶解した。この溶液を濾過し、不溶物を除去した後、この溶液をア ルミナを充填したカラムを通し、精製した。次に、このトルエン溶液を約3%アンモニア 水で洗浄した後、静置、分液、トルエン溶液を回収、次に、このトルエン溶液をイオン交 換水で洗浄し、静置、分液、トルエン溶液を回収した。このトルエン溶液に、攪拌下、メ タノールを加えることにより、再沈精製した。

次に、生成した沈殿を回収し、この沈殿を減圧乾燥して、重合体0.16gを得た。この 重合体を高分子化合物11と呼ぶ。得られた高分子化合物11のポリスチレン換算重量平 均分子量は、1.3 x 1 0^5 であり、数平均分子量は、2.1 x 10^4 であった。

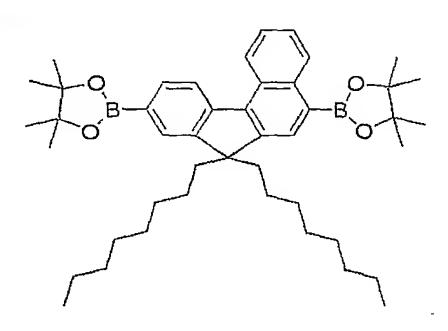
[0254]

合成例4

Ť

100mL4口丸底フラスコをアルゴンガス置換後、化合物 H (3.2g、5.3mmo1) 、ビスピナコーラートジボロン (3.8g、14.8mmol)、PdCl2 (dppf) (0.39g、0.45mmol)、 ビス (ジフェニルホスフィノフェロセン (0. 27g、0.45mmol)、酢酸カリウム(3.1g、32mmol)を仕込み、脱水 ジオキサン45m1を加えた。アルゴン雰囲気下、100℃まで昇温し、36時間反応させ た。放冷後、セライト2gをプレコートで濾過を実施し、濃縮したところ黒色液体を取得 した。ヘキサン50gに溶解させて活性炭で着色成分を除去し37gの淡黄色液体を取得し た (濾過時、ラジオライト5gプレコート実施)。

酢酸エチル6g、脱水メタノール12g、ヘキサン2gを加え、ドライアイスーメタノー ル浴に浸して、化合物 I 2. 1 g の無色結晶を取得した。



化合物 I

[0255]

実施例13

不活性雰囲気下にて化合物 I (0.10g、0.14 mmol)、N、N'ービス (4-ブロモフェニル)ーN、N'ービス (4ーtーブチルー2,6ージメチルフェニル)ー1,4ーフェニレンジアミン (0.10g、0.14 mmol)をトルエン2.9 mlに溶解させ、これにテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0.003g、0.0028 mmol)を加え、室温にて10分間攪拌した。つづいてテトラエチルアンモニウムハイドロオキサイド20%水溶液を0.5 mlを加え昇温し、2時間加熱還流した。そしてフェニルボロン酸(0.017g、0.014 mmol)を加え1時間加熱還流した。加熱完了後室温まで冷却し、反応マスをメタノール30 mlに滴下し、析出した沈殿を濾別した。得られた沈殿は、メタノールで洗浄し、減圧乾燥を行い、固形物を得た。得られた固形物をトルエン3 mlに溶解させ、アルミナカラムで通液後、メタノール20 mlに滴下して1時間攪拌し、析出した沈殿を濾別した。得られた沈殿は、メタノール20 mlに滴下して1時間攪拌し、析出した沈殿を濾別した。得られた沈殿は、メタノールで洗浄し、減圧乾燥を行った。収量は0.060gであった。この重合体を高分子化合物12と呼ぶ。ポリスチレン換算の数平均分子量および重量平均分子量は、それぞれMn=9.8×10³、Mw=2.4×10⁴であった。

【表1】

			ガラス 転移温度 (°C)	蛍光ピーク 波長 (nm)	蛍光強度 (相対値)
実施例2	高分子化合物	1	134	456	6.1
実施例3	高分子化合物	2	137	462	5.7
実施例4	高分子化合物	3	159	462	4.8
実施例 5	高分子化合物	4	175		
実施例 6	高分子化合物	5	207	472	2.9
実施例7	高分子化合物	6	132	457	7.2
実施例8	高分子化合物	7	161		
実施例 9	高分子化合物	8	193	456	5.3
実施例10	高分子化合物	9	213	458	4.0
実施例11	高分子化合物	1 0	167	467	4.1
実施例12	高分子化合物	1 1	175	467	4.9
実施例13	高分子化合物	1 2	210	469	1.6

[0256]

合成例 5 <化合物 Mの合成> (化合物] の合成)

化合物]

アルゴン雰囲気下、500mLフラスコにマグネシウム小片(9.99g、0.411mol)とテトラヒド ロフラン (脱水溶媒) (30mL) を仕込んだ。1,2-ジブロモエタン (5.94g、0.032mol)を滴下し、発泡を確認した後に、テトラヒドロフラン(脱水溶媒) (484ml) に溶解し た2-ブロモ-6-メトキシナフタレン (75g、0.316mol) を40分かけて滴下した後に、30分還 流させ、Grignard溶液を調製した。

アルゴン雰囲気下、500mLフラスコに、トリメトキシボラン(49.3g、0.476mol)、テトラ ヒドロフラン (脱水溶媒) (160mL) を仕込み、-78℃に冷却した中へ、上記Grignard溶液 を1.25時間かけて滴下した。室温まで2時間かけて昇温した後、イオン交換水75mLを加え 、約30分撹拌した。減圧濃縮により溶媒を留去した後に、イオン交換水(200mL)、1NH Cl (500mL)、ジクロロメタン (80mL) を加え、30分激しく撹拌した。固体をろ取し、ジ クロロメタン (100mL) で洗浄し、減圧乾燥することにより化合物 J (53.0g、収率75%) を白色固体として得た。

 1 H-NMR (300MHz/CDCl₃):

 δ 3.35(s,2H), 3.95(s,3H), 7.15(d,1H), 7.22(s,1H), 7.63-7.82(m,3H), 8.10-8.25(b) d, 1H)

[0257]

(化合物 K の合成)

化合物K

アルゴン雰囲気下、1Lフラスコに、2-ブロモ-5-メトキシ安息香酸メチル(56.0g、0.229mol)、化合物 J (51.0g, 0.240mol)、予めアルゴンガスをバブリングすることにより脱 気したトルエン (268mL) を仕込み、アルゴンガスでバブリングしながら60℃まで昇温し た。別途、イオン交換水 (273mL) に溶解した炭酸カリウム (82.0g,0.593mol) の水溶液 をアルゴンガスで30分バブリングして脱気した後に、上記液中へ仕込んだ。マスが65℃に なった時点でテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(2.743g,0.0024mol) を仕込み、昇温して3時間還流させた。2-ブロモ-5-メトキシ安息香酸メチル(2.17g,0.09 Omo1) を追加仕込みし、3時間還流させた。分液し、水層よりトルエンで抽出した後、油 層を合一した。シリカゲルショートカラムに通液したのち、濃縮晶析を行い、ろ過、乾燥 することにより、化合物 K (71.9g, 収率93%) を白色固体として得た。

 1 H-NMR (300MHz/CDC1₃) : δ 3.59(s,3H), 3.86(s,3H), 3.94(s,3H), 7.07-7.19(m,2H), 7.34-7.42(m,2H), 7.69-7 .76(m, 2H)

 $LC/MS(APPI(+)): M^+ 322$

[0258]

(化合物 Lの合成)

化合物L

アルゴン雰囲気下、1Lフラスコに、化合物 K (40.00g, 0.122mol) をテトラヒドロフラ ン (脱水溶媒) (220g) に攪拌溶解し、氷浴にて冷却した。そこに、 n ーオクチルマグネ シウムブロミド (22wt%、テトラヒドロフラン溶液、482g、0.487mol) を滴下し、室温に て終夜撹拌した。反応後、1N塩酸水(820mL)を加え攪拌した後、分液した。水層よりトル エンで抽出した後、有機層を合一した。得られた有機層を水洗した後、無水硫酸ナトリウ ムで乾燥し、濃縮することにより溶媒を留去し、アルキル化粗生成物を油状物(64.5g) として得た。

アルゴン雰囲気下、500mLフラスコに、上記アルキル化粗生成物 (30g) をテトラヒドロ フラン(脱水溶媒) (242g) に攪拌溶解し、氷浴にて冷却した。そこに、水素化ホウ素ナ トリウム (1.269g, 0.0335mol) を仕込み、氷浴を外し、室温にて15.5時間保温した。水素 化ホウ素ナトリウム (1.3g, 0.0344mol) を追加し、40℃にて7時間保温した後に、エタノ ール (30g) を追加し、50℃に昇温して7.5時間保温した。1N塩酸水(400g)に反応マスを注 加して攪拌後、クロロホルムで有機層を抽出した。得られた有機層を水洗した後、無水硫 酸ナトリウムで乾燥し、濃縮することにより溶媒を留去し、還元粗生成物を油状物(28.8 g) として得た。

アルゴン雰囲気下、500mLフラスコに三フッ化ホウ素・ジエチルエーテル錯体(98.2g,0. 692mol)を塩化メチレン (63.9g) に攪拌混合した中へ上記還元組成生物 (15.29g) を演歌 メチレン(63.9g)に希釈した後に、室温にて14分かけて滴下した後、室温にて3時間保温 した。反応後、水(250mL)に反応マスを注加して攪拌し、クロロホルムで有機層を抽出 した。得られた有機層を水洗した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濃縮することにより 溶媒を留去し、環化粗生成物を油状物(14.8g)として得た。

アルゴン雰囲気下、200mLフラスコに、水酸化ナトリウム (30.8g, 0.769mol) を水 (32g) で攪拌溶解し、室温に冷却した後に、上記環化粗生成物(14.78g)をトルエン(37g) で希釈したものを室温化で仕込んだ。続いて、テトラーnーブチルアンモニウムブロミド (2.48g,0.00769mo1) を仕込み、50℃まで昇温した後、1ーブロモオクタン(9.90g,0.05 13mol) を6分かけて滴下し、50℃で5時間、60℃で7時間保温した。反応後、水(200mL) に反応マスを注加し、攪拌した後、分液した。水層からトルエンにて抽出し、油層を合一 した。得られた油層を水洗した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濃縮することにより溶 媒を留去し、油状物を得た(12.6g)。得られた油状物をヘキサン/トルエン= 4/1の 混合溶媒を展開溶媒とするシリカゲルカラムで精製することにより化合物 L (7.59g、収 率50%)を油状物として得た。

 1 H-NMR (300MHz/CDC1₃):

 $\delta \ 0.30 - 0.50 \, (\text{m, 4H}) \,, \ 0.72 - 0.83 \, (\text{t, 6H}) \,, \ 0.83 - 1.20 \, (\text{m, 20H}) \,, \ 2.05 - 2.20 \, (\text{m, 2H}) \,, \ 2.35 - 1.20 \, (\text{m, 2H}) \,,$ 2.50(m, 2H), 3.90(s, 3H), 3.94(s, 3H), 6.87-6.95(m, 2H), 7.19-7.23(m, 2H), 7.61(d, 1H)7.70-7.80 (m, 2H), 8.06 (d, 1H)

[0259]

(化合物Mの合成)

化合物M

アルゴン雰囲気下、200mLフラスコに化合物 L (4.07g, 0.0080mol)、塩化メチレン(36 .3g)を仕込み、攪拌希釈した後、-78℃に冷却した中へ、トリメトキシボランの塩化メ チレン溶液 (1M、20.1mL、0.0201mol) を1時間かけて滴下した。室温まで1時間かけて昇 温した後、室温にて4時間保温した。氷冷水(15g)に反応マスを注加し、油層が清澄にな るまで撹拌した。分液し、水層から塩化メチレンで抽出した後、油層を合一した。得られ た油層を水洗し、濃縮することにより、化合物M(4.16g,収率96%)を白黄色固体として 得た。

 1 H-NMR (300MHz/CDC1₃) :

 $\delta \; 0.\; 30-0.\; 50 \, (\text{m, 4H}) \; , \; \; 0.\; 78 \, (\text{t, 6H, J=6.9Hz}) \; , \; \; 0.\; 85-1.\; 21 \, (\text{m, 20H}) \; , \; \; 2.\; 22 \, (\text{dt, 4H, J=11.4,} \; \; 5. \; \text{most of the second sec$ 4Hz), 4.83(s,1H), 4.98(s,1H), 6.83(d,1H), 6.90(s,1H), 7.15(d,1H), 7.25(s,1H), 7. 57(d, 1H), 7.60(d, 1H), 7.63(d, 1H), 8.06(d, 1H)

 $LC/MS(APPI(+)): (M+H)^{+} 473$

[0260]

実施例14 (化合物Nの合成)

$$F_3CO_2SO$$
 $n-C_8H_{17}$ $n-C_8H_{17}$

化合物N

アルゴン雰囲気下、200mLフラスコに、化合物M(4.00g,0.0082mol)、トリエチルアミ ン (2.49g, 0.0246mol)、塩化メチレン (55.8g) を仕込み、攪拌溶解した後、-78℃に冷 却した中へ、トリフルオロメタンスルホン酸無水物(5.09g,0.0181mol)を30分かけて滴 下した。室温まで1.5時間かけて昇温した後、室温にて5時間保温した。氷冷した1N塩酸水 (80g) に反応マスを注加し、n-ヘキサンにて抽出した。得られた油層を、飽和炭酸水素 ナトリウム水溶液で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。得られた油層をシリカ ゲルショートカラムに通液し、更にトルエンを同シリカゲルショートカラムに通液し、合 一した後、濃縮乾固した。得られた固体をn-ヘキサンにて再結晶し、ろ取、乾燥すること により、化合物 N (5.13g, 収率85%) を白色固体として得た。

 1 H-NMR (300MHz/CDC1₃): $\delta \; 0.\; 28-0.\; 43 \, (\text{m, 4H}) \; , \; \; 0.\; 77 \, (\text{t, 6H, J=7.1Hz}) \; , \; \; 0.\; 83-1.\; 26 \, (\text{m, 20H}) \; , \; \; 2.\; 17-2.\; 30 \, (\text{m, 2H}) \; , \; \; 2.\; 35 \, (\text{m, 2H})$ -2.49(m, 2H), 7.33(d, 1H), 7.35(s, 1H), 7.48(d, 1H, J=9.3Hz), 7.81-7.95(m, 4H), 8.26(d, 2H), 1H, J=9.3Hz)

LC/MS(APPI(+)): M+ 736

[0261]

実施例15 (化合物〇の合成)

化合物O

アルゴン雰囲気下、200mLフラスコに、化合物 N (3.88g, 0.0053mol) 、ピナコールジボラン (2.94g, 0.0116mol) 、ジクロロビスジフェニルホスフィノフェロセンパラジウム (II) (0.258g, 0.00027mol) 、ジフェニルホスフィノフェロセン (0.175g, 0.00027mol) 、酢酸カリウム (3.10g, 0.0316mol) を仕込み、アルゴンガスでフラスコ内を置換した後に、1,4-ジオキサン (脱水溶媒) (46.4g)を仕込み、100 でまで昇温し、100 でにて4時間保温した。室温まで放冷した後、n-ヘキサン (100mL) で希釈し、ラジオライトをプレコートしたろ過器で不溶物をろ別した。濃縮し、n-ヘキサンに溶媒置換した後、シリカゲルショートカラムに通液した。濃縮し、n-ヘキサンに溶媒置換した後に、活性炭(5g)を加え、30分攪拌した後に、ラジオライトをプレコートしたろ過器で不溶物をろ別し、無色透明の液体を得た。濃縮乾固することにより、白色固体を得た。酢酸エチル (5.1g) を加え、60 に加温することにより溶解させた後、室温まで放冷し、メタノール (40g) を攪拌下滴下することにより晶析し、ろ取、乾燥することにより化合物 O (2.04g、収率55%)を白色固体として得た。

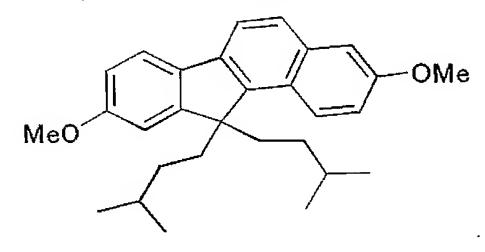
 1 H-NMR (300MHz/CDC1₃):

 δ 0.22-0.43(m,4H), 0.77(t,3H), 0.83-1.22(m,20H), 1.40(s,24H), 2.20-2.40(m,2H), 2.40-2.55(m,2H), 7.76-7.95(m,6H), 8.19(d,1H), 8.47(s,1H) LC/MS(APPI(+)): M+ 692

[0262]

合成例 6

(化合物 P の合成)



化合物P

化合物Lの合成と同様の方法で、n-オクチルマグネシウムブロミドの代わりに、マグネシウムおよびイソアミルブロミドから通常の方法により調製した、イソアミルマグネシウムブロミドを用いて、化合物 J(30.0g,0.0919mol)より合成し、化合物 P(18.2g,収率47%)を白色固体として得た。

1 H-NMR (300MHz/CDCl₃):

 $\delta \ 0.20-0.40 (\mathrm{dt}, 4\mathrm{H}), \ 0.57 (\mathrm{d}, 6\mathrm{H}, \mathrm{J=7Hz}), \ 0.59 (\mathrm{d}, 6\mathrm{H}, \mathrm{J=7Hz}), \ 1.14-1.27 (\mathrm{qq}, 2\mathrm{H}), \ 2.10 \\ -2.20 (\mathrm{dt}, 2\mathrm{H}), \ 2.37-2.48 (\mathrm{dt}, 2\mathrm{H}), \ 3.88 (\mathrm{s}, 3\mathrm{H}), \ 3.93 (\mathrm{s}, 3\mathrm{H}), \ 6.89-6.92 (\mathrm{d}, 1\mathrm{H}), \ 6.95 (\mathrm{s}, 1\mathrm{H}), \ 7.15-7.24 (\mathrm{m}, 2\mathrm{H}), \ 7.60-7.63 (\mathrm{d}, 1\mathrm{H}), \ 7.71-7.78 (\mathrm{m}, 2\mathrm{H}), \ 8.05-8.08 (\mathrm{d}, 1\mathrm{H}) \\ \mathrm{LC/MS}(\mathrm{APPI}(+)) : (\mathrm{M}+\mathrm{H})^+ \ 417$

[0263]

(化合物 Qの合成)

化合物Q

化合物Mと同様の方法により、化合物P (18.0g, 0.0430mol) より合成し、化合物Q (1 5.2g,収率90%) を白色固体として得た。

 1 H-NMR (300MHz/THF-d₈):

 $\delta\ 0.\ 20-0.\ 52\ (m,\ 4H)\ ,\ \ 0.\ 53-0.\ 78\ (m,\ 12H)\ ,\ 1.\ 10-1.\ 35\ (m,\ 2H)\ ,\ \ 2.\ 10-2.\ 23\ (m,\ 2H)\ ,\ \ 2.\ 40-2.\ 6$ 0(m, 2H), 6.73(d, 1H), 6.85(s, 1H), 7.05-7.20(m, 2H), 7.50-7.72(m, 3H), 8.08(d, 1H), 8.08(d, 1H).17(s, 1H), 8.43(s, 1H)

 $LC/MS(APPI(+)): (M+H)^{+} 389$

[0264]

実施例16 (化合物Rの合成)

化合物R

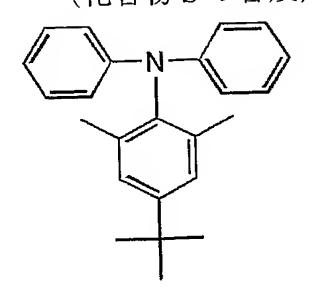
化合物Nと同様の方法により、化合物Q(15g,0.0380mo1)より合成し、化合物R(21. 6g,収率87%)を白色固体として得た。

 1 H-NMR (300MHz/CDC1₃):

 δ 0.19-0.27(m,4H), 0.51-0.63(m,12H), 1.16-1.30(m,2H), 2.20-2.31(m,2H), 2.40-2. 51(m, 2H), 7.25-7.37(m, 2H), 7.47-7.52(d, 1H), 7.82-7.99(m, 4H), 8.24-8.28(d, 1H) $LC/MS(APPI(+)): M^+ 652$

[0265]

合成例7 <化合物 T の合成> (化合物Sの合成)



化合物S

不活性雰囲気下で、300m1の3つ口フラスコに脱気した脱水トルエン100mlを 入れ、ジフェニルアミン16.9g、1ーブロモー4ーtーブチルー2、6ージメチルベ ンゼン 25.3gを加えた。

続いてトリス (ジベンジリデンアセトン) ジパラジウム 0.92g、tーブトキシナト リウム12.0g、を加えた後、トリ(tーブチル)ホスフィン 1.01gを加えた。

出証特2004-3120184

その後、100℃で7時間反応させた。

反応液を飽和食塩水にあけ、トルエン100mlで抽出した。トルエン層を希塩酸、飽 和食塩水で洗浄後、溶媒を留去して黒色の固体を得た。これをシリカゲルカラムクロマト グラフィー (ヘキサン/クロロホルム 9/1) で分離精製し、白色の固体30.1gを 得た。

 $^{1}H-NMR$ (300MHz/CDCl₃) : δ (ppm) = 1.3 [s, 9H], 2.0 $(s, 6H), 6.8 \sim 7.3 (m, 10H)$

[0266]

(化合物Tの合成)

化合物T

不活性雰囲気下で、1000mlの3つ口フラスコに脱水N, N-ジメチルホルムアミド 333m1、ヘキサン166m1を入れ、上記のN, NージフェニルーNー(4-tーブ チルー2,6-ジメチルフェニル)-アミン29.7gを溶解した後、遮光および氷浴下 でN-ブロモスクシンイミド33.6g/N, N-ジメチルホルムアミド溶液100m1 を滴下し、一昼夜反応させた。

反応液を200m1まで減圧濃縮し、水1000m1に加え、析出した沈殿をろ過した。 さらに得られた結晶をDMF/エタノールで2回再結晶して白色固体23.4gを得た。 $^{1}H-NMR$ (3 0 0 MHz/CDC 1 3):

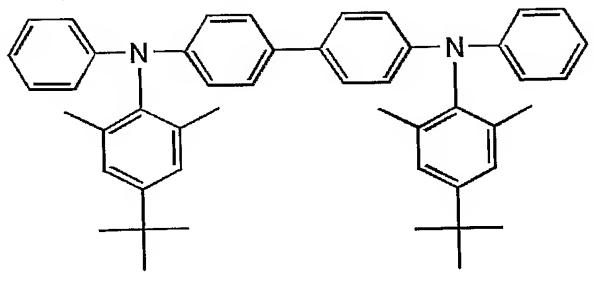
 $\delta(ppm) = 1.3 (s, 9H), 2.0 (s, 6H), 6.8 (d, 2H), 7.$ 1 (s, 2H), 7.3 (d, 2H),

 $MS (APCI (+)) : M^{+} 488$

[0267]

合成例8 [化合物 V の合成]

(化合物 Uの合成)



化合物U

不活性雰囲気下で、300mlの3つ口フラスコに脱気した脱水トルエン1660ml を入れ、N, N, N, -ジフェニルベンジジン275. 0g、1-ブロモー4-t-ブチルー 2,6-ジメチルベンゼン449.0gを加えた。

続いて トリス (ジベンジリデンアセトン) ジパラジウム 7.48g、tーブトキシナ トリウム196.4g、を加えた後、トリ (tーブチル)ホスフィン5.0gを加えた。 その後、105℃で7時間反応させた。

反応液にトルエン2000m1を加え、セライト濾過し、濾液を水1000m1で3回 出証特2004-3120184 洗浄した後、700m1まで濃縮した。これにトルエン/メタノール(1:1)溶液16 00m1を加え、析出した結晶を濾過し、メタノールで洗浄した。白色の固体479.4 gを得た。

MS (APCI (+)) : (M+H) + 657.4

[0268]

(化合物 V の合成)

化合物V

不活性雰囲気下で、クロロホルム4730gに、上記N, N, ージフェニルーN, N, ー ビス (4-t-ブチルー2,6-ジメチルフェニル)ーベンジジン472.8gを溶解し た後、遮光および氷浴下でN-ブロモスクシンイミド281.8gを12分割で1時間か けて仕込み、3時間反応させた。

クロロホルム1439m1を反応液に加え、濾過し、濾液のクロロホルム溶液を5%チオ 硫酸ナトリウム2159m1で洗浄し、トルエンを溶媒留去して白色結晶を得た。得られ た白色結晶をトルエン/エタノールで再結晶し、白色結晶678.7gを得た。

MS (APCI (+)) : (M+H) + 815.2

[0269]

実施例17 (高分子化合物13の合成)

化合物 H 0.9gと2,2'ービピリジル0.50gとを反応容器に仕込んだ後、反 応系内を窒素ガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガスでバブリングして、脱気 したテトラヒドロフラン (脱水溶媒) 60gを加えた。次に、この混合溶液に、ビス (1 , 5 ーシクロオクタジエン)ニッケル(0)を0.92gを加え、室温で10分間攪拌し た後、60℃で3時間反応した。なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。

反応後、この溶液を冷却した後、25%アンモニア水10m1/メタノール150m1/ イオン交換水150m1混合溶液をそそぎ込み、約1時間攪拌した。次に、生成した沈殿 を濾過し、回収した。この沈殿を乾燥した後、トルエンに溶解した。この溶液を濾過し、 不溶物を除去した後、この溶液をアルミナを充填したカラムを通し、精製した。次に、こ のトルエン溶液を1規定塩酸で洗浄した後、静置、分液、トルエン溶液を回収、このトル エン溶液を、約3%アンモニア水で洗浄した後、静置、分液、トルエン溶液を回収、次に 、このトルエン溶液をイオン交換水で洗浄し、静置、分液、トルエン溶液を回収した。こ のトルエン溶液に、攪拌下、メタノールを加えることにより、再沈精製した。

次に、生成した沈殿を回収し、この沈殿を減圧乾燥して、重合体0.08gを得た。この 重合体を高分子化合物13と呼ぶ。得られた高分子化合物13のポリスチレン換算重量平 均分子量は、2. 4×10^5 であり、数平均分子量は、7. 3×10^4 であった。

[0270]

実施例18 (高分子化合物14の合成)

化合物 H 0.58 g E N' ージフェニルー N' ービス (4 t ブチルー 2 , 6-ジメチルフェニル) -1, 4-フェニレンジアミン 0.089gとTPA 0.053gと2,2'一ビピリジル0.45gとを反応容器に仕込んだ後、反応系内を窒素 ガスで置換した。

TPA

これに、あらかじめアルゴンガスでバブリングして、脱気したテトラヒドロフラン(脱水 溶媒) 40gを加えた。次に、この混合溶液に、ビス(1,5ーシクロオクタジエン)ニ ッケル (0) を 0.8 g を 加え、室温で 1 0 分間攪拌した後、 6 0 ℃で 3 時間反応した。 なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。

反応後、この溶液を冷却した後、メタノール50m1/イオン交換水50m1混合溶液を そそぎ込み、約1時間攪拌した。次に、生成した沈殿を濾過し、回収した。この沈殿を乾 燥した後、トルエンに溶解した。この溶液を濾過し、不溶物を除去した後、この溶液をア ルミナを充填したカラムを通し、精製した。次に、このトルエン溶液を1規定塩酸で洗浄 した後、静置、分液、トルエン溶液を回収、このトルエン溶液を、約3%アンモニア水で 洗浄した後、静置、分液、トルエン溶液を回収、次に、このトルエン溶液をイオン交換水 で洗浄し、静置、分液、トルエン溶液を回収した。このトルエン溶液に、攪拌下、メタノ ールを加えることにより、再沈精製した。

次に、生成した沈殿を回収し、この沈殿を減圧乾燥して、重合体 0.16 gを得た。この 重合体を高分子化合物14と呼ぶ。得られた高分子化合物14のポリスチレン換算重量平 均分子量は、1.5 x 1 0^5 であり、数平均分子量は、2.9 x 10^4 であった。

[0271]

実施例19 (高分子化合物15の合成)

化合物N1250mg、化合物H1107mg、2,2'ービピリジル 1590mg を脱水したテトラヒドロフラン102mLに溶解した後、窒素雰囲気下において、この溶 液に、ビス (1、5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) {Ni (COD) 2} 28 00mg加え、60℃まで昇温し、3時間反応させた。反応後、この反応液を室温まで冷 却し、25%アンモニア水12ml/メタノール102ml/イオン交換水102ml混 合溶液中に滴下して30分攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トル エン102mlに溶解させた。溶解後、ラヂオライト0.41gを加えて30分攪拌し、 不溶解物を濾過した。得られた濾液をアルミナカラム(アルミナ量10g)を通して精製 を行い、回収したトルエン溶液に5.2%塩酸200mLを加えて3時間攪拌した。攪拌後 、水層を除去したのち、有機層に2.9%アンモニア水200mLを加えて2時間攪拌し 、水層を除去した。さらに有機層に水200mLを加えて1時間攪拌し、水層を除去した 。その後、有機層にメタノール100mLを滴下して30分攪拌し、析出した沈殿をろ過 して2時間減圧乾燥した。

得られた重合体の収量は985mgであった。この重合体を高分子化合物15と呼ぶ。得 られた高分子化合物 15のポリスチレン換算重量平均分子量は、2.5 x 10 5 であり、 数平均分子量は、 9.6×10^4 であった。

[0272]

(高分子化合物16の合成)

不活性雰囲気下にて2,7ージブロモー9,9ージオクチルフルオレン(287mg、 0.523mmol)、2,7-(9,9-ジオクチル)フルオレンジボロン酸エチレン グリコール環状エステル (305mg、0.575mmo1)、アリコート336(15m g)をトルエン(4.3 g)に溶解させ、これに炭酸カリウム(2 3 1 m g、1.67 m m o 1)を約1gの水溶液とし加えた。さらにテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウ ム(0.39mg、0.00034mmol)を加え、20時間加熱還流した。続いてブロ 得られた高分子化合物 1 6 のポリスチレン換算の分子量は、Mn=1. 2×10^3 、Mw=3. 2×10^3 であった。

[0273]

<u>5</u>

比較例2 (高分子化合物17の合成)

2, 7-ジプロモー9, 9-ジオクチルフルオレン 307mg、N, N'-ビス(4-プロモフェニル)-N, N'-ビス(4-t-ブチルー2, 6-ジメチルフェニル)-1, 4-フェニレンジアミン 52mg、TPA 32mg、2, 2'-ビピリジル 250mgを脱水したテトラヒドロフラン20mLに溶解した後、窒素雰囲気下において、この溶液に、ビス(1、5-シクロオクタジエン)ニッケル(0) $\{Ni$ (COD) $2\}$

440mg加え、60℃まで昇温し、3時間反応させた。反応後、この反応液を室温まで冷却し、25%アンモニア水10ml/メタノール120ml/イオン交換水50ml混合溶液中に滴下して30分攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン30mlに溶解させた。1N塩酸30mLを加えて3時間攪拌した後、水層を除去した。次に有機層に4%アンモニア水30mLを加えて3時間攪拌した後に水層を除去した。つづいて有機層をメタノール150mLに滴下して30分攪拌し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン90mLに溶解させた。その後、アルミナカラム(アルミナ量10g)を通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール200mLに滴下して30分攪拌し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた。得られた重合体の収量は170mgであった。この重合体を高分子化合物17と呼ぶ。

得られた高分子化合物 1 7 のポリスチレン換算の数平均分子量は、Mn=3. 2×10^4 、重量平均分子量は、Mw=8. 3×10^4 であった。

[0274]

実施例20 (ガラス転移温度測定)

ガラス転移温度の測定は、DSC (DSC 2920、TA Instruments製) により行なった。サンプルを200℃で5分間保持した後、-50℃まで急冷して30分間保持した。30℃まで温度を上げた後、毎分5℃の昇温速度で300℃まで測定を行なった。

得られたガラス転移点を下表2に示す。本発明の高分子化合物13、15はガラス転移温度が高く、耐熱性に優れることがわかる。

[0275]

実施例21 (蛍光特性評価)

蛍光特性の評価は、サンプルの 0.8wt%トルエン溶液を調製し、石英上にスピンコートして高分子化合物の薄膜を形成することにより得た試料を、蛍光分光光度計(JOBINYVON-SPEX社製 Fluorolog)を用い、励起波長 350nmで測定することにより行った。薄膜での相対的な蛍光強度を得るために、水のラマン線の強度を標準に、波数プロットした蛍光スペクトルをスペクトル測定範囲で積分して、分光光度計(Varian社製 Cary5E)を用いて測定した、励起波長での吸光度で割り付けた値を求めた。下表 2 に得られた蛍光ピーク波長、および蛍光強度を示した。

【表2】

高分子化合物	ガラス転移温度	蛍光ピーク	蛍光強度
	(°C)	波長 (n m)	
高分子化合物13(実施例17)	1 2 9	450	8.3
高分子化合物 1 5 (実施例 1 9)	1 2 9	450	5.3
高分子化合物 1 6 (比較例 1)	7 3	4 2 8	3. 6
高分子化合物14(実施例18)	167	467	
高分子化合物17(比較例2)	98	4 4 6	

[0277]

5

実施例22 (高分子化合物18の合成)

化合物 H $18621 \,\mathrm{mg}$ 、化合物 V $10863 \,\mathrm{mg}$ 、2, 2'-ビピリジル $18741 \,\mathrm{mg}$ を反応容器に仕込んだ後、あらかじめアルゴンガスでバブリングした、脱水テトラヒドロフラン $3600 \,\mathrm{mLe}$ 加えた。窒素雰囲気下において $60 \,\mathrm{C}$ まで昇温し、この溶液にビス(1, 5-シクロオクタジエン)ニッケル(0)を $33006 \,\mathrm{mg}$ 加え、3時間反応した。なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。

反応後、この反応液を室温まで冷却し、25%アンモニア水約160m1/メタノール約2400m1/イオン交換水約2400m1混合溶液中に滴下して約1時間攪拌した。析出した沈殿を濾過し、回収した。この沈殿を3.5時間減圧乾燥し、トルエン約1500mLに溶解させた。溶解後、ラデオライト約230gを加えて30分攪拌し、不溶解物を濾過した。得られた濾液をアルミナカラム(アルミナ量290g)を通して精製を行い、回収したトルエン溶液に5.2%塩酸約2900mLを加えて3時間攪拌した後、静置、分液し、トルエン溶液を回収した。このトルエン溶液を、約4%アンモニア水やく2900mLに加えて2時間攪拌し、水層を除去した。さらに有機層に水約2900mLを加えて1時間攪拌し、水層を除去した。さらに有機層に水約2900mLを加えて1時間攪拌し、水層を除去した。このトルエン溶液を、攪拌下、メタノール3102mLに滴下して30分攪拌し、再沈精製した。

次に、生成した沈殿を回収し、この沈殿を減圧乾燥して、重合体 20080 m g を得た。この重合体を高分子化合物 18 と呼ぶ。得られた高分子化合物 18 のポリスチレン換算重量平均分子量は、 8.8×10^4 であり、数平均分子量は、 1.3×10^4 であった。

[0278]

実施例23 (高分子化合物19の合成)

化合物 H 5 2 4 9 m g、化合物 V 3 0 6 3 m g、2, 2'-ビピリジル 5 2 8 4 m g を反応容器に仕込んだ後、あらかじめアルゴンガスでバブリングした、脱水テトラヒドロフラン 2 2 6 mLを加えた。窒素雰囲気下において 6 0 $\mathbb C$ まで昇温し、この溶液にビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケル(0)を 9 3 0 5 m g 加え、3 時間反応した。なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。

反応後、この反応液を室温まで冷却し、25%アンモニア水45m1/メタノール226m1/イオン交換水226m1混合溶液中に滴下して約1時間攪拌した。析出した沈殿を濾過し、回収した。この沈殿を2時間減圧乾燥し、トルエン約420mLに溶解させた。溶解後、ラヂオライト66gを加えて30分攪拌し、不溶解物を濾過した。得られた濾液をアルミナカラム(アルミナ量83g)を通して精製を行い、回収したトルエン溶液に52%塩酸約820mLを加えて3時間攪拌した後、静置、分液し、トルエン溶液を回収した。このトルエン溶液を、約4%アンモニア水約820mLに加えて2時間攪拌し、水層を除去した。さらに有機層に水約820mLを加えて1時間攪拌し、水層を除去した。このトルエン溶液にメタノール約170m1を加えて室温で1時間撹拌後、生じた不溶物を除去し、溶媒を留去した。残った固体にトルエン約20m1を加えて溶解させ、メタノール約130m1に滴下して30分撹拌し、再沈精製した。次に、精製した沈殿を回収し

、この沈殿を真空乾燥することにより、重合体 350mg を得た。この重合体を高分子化合物 19 と呼ぶ。得られた高分子化合物 19 のポリスチレン換算重量平均分子量は、9 . 3×10^3 であり、数平均分子量は、6 . 4×10^3 であった。

[0279]

実施例24 (高分子化合物20の合成)

[0280]

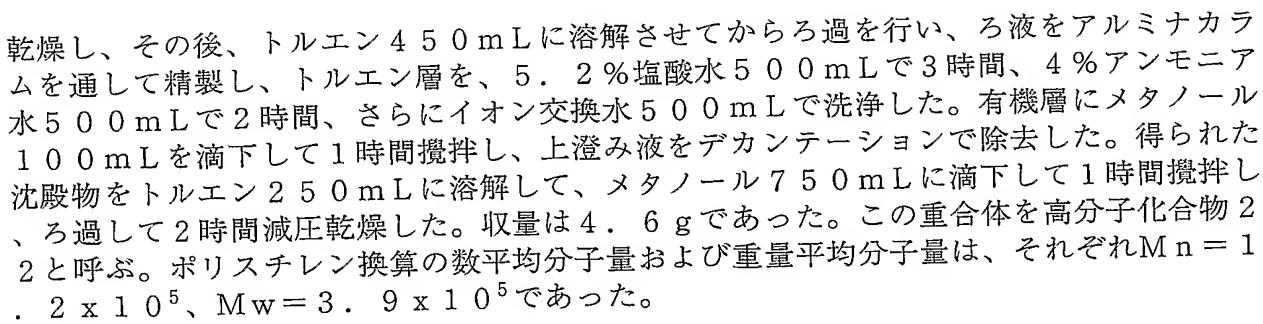
実施例25 (高分子化合物21の合成)

化合物H (7.35g、12.3mmol)、N、N'ービス(4-ブロモフェニル)ー N、N' -ビス (4-t - ブチルー 2 , 6 - ジメチルフェニル) -1 , 4 - フェニレンジ アミン (0. 19g、0. 25mmol) および2, 2'ービピリジル (5. 28g、3 3. 9 mm o 1) を脱水したテトラヒドロフラン450 m L に溶解した後、窒素でバブリ ングして系内を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液を60℃まで昇温し、6 0 ℃でビス (1、5 - シクロオクタジエン) ニッケル (0) {Ni(COD) 2} (9. 3g、33.9mmol)加え、攪拌しながら3時間反応させた。反応後、この反応液を 室温(約25℃)まで冷却し、25%アンモニア水90mL/メタノール450mL/イ オン交換水450mL混合溶液中に滴下して攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間 減圧乾燥し、その後、トルエン700mLに溶解させてからろ過を行い、ろ液をアルミナ カラムを通して精製し、トルエン層を、4%アンモニア水750mLで2時間、さらにイ オン交換水750mLで洗浄した。有機層にメタノール150mLを滴下して1時間攪拌 し、上澄み液をデカンテーションで除去した。得られた沈殿物をトルエン300mLに溶 解して、メタノール600mLに滴下して1時間攪拌し、ろ過して2時間減圧乾燥した。 4. 7gであった。この重合体を高分子化合物21と呼ぶ。ポリスチレン換 算の数平均分子量および重量平均分子量は、それぞれMn=7. $6x10^4$ 、Mw=6. 6×10^5 であった。

[0281]

実施例26 (高分子化合物22の合成)

化合物 H (4.5 g、7.5 mm o 1)、N、N'ービス(4-ブロモフェニル)ーN、N'ービス(4ーt・ブチルー2,6ージメチルフェニル)ー1,4ーフェニレンジアミン(0.6 2 g、0.83 mm o 1)および 2,2'ービピリジル(3.5 2 g、2 2.6 mm o 1)を脱水したテトラヒドロフラン 2 10 mLに溶解した後、窒素でバブリングして系内を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液を 60 $\mathbb C$ まで昇温し、60 $\mathbb C$ でビス(1、5ーシクロオクタジエン)ニッケル(0) $\{\text{Ni(COD)}_2\}$ (6.2 g、2 2.6 mm o 1)加え、攪拌しながら 3 時間反応させた。反応後、この反応液を室温(約25 $\mathbb C$)まで冷却し、25%アンモニア水 30 mL/メタノール 600 mL/イオン交換水 600 mL混合溶液中に滴下して攪拌した後、析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧



[0282]

実施例 2 7

(溶液の調整)

上記で得た高分子化合物20を67重量%、高分子化合物5を33重量%の比率でトル エンに溶解し、ポリマー濃度1.3重量%のトルエン溶液を作製した。

(EL素子の作製)

スパッタ法により150nmの厚みでITO膜を付けたガラス基板上に、ポリ(3,4)エチレンジオキシチオフェン/ポリスチレンスルホン酸(Bayer製、Baytro nP AI4083)の懸濁液を0.2μmメンブランフィルターで濾過した液を用いて 、スピンコートにより70nmの厚みで薄膜を形成し、ホットプレート上で200℃、1 0分間乾燥した。次に、上記で得たトルエン溶液を用いて、スピンコートにより1500 rpmの回転速度で成膜した。成膜後の膜厚は約70nmであった。さらに、これを減圧 下80℃で1時間乾燥した後、フッ化リチウムを約4mm蒸着し、陰極としてカルシウム を約5 nm、次いでアルミニウムを約80 nm蒸着してEL素子を作製した。なお真空度 が1×10⁻⁴Pa以下に到達した後に金属の蒸着を開始した。得られた素子に電圧を印加 することにより、この素子から475nmにピークを有するEL発光が得られた。EL発 光の強度は電流密度にほぼ比例していた。

(寿命測定)

上記で得られたEL素子を100mA/cm2の定電流で駆動し、輝度の時間変化を測 定したところ、該素子は初期輝度が2620cd/m2、輝度半減時間が41時間であっ た。これを輝度-寿命の加速係数が2乗であると仮定して、初期輝度400cd/m2の 値に換算したところ、半減寿命は1760時間となった。

[0283]

実施例 2 8

(溶液の調整)

上記で得た高分子化合物21を71重量%、高分子化合物5を29重量%の比率でトル エンに溶解し、ポリマー濃度1.3重量%のトルエン溶液を作製した。

(EL素子の作製)

上記で得たトルエン溶液を用い、実施例27と同様の方法によってEL素子を得た。得 られた素子に電圧を印加することにより、この素子から475nmにピークを有するEL 発光が得られた。EL発光の強度は電流密度にほぼ比例していた。

(寿命測定)

上記で得たEL素子を100mA/cm2の定電流で駆動し、輝度の時間変化を測定し たところ、該素子は初期輝度が2930cd/m2、輝度半減時間が30時間であった。 これを輝度-寿命の加速係数が2乗であると仮定して、初期輝度400cd/m2の値に 換算したところ、半減寿命は1610時間となった。

[0284]

実施例37

(溶液の調整)

上記で得た高分子化合物22をトルエンに溶解し、ポリマー濃度1.3重量%のトルエ ン溶液を作製した。

(EL素子の作製)

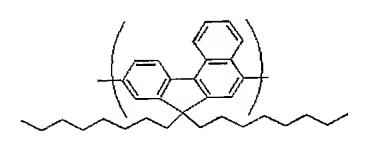
上記で得たトルエン溶液を用い、実施例27と同様の方法によってEL素子を得た。得 られた素子に電圧を印加することにより、この素子から475nmにピークを有するEL 発光が得られた。EL発光の強度は電流密度にほぼ比例していた。

(寿命測定)

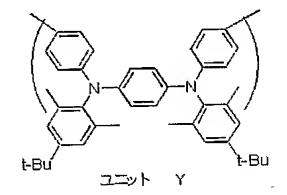
上記で得られたEL素子を100mA/cm2の定電流で駆動し、輝度の時間変化を測 定したところ、該素子は初期輝度が2750cd/m2、輝度半減時間が19時間であっ た。これを輝度-寿命の加速係数が2乗であると仮定して、初期輝度400cd/m2の 値に換算したところ、半減寿命は900時間となった。

【表3】

ポリマー1 <u>ポリマー2</u>		X:Y			(<u>h)</u>
実施例27 高分子化合物20高分子化合	<u>混合比</u> 物5 67:33	90:10	2620	41	1752
実施例27 高分子化合物21 高分子化合 実施例37 高分子化合物22	物5 71:29	90:10 90:10	2930 2750	30 19	<u>1610</u> 914



[0285]



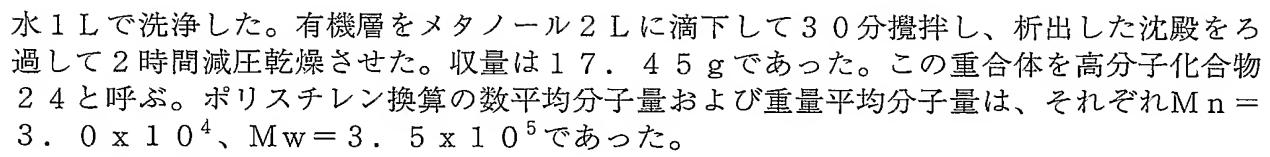
(高分子化合物23の合成) 実施例 2 9

化合物 H (10.7g、18mmol)、および2,2'ービピリジル(7.59g、 48.6mmo1)を脱水したテトラヒドロフラン840mLに溶解した後、窒素でバブ リングして系内を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液を60℃まで昇温し、 60℃でビス (1、5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) {Ni (COD) 2} (1 3. 4g、48.6mmol)加え、攪拌しながら3時間反応させた。反応後、この反応 液を室温(約25℃)まで冷却し、25%アンモニア水60mL/メタノール1.3L/ イオン交換水1.3 L混合溶液中に滴下して攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間 減圧乾燥し、その後、トルエン1Lに溶解させてからろ過を行い、ろ液をアルミナカラム を通して精製し、トルエン層を、5.2%塩酸水1Lで3時間、4%アンモニア水1Lで 2時間、さらにイオン交換水1 Lで洗浄した。有機層をメタノール2 Lに滴下して30分 攪拌し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた。収量は17.35gであった。 この重合体を高分子化合物23と呼ぶ。ポリスチレン換算の数平均分子量および重量平均 分子量は、それぞれ $Mn=7.6 \times 10^4$ 、 $Mw=4.9 \times 10^5$ であった。

[0286]

実施例30(高分子化合物24の合成)

化合物H (15.5g、25.9mmol)、上記で合成した N, N'ージフェニルー N, N' ービス (4-t-ブチルー2, 6-ジメチルフェニル) ーベンジジン <math>(9.05)g、11. 1mmol) および2, 2'ービピリジル (15.6g、100mmol) を 脱水したテトラヒドロフラン1.2 Lに溶解した後、窒素でバブリングして系内を窒素置 換した。窒素雰囲気下において、この溶液を60℃まで昇温し、60℃でビス(1、5− シクロオクタジエン) ニッケル (0) {Ni (COD) 2} (27.5g、100mmo 1)加え、攪拌しながら3時間反応させた。反応後、この反応液を室温(約25℃)まで 冷却し、25%アンモニア水70mL/メタノール1.2L/イオン交換水1.2L混合 溶液中に滴下して攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、その後、トル エン11に溶解させてからろ過を行い、ろ液をアルミナカラムを通して精製し、トルエン 層を、5.2%塩酸水1Lで3時間、4%アンモニア水1Lで2時間、さらにイオン交換



[0287]

実施例31 (高分子化合物25の合成)

[0288]

実施例32

(溶液の調整)

上記で得た高分子化合物23を67重量%、高分子化合物24を33重量%の比率でトルエンに溶解し、ポリマー濃度1.3重量%のトルエン溶液を作製した。

(EL素子の作製)

上記で得たトルエン溶液を用い、実施例27と同様の方法によってEL素子を得た。得られた素子に電圧を印加することにより、この素子から470nmにピークを有するEL発光が得られた。EL発光の強度は電流密度にほぼ比例していた。また該素子は2.9Vから発光開始が見られ、最大発光効率は3.12cd/Aであった。

[0289]

実施例38

(溶液の調整)

上記で得た高分子化合物25をトルエンに溶解し、ポリマー濃度1.3重量%のトルエン溶液を作製した。

(EL素子の作製)

上記で得たトルエン溶液を用い、実施例 27 と同様の方法によってEL素子を得た。得られた素子に電圧を印加することにより、この素子から 460 nmにピークを有するEL発光が得られた。EL発光の強度は電流密度にほぼ比例していた。また該素子は 3.2 Vから発光開始が見られ、最大発光効率は 0.66 c d / Aであった。

[0290]

【表4】

表4					
				系内モノマー 組成比	最高輝度 (cd/A)
	木。リマー1	ホ°リマー2	混合比		
実施例32	高分子化合物23	高分子化合物24	67:33	90:10	3.12
実施例38	高分子化合物25			90:10	0.66



[0291]

実施例33 (高分子化合物26の合成)

化合物 H (10.6g、17.6mmol)、N,N'ービス(4ーブロモフェニル) -N, N' -ビス (4-t-ブチルー2, 6-ジメチルフェニル) ーベンジジン (0. 29g、0.36mmol) および2,2'ービピリジル(7.6g、48.6mmol) を脱水したテトラヒドロフラン1100mLに溶解した後、窒素でバブリングして系内を 窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液を60℃まで昇温し、60℃でビス(1 、5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) $\{Ni(COD)_2\}$ (13.4g、48. 6 mm o 1) 加え、攪拌しながら3時間反応させた。反応後、この反応液を室温(約25 ℃)まで冷却し、25%アンモニア水65mL/メタノール1100mL/イオン交換水 1100mL混合溶液中に滴下して攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥 し、その後、トルエン550mLに溶解させてからろ過を行い、ろ液をアルミナカラムを 通して精製し、トルエン層を、5.2%塩酸水約550mLで3時間、4%アンモニア水 約550mLで2時間、さらにイオン交換水約550mLで洗浄した。有機層をメタノー ル約550mLに滴下して30分攪拌し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた 。得られた重合体の収量は6.3gであった。この重合体を高分子化合物26と呼ぶ。ポ リスチレン換算重量平均分子量は、4.2 x 10⁵であり、数平均分子量は、6.6 x 1 0^4 であった。

[0292]

実施例34 (高分子化合物27の合成)

化合物 H (13.8g、23.1mmol)、N, N'ービス(4ープロモフェニル)ーN, N'ービス(4ーtーブチルー2, 6ージメチルフェニル)ーベンジジン(8.07g、9.9mmol) および2, 2'ービピリジル(13.9g、89.1mmol)を脱水したテトラヒドロフラン1100mLに溶解した後、窒素でバブリングして系内を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液を60℃まで昇温し、60℃でビス(1、5ーシクロオクタジエン)ニッケル(0) $\{Ni(COD)_2\}$ (24.5g、89.1mmol)加え、攪拌しながら3時間反応させた。反応後、この反応液を室温(約25℃)まで冷却し、25%アンモニア水120mL/メタノール2.4L/イオン交換水2.4L混合溶液中に滴下して攪拌した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、その後、トルエン1Lに溶解させてからろ過を行い、ろ液をアルミナカラムを通して精製し、トルエン層を、5.2%塩酸水2Lで3時間、4%アンモニア水2Lで2時間、さらにイオン交換水2Lで洗浄した。有機層をメタノール3Lに滴下して30分攪拌し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた。得られた重合体の収量は13.36gであった。この重合体を高分子化合物27と呼ぶ。ポリスチレン換算重量平均分子量は、2.3x104であり、数平均分子量は、3.6x105であった。

[0293]

実施例35

(溶液の調整)

上記で得た高分子化合物23を50重量%、高分子化合物24を50重量%の比率でトルエンに溶解し、ポリマー濃度1.3重量%のトルエン溶液を作製した。

(EL素子の作製)

上記で得たトルエン溶液を用い、実施例27と同様の方法によってEL素子を得た。得られた素子に電圧を印加することにより、この素子から460nmにピークを有するEL



発光が得られた。EL発光の強度は電流密度にほぼ比例していた。また該素子は2.7Vから発光開始が見られ、最大発光効率は1.80cd/Aであった。

[0294]

実施例36

(溶液の調整)

上記で得た高分子化合物26を53重量%、高分子化合物27を47重量%の比率でトルエンに溶解し、ポリマー濃度1.3重量%のトルエン溶液を作製した。

(EL素子の作製)

上記で得たトルエン溶液を用い、実施例 27 と同様の方法によってE L素子を得た。得られた素子に電圧を印加することにより、この素子から 470 nmにピークを有するE L発光が得られた。E L発光の強度は電流密度にほぼ比例していた。また該素子は 3.8 Vから発光開始が見られ、最大発光効率は 1.02 c d / Aであった。

[0295]

【表5】

表5

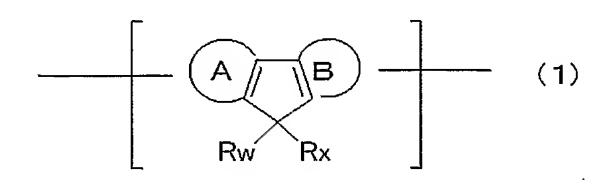
<u>4X O</u>					
				系内モノマー 組成比	最高輝度 (cd/A)
	ポリマー1	ホッリマー2	混合比	X:Z	
実施例35	高分子化合物23		50:50	85:15	1.81
実施例36		高分子化合物27	53:47	85:15	1.02
実施例38	高分子化合物25			90:10	0.66



【要約】

【課題】 発光材料や電荷輸送材料として有用で、耐熱性、蛍光強度等に優れた高分子化合物を提供する。

【解決手段】 下記式 (1) で示される繰り返し単位を含み、ポリスチレン換算の数平均分子量が $10^3 \sim 10^8$ である高分子化合物。



〔式中、A環およびB環はそれぞれ独立に、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環を表すが、A環における芳香族炭化水素環とB環における芳香族炭化水素環とは互いに異なる環構造の芳香族炭化水素環であり、2つの結合手はそれぞれA環および/またはB環上に存在し、RwおよびRxはそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基等を表し、RwとRxはそれぞれ互いに結合して環を形成していてもよい。〕

【選択図】

なし



認定・付加情報

特許出願の番号 特願2004-321803

受付番号 50401890256

書類名 特許願

担当官 兼崎 貞雄 6996

作成日 平成16年11月11日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000002093

【住所又は居所】 東京都中央区新川二丁目27番1号

【氏名又は名称】 住友化学株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100093285

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 住友化学

知的財産センター株式会社内

【氏名又は名称】 久保山 隆

【選任した代理人】

【識別番号】 100113000

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 住友化学

知的財産センター株式会社内

【氏名又は名称】 中山 亨

【選任した代理人】

【識別番号】 100119471

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友

化学知的財産センター株式会社

【氏名又は名称】 榎本 雅之



特願2004-321803

出願人履歴情報

識別番号

[000002093]

1. 変更年月日「亦更理力」

2004年10月 1日

[変更理由] 名称変更

住所変更

住 所

東京都中央区新川二丁目27番1号

氏 名

住友化学株式会社